



Title	回折格子によつて発生した空間搬送波の変調と復調による歪測定
Author(s)	三野, 正幸
Citation	大阪大学, 1966, 博士論文
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/28960
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

回折格子によつて発生した空間搬送波 の変調と復調による歪測定

三 野 正 幸

目 次

序 論	1
第1章 測定原理	5
1.1 写像光学系の結像理論	7
1.2 応力歪により周波数変調をうけた回折格子	17
1.3 歪分布検出法としての <i>Spatial filtering</i>	22
1.4 まとめ	29
第2章 歪をうけた回折格子からの歪の検出	30
2.1 光学要素の配置	31
2.2 試料の作成	37
2.3 ナイフエッジによる復調	42
2.3.1 復調理論	42
2.3.2 実験結果および考察	46
2.4 光学楔による復調	53
2.4.1 復調の忠実度	53
2.4.2 光学楔の作成	56
2.4.3 実験結果および考察	58
2.5 面積型楔による復調	65
2.5.1 復調理論	65
2.5.2 面積型楔を改良した方法による復調	68
2.5.3 実験結果および考察	71
2.6 色差による復調	74
2.6.1 復調の原理	74

2.6.2 実験結果および考察	75
2.7 まとめ	80
第3章 平面応力による歪の測定	82
3.1 荷重に基づく試料の厚み変化の補正	83
3.2 三試料を用いる方法	89
3.3 一試料を用いる方法	96
3.4 測定感度	98
3.5 まとめ	105
第4章 引張り変形されたアルミニウム粗大結晶の 歪分布の測定	107
4.1 試料の調製	107
4.2 実験結果および考察	108
4.3 測定方法に対する考察	115
4.4 まとめ	116
第5章 分光用回折格子のピッチ誤差の測定	118
5.1 測定の原理	118
5.2 試料および測定光学系	120
5.3 実験結果および考察	121
5.4 まとめ	126
総 括	127
謝 辞	131
参考文献	132
講演ならびに論文目録	134

序　論

材料の歪、あるいは応力の分布状態を知ることは、工学的にも、また物理学的にも重要な問題であり、各種の測定方法が用いられている。各測定方法は、それぞれの特徴を持っていて、直接に対象物の歪分布の状態を試料全体にわたって簡単にしかも感度よく解析することは困難である。本研究は、回折格子を用いることによって、これらの問題点を解決した測定方法を開発したものである。

光弾性法¹⁾は最も広く用いられている測定方法の一つであり、弾性理論によって求めた解を実験的に検証しようと共に、理論によって解き難い実用的な問題に適用しても良好な結果が得られる。しかしながら光弾性実験では光弾性的性質を持つ透明材料で、実際の原型と相似形の模型を作成し、これについて測定を行うのが普通である。材料を直接試料とする場合には光弾性皮膜法²⁾が用いられているが、この場合、測定感度は皮膜の厚さに比例する。皮膜を厚くすると感度を上げることができが、厚い皮膜のために試料の歪分布の状態は、影響をうけ、実際のものと異なる恐れがあり、また試料に生じた歪は厚い皮膜に忠実に伝えられるとは限らない。したがって光弾性法は測定対象物を直接試料としようとする場合に、一般には種々困難を伴う。対象物を直接に試料として、その歪分布を測定しようとする試みとしては、試料上に格子を刻線し、それを印として利用し、荷重により試料が歪んだとき、

その格子線の位置を測定器で一個一個読みとつて行く方法が
行われている。³⁾ しかしこれによれば、試料全体にわたる歪分布の状態を知るには非常に手間がかかる、測定精度について
も多くは期待できなり。また他の規則格子と重ねあわせてモ
アレを出し、格子歪を拡大して測定を行う方法もとられてお
り、⁴⁾⁵⁾ その感度は他の測定方法にくらべて勝っている。モアレ
法はモアレ間隔を大きくしてその感度を得ているために、縞
の中間にある近接した場所の歪の変動を知ることは困難とな
る。一方、格子による回折を利用して回折光の移動から歪
を測定することができる。⁶⁾⁷⁾ しかしこれによれば試料全体の平
均的な歪しか知ることができず、試料全体にわたる歪の分布
を測定するには、細く絞った光を試料にあてるかあるいはビ
ンホールを置くことによって、その一部分の歪を測定し、そ
れを試料全体にわたって走査しなければならず、非常な労力
を要する。

以上のように直接対象としたものの試料全体にわたる歪分布を簡単に、しかも感度よく微小領域まで測定することは困
難であって、それらに代る測定方法を開発することが必要と
される。本研究では回折格子を用り、荷重により歪んで⁸⁾回折
格子および測定に用いる光学系を情報通信理論の立場から考
えて上に述べた歪測定における諸問題を解決する測定方法を
開発することを目的とした。

Duffieux のフーリエ解析による結像論以来、光学系は情報
通信理論の立場から論じられ、レンズが通信系における線型

のフィルター回路に相当することが明らかとなつた。⁹⁾したがつて通信系において回路の特性を周波数特性で表現するのと全く同様に物体の構造、すなわち場所的な明暗および位相の分布を空間軸上で一つの波形と考え、空間周波数と言うものを設定して写像光学系の結像特性を空間周波数に対して考えることができる。この立場から通信系で行われている種々の技巧がそのまま光学系にも適用でき、像の評価^{10) 11)}および改良^{12) 13)}などに有用な働きを示している。従来、写像光学系を情報通信理論から取扱う場合、通常光波そのものを搬送波とみなし、それが物体を通過することによって振幅あるいは位相変調をうけると言う考え方であった。¹⁴⁾ここでは、変形前の規則格子はその透過率分布あるいは位相分布にしたがう空間的な波を発生させ、それを空間的搬送波と考えた。荷重により歪んだ回折格子は、その空間搬送波が歪の分布を変調波として空間周波数変調をうけたとみなし、この考え方のもとに本研究は行われている。

歪んだ回折格子による Fraunhofer の回折像はある方がりを持つようになるが、これは周波数変調をうけた空間搬送波のスペクトルが Fraunhofer の回折像として得られているためである。そこに光学楔などのマスクを挿入し、各スペクトルの空間周波数に対する透過特性を減じたり、切除したりして、空間的なフィルタリング (spatial filtering) を施せば変調波、すなわち歪の分布は試料の像面上に光の強度分布として現われる。すなわち復調が達成されて、歪分布が測定されること

になる。感光材料を塗布して写真的に格子を転写すれば、直接測定対象物を試料とすることができる。上のような原理に基づく測定方法について理論的、実験的に検討したところ、試料全体にわたる歪の分布状態を一度に感度よく測定できることが明らかとなった。

測定光学系の光源として線光源を用いれば、光学的な取扱いは、一次元に簡単化され、線光源に垂直方向の歪成分の分布が測定される。任意方向の歪を決定するには一般に三方向の歪成分を知ればよく¹⁵⁾、これには各々異なる三方向の格子を利用する方法、および一向向の格子のみを使用して、試料を線光源に対して傾けて測定する方法が考えられる。

金属結晶を引張り変形させた場合、その歪分布はどういうになるかは、実用上の構造材の強度と関連し、結晶学的に重要な問題である。ここでは本測定法の一つの実験例として、アルミニウム粗大結晶を引張り変形させたときの歪分布を調べてみたところ、結晶粒内および粒界の試料全体にわたる歪の分布状態を一度に感度よく微小領域まで測定できた。

さらに発展させて、荷重による歪だけではなく、分光回折格子の製作上生じるピッチ誤差の検定に利用し、ruling engine の不良箇所のために周期的に生じているピッチ誤差などの測定をも試みた。

第1章 測定原理

光学系を情報通信理論の立場から考えると、その取扱いが簡単になり、種々の問題に対して有用な働きを示している。本研究にあたりても、せんに回折格子の結像問題をこの情報通信理論の立場から考えた。

光学系で物体の像を作るには、適当な方法で物体を照明することが必要である。例えは、顕微鏡や投影機では光源とコンデンサー、レンズによつて照明光束を作り、物体をこの光束中に置り、その透過光をレンズに受けて結像が行われる。この際、物体の像は光源の大きさなどに基づく照明光の性質、すなわち照明光の *coherency* によつて大きく変化することが知られている。このような照明系を含めた写像光学系の結像に関する研究は Hopkins と Barham¹⁶⁾, Goodbody¹⁷⁾ が一般的な計算を発表しており、さらにこれを情報通信理論の立場から O'Neil¹⁸⁾, 辻内¹⁹⁾, Suzuki¹⁹⁾, Wolf⁹⁾ などが解析している。本研究に用ひる測定光学系を顕微鏡、投影機と同種の光学系とし、以下の取扱いに便利なように Hopkins の発表による *coherence factor*²⁰⁾ を用いて結像式を導き、さらにこれを情報通信理論の立場から記述して、§1.1 に示した。

ここでの物体は、荷重によりせんに回折格子とした場合、その回折格子は情報通信理論の立場から考えると、もとの規則格子によつて発生した空間搬送波がせんの分布を変調波として空間周波数変調をうけたものとみなされる。この考え方が本

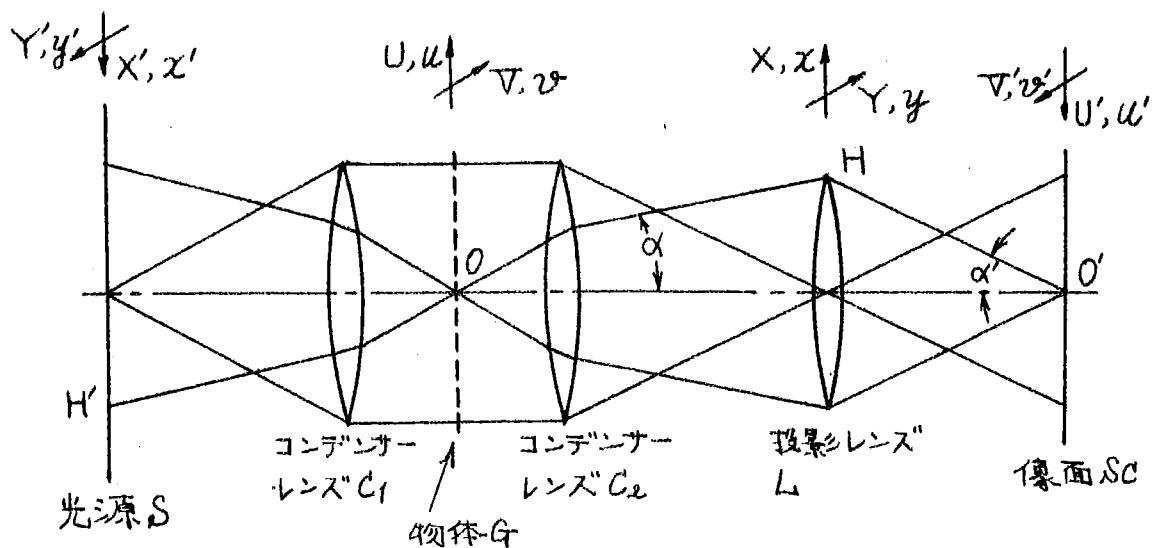
研究の基本となるが、これについて §1.2 ご考察する。

従来、物体の像を一つの情報として、格子の形で記録する考え方は、樹脂上に作られた格子の高低による *thermoplastic recording*^{21) 22)} および格子線の角度を変える方法²³⁾ などに見られる。像の再現は、回折光の一部をさえぎり、そのさえぎられた光を出している部分は暗くなると言う考え方である。本研究の荷重によつて歪んだ回折格子も、見方を変えれば、歪の分布と言う情報を格子に記録したとみなすことができるが、この再現は周波数被変調波の復調と言う従来とは別の立場から考えることができ、通信系における周波数分割器の特性と同じように各空間周波数に対する透過特性を直線的に減じて *spatial filtering* を施してやれば、変調波すなわち歪の分布は光の強度分布として得ることができる。その方法の考え方について §1.1 ご求めた結像式をもととして §1.3 ご考察する。

1.1 写像光学系の写像理説

光学系は第1.1図に示した通りで、物体はコンデンサーレンズ C_1 および C_2 の間に置かれ、また光源の像はコンデンサーレンズ" C_1 および C_2 によって投影レンズ" の瞳面上に作られる。コンデンサーレンズ" C_1 は、光源との距離が C_1 の焦点距離となるように置かれている。したがって光源が点光源であれば、物体は平面波で照明されることとなり、実際の光学系を想定する上での便利のために置かれているものであり、コンデンサーレンズ" C_1 を省いても、物体をコンデンサーレンズ" C_2 の瞳面に置けば、以下に述べるのと同じ結像関係が得られる。

第1.1図に示したごとく、物体面の下心 O と投影レンズ" の瞳面 H を結ぶ光線が光軸となす角を α とし、またこの光線が像面の中心 O' に到達したときに光軸となす角を α' とする。この



第1.1図 照明系を含む写像光学系

光線を物体面の後方に延長して光源と交わる点をH'として、式の取扱いを簡単にするために次のような線形の変換座標を考える。

$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{X}{H}, \quad y = \frac{Y}{H}, \quad x' = \frac{X'}{H'}, \quad y' = \frac{Y'}{H'} \\ u &= \left(\frac{2\pi}{\lambda} \sin \alpha\right) U, \quad v = \left(\frac{2\pi}{\lambda} \sin \alpha\right) V \\ u' &= \left(\frac{2\pi}{\lambda} \sin \alpha'\right) U', \quad v' = \left(\frac{2\pi}{\lambda} \sin \alpha'\right) V' \end{aligned} \right\} \quad (1.1)$$

ここに (X, Y) , (X', Y') , (U, V) および (U', V') の大文字は各々実長を示している。また λ は光の波長である。この (1.1) の変換座標を用いると光源面上のある点と投影レンズ瞳面上のその共轭点とは同じ座標値が対応し、また物体面上のある点とその共轭な像点とは同じ座標値が対応する。

光源の輝度分布を $B'(x', y')$ とし*、光源内の点 (x', y') に $dx' dy'$ なる微小部分を考える。この微小光源によって物体上 (u, v) において生じる光波の複素振幅**は $E(u, v)$ であるとする。いま物体の透過率分布***を $\Theta(u, v)$ とすれば、この物体を通過した光

* 座標 $x'y'$ は $-\infty \sim +\infty$ を考え、光源外では $B'(x', y') = 0$ と考える。

以下他の座標 u, v , x, y および x', y' の函数についても同様とする。

** 光波の振幅 a と位相 ϕ を同時に表わしたもので $a e^{i\phi}$ と書ける。

*** 一般的の物体は光波の振幅の減衰をもたらす明暗分布と、光波の位相に変化を与える位相分布の両方を兼備しており、明暗分布を $\Theta(u, v)$ 、位相分布を $\phi(u, v)$ とすれば物体は

$$f(u, v) \exp\{i\phi(u, v)\}$$

で表わされる。

の複素振幅は $E(u, v) \mathcal{O}(u, v)$ となる。いま物体上 (u, v) 点にある振幅 1 、位相ゼロの点光源の像は、その共軸点 (u, v) を中心として考え、その複素振幅を $t(u-u, v-v)$ と表わす。簡単のためにコンデンサーレンズ C_2 は無収差であるとして、物体を透過し、投影レンズ "ムの瞳に入る光をすべて通すだけの大きさを持っていたとする。投影レンズの波面収差を $w(x, y)$ とし、座標 x, y と u, v とは逆方向であることを考慮して

$$t(u, v) = \iint_{-\infty}^{\infty} \bar{e}(x, y) \exp\{i(u'x + v'y)\} dx dy \quad (1.2)$$

で示される。ただし

$$\begin{aligned} \bar{e}(x, y) &= \exp\left\{i \frac{2\pi}{\lambda} w(x, y)\right\} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ &= 0 & x^2 + y^2 > 1 \end{aligned} \quad (1.3)$$

である。 $\bar{e}(x, y)$ は $u=0, v=0$ に置いた点光源によって作られる投影レンズの瞳面における複素振幅分布であることを函数と呼ばれる。光源 $d\sigma$ によつて照明された物体上 (u_1, v_1) 点からのお光による像面上 (u', v') 点の複素振幅は

$$E(u_1, v_1) \mathcal{O}(u_1, v_1) t(u'-u_1, v'-v_1)$$

である。像面の点 (u', v') における複素振幅 $E'(u', v')$ は物体面全体からの光の寄与を積分して、

$$E'(u', v') = \iint_{-\infty}^{\infty} E(u_1, v_1) \mathcal{O}(u_1, v_1) t(u'-u_1, v'-v_1) du_1 dv_1 \quad (1.4)$$

となる。物体上の独立な他の点 (u_2, v_2) に関して (1.4) と同じ式が得られ、像面上 (u', v') 点における光源 $d\sigma$ による強度は次式のようになる。

$$\begin{aligned}
dI &= E(u, v) E^*(u, v) \\
&= \left\{ \iint_{-\infty}^{\infty} E(u_1, v_1) \mathcal{O}(u_1, v_1) t(u-u_1, v-v_1) du_1 dv_1 \right. \\
&\quad \left. \times \iint_{-\infty}^{\infty} E^*(u_2, v_2) \mathcal{O}^*(u_2, v_2) t^*(u-u_2, v-v_2) du_2 dv_2 \right\} d\sigma
\end{aligned} \tag{1.5}$$

ここに記号*は複素共轭を示す。像面上 (u, v) 点における強度 $I(u, v)$ は光源全体からの寄与を積分して得られ、変数はすべて独立であるから積分順序を変更して、

$$\begin{aligned}
I(u, v) &= \iint_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{\Sigma} E(u_1, v_1) E^*(u_2, v_2) d\sigma \right\} \mathcal{O}(u_1, v_1) \mathcal{O}^*(u_2, v_2) \\
&\quad \times t(u-u_1, v-v_1) t^*(u-u_2, v-v_2) du_1 dv_1 du_2 dv_2
\end{aligned} \tag{1.6}$$

となり、さらに

$$\begin{aligned}
I(u, v) &= \iint_{-\infty}^{\infty} \gamma_{12} \mathcal{O}(u_1, v_1) \mathcal{O}^*(u_2, v_2) \\
&\quad \times t(u-u_1, v-v_1) t^*(u-u_2, v-v_2) du_1 dv_1 du_2 dv_2
\end{aligned} \tag{1.7}$$

となる。このとき

$$\gamma_{12} = \frac{1}{\sqrt{B(u_1, v_1) B(u_2, v_2)}} \int_{\Sigma} E(u_1, v_1) E^*(u_2, v_2) d\sigma \tag{1.8}$$

である。 $B(u, v)$ は (u, v) 点における照明光の強度である、

$$B(u, v) = \int_{\Sigma} |E(u, v)|^2 d\sigma \tag{1.9}$$

となる。光源面における輝度 $B'(x', y')$ の変化が小さいとすると

$$\frac{1}{\sqrt{B(u_1, v_1) B(u_2, v_2)}} = \text{一定} \tag{1.10}$$

と考えよう。

この γ_{12} は coherence factor で物体面上任意の二点 $(u_1, v_1), (u_2, v_2)$ 間の光の干涉の程度を示し、Hopkins^{20) 24)}, Wolf⁹⁾ などによつて

解釈され、像形成および分解能の研究などに応用されたものである。この物理的意味は (u_1, v_1) および (u_2, v_2) から出る二つの光波のある時間内の平均値をそれぞれ $a_1 e^{i\delta_1}$ および $a_2 e^{i\delta_2}$ で表わすとき、その干涉光の時間的平均強度が

$$I = a_1^2 + a_2^2 + a_1 a_2 V_{12} 2 \cos(\delta_2 - \delta_1 + \beta_{12})$$

となるだとすると

$$V_{12} e^{i\beta_{12}} = \gamma_{12}$$

を考えることができる。したがって $|\gamma_{12}|$ はこの二つの光波による干渉率の visibility を表わすと考へてよく、この二点からの光波が coherent な場合には $|\gamma_{12}| = 1$ 、incoherent な場合には $|\gamma_{12}| = 0$ であり、一般的な場合には、その中間の値をとる。

上記 (1.7) が照明系を含めた一般的な結像関係を示しており、像は物体面の座標の函数として表わされている。これを情報通信理論の立場から論じるには、フーリエ変換で与えられる空間周波数の函数として表わさなければいけない。ここで物体の振幅透過程 $\mathcal{O}(u, v)$ のフーリエ変換をとり、

$$O(x, y) = \iint_{-\infty}^{\infty} \mathcal{O}(u, v) \exp\{-i(ux + vy)\} du dv \quad (1.11)$$

を考える。この $O(x, y)$ は $\S 1.1$ 図の光学系で、光軸上 $x' = 0$, $y' = 0$ に点光源を置いた場合、その光源の共轭面上、すなわち投影レンズの瞳面上における物体による回折像の振幅分布に等しい。^{*} この光源の共轭面上の回折像は Fraunhofer の回折像と呼ばれ、光学上種々重要な意味を持つ。フーリエ変換の意

* 13頁～16頁参照。

味が5明るみに、 $O(x, y)$ は物体のスペクトルであり、 x および y は空間周波数の dimension を持っている。したがって、Fraunhofer の回折面である xy 面は物体のスペクトル面であり、座標軸 x および y は空間周波数軸である。

一方、ある *incoherent* 光源から照らされている物体上の二点間の coherence factor はその光源と同じ大きさ、形を持つ開口によつて球面波が回折された場合の Fraunhofer の回折像の振幅分布に等しく⁹⁾、またコンデンサーレンズ C_1 と光源との間隔が C_1 の焦点距離となる場合には物体の置かれる位置に無関係であることが、 γ_{12} は C_1 が無位置のとき、定数係数は別として、

$$\gamma_{12} = \iint_{-\infty}^{\infty} B(x', y') \exp[i\{(u_1 - u_2)x' + (v_1 - v_2)y'\}] dx' dy' \quad (1.12)$$

となる。いま

$$\left. \begin{array}{l} u' - u_1 = u_1'', \quad u' - u_2 = u_2'' \\ v' - v_1 = v_1'', \quad v' - v_2 = v_2'' \end{array} \right\} \quad (1.13)$$

と座標を変換する。(1.11) および (1.13) を用いて (1.7) を整頓すると

$$\begin{aligned} I(u, v) = & \iiint_{-\infty}^{\infty} \left(\iiint_{-\infty}^{\infty} \gamma_{12} t(u_1'', v_1'') \exp\{-i(u_1''x_1 + v_1''y_1)\} \right. \\ & \times t^*(u_2'', v_2'') \exp\{i(u_2''x_2 + v_2''y_2)\} du_1'' dv_1'' du_2'' dv_2'' \\ & \times O(x_1, y_1) O^*(x_2, y_2) \exp[i\{(x_1 - x_2)u' + (y_1 - y_2)v'\}] \\ & \left. \times dx_1 dy_1 dx_2 dy_2 \right) \end{aligned} \quad (1.14)$$

となる。(1.2) および (1.12) を用ければ (1.14) は

$$I(u', v') = \iiint_{-\infty}^{\infty} C(x_1, y_1, x_2, y_2) O(x_1, y_1) O^*(x_2, y_2) \times \exp[i\{(x_1 - x_2)u' + (y_1 - y_2)v'\}] dx_1 dy_1 dx_2 dy_2 \quad (1.15)$$

および

$$C(x_1, y_1, x_2, y_2) = \iint_{-\infty}^{\infty} B'(x', y') \bar{C}(x' + x_1, y' + y_1) \bar{C}^*(x' + x_2, y' + y_2) dx' dy' \quad (1.16)$$

と書きなおすことができる。

(1.11) で示された $O(x, y)$ および (1.16) によって示された $C(x_1, y_1, x_2, y_2)$ を用いることにより、結像式 (1.7) を空間周波数の函数として表わしたもの (1.15) に書き換えることができた。 (1.15) が明示的に (1.16) は光学系の周波数伝達特性を示し、光源の大きさ、投影レンズの位置およびその径に依存している。また $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ は独立にえらばれるから像は各々異なる周波数のスペクトル成分間の寄り合^{*}、像の構造をもつもし、通信系との対応からそれを交流成分と呼ぶことがある。 直流成分は $x_1 = x_2, y_1 = y_2$ のように同じ周波数のスペクトル成分から生じ、それは像のコントラストを下げる。

物体の振幅透過分布 $O(u, v)$ のフーリエ変換である (1.11) は、光軸上 $x' = 0, y' = 0$ に存在する点光源によって生じる物体の Fraunhofer の回折像の振幅分布であることを述べたが、これは次のように考えれば明らかである。 $x' = 0, y' = 0$ に存在

* 音響学などでは使用されている寄り合は、振動数すなわち周波数の集まりで表わされるが、それと同じ内容であるからこの言葉を用いた。

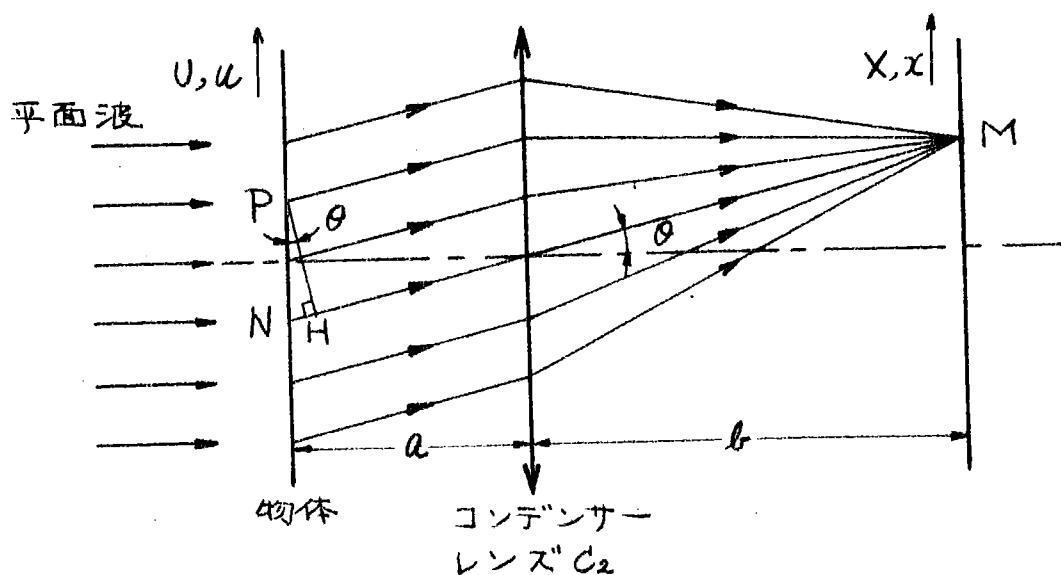
する点光源を出た光波は、コンデンサーレンズ C_1 を通過した後、平行平面波となって、1.2 図に示したとく物体に到達する。物体を通過し、回折された光のうち、光軸と \neq な傾むいた光は、点光源の共轭面である投影レンズ C_2 の瞳面上の M 点へすべて集められる。いま簡単のために一次元について議論を進める。物体に平行平面波 $A_0 \sin(\omega t + \delta)$ が到達したとする。物体は複素表示して

$$\Theta(U) = F(U) \exp\left\{i \frac{2\pi}{\lambda} L(U)\right\} \quad (1.17)$$

で表わされる。ここに $L(U)$ は物体によって生じた光路差である。物体を通過した直後の光波は

$$A_0 F(U) \sin\left\{\omega t + \delta - \frac{2\pi}{\lambda} L(U)\right\}$$

となる。いま物体上の点 $P(U)$ にある微小部分 dU から出た回折光のうち光軸と \neq なる角をなす光は XY 面上の点 $M(X)$ に到達する。このとき光波は $M(X)$ への到達距離に応じて、次の (1.18), (1.19) で示されるごとく λ の割合の減少、位相の遅れを生じる。



1.2 図 物体による Fraunhofer の回折

$$A_0 \frac{F(U)}{PM} \sin [\omega t + \delta - \frac{2\pi}{\lambda} \{ L(U) + PM \}] \quad (1.18)$$

ここに P における光の *inclination factor* は 1 とした。また PM は

$$\begin{aligned} PM &= MN - NH = (a+b) \frac{1}{\cos \theta} - \left(\frac{ax}{b} + u \right) \frac{x}{b} \\ &\approx a+b - \frac{ux}{b} \end{aligned} \quad (1.19)$$

である。ただし $x \ll b$ と仮定した。 $M(X)$ に集まる合成光波は (1.18) を物体全面にわたって積分して

$$W(X) = \int_{-\infty}^{\infty} A_0 \frac{F(U)}{PM} \sin [\omega t + \delta - \frac{2\pi}{\lambda} \{ L(U) + PM \}] dU \quad (1.20)$$

となる。これに (1.19) を代入し、正弦函数外の PM は近似的に $a+b$ と置いて積分の外へ出し、また振幅の比のみを考えるから $A_0/a+b$ なる定数係数は省略して

$$W(X) = A \sin \{ \omega t + \delta - \frac{2\pi}{\lambda} (a+b) \} - B \cos \{ \omega t + \delta - \frac{2\pi}{\lambda} (a+b) \} \quad (1.21)$$

となる。ここに

$$\left. \begin{aligned} A &= \int_{-\infty}^{\infty} F(U) \cos \frac{2\pi}{\lambda} \{ L(U) - \frac{XU}{b} \} dU \\ B &= \int_{-\infty}^{\infty} F(U) \sin \frac{2\pi}{\lambda} \{ L(U) - \frac{XU}{b} \} dU \end{aligned} \right\} \quad (1.22)$$

である。 (1.21) はさらに

$$W(X) = |O| \sin \{ \omega t + \delta - \frac{2\pi}{\lambda} (a+b) - \psi \} \quad (1.23)$$

と書き換えられ、 O よび ψ は各々

$$\begin{aligned} O &= A + iB \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} F(U) \exp \{ i \frac{2\pi}{\lambda} L(U) \} \exp \{ -i \frac{2\pi}{\lambda} \frac{X}{b} U \} dU \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} O(U) \exp \{ -i \frac{2\pi}{\lambda} \frac{X}{b} U \} dU \end{aligned} \quad (1.24)$$

$$\psi = \tan^{-1} \frac{B}{A} \quad (1.25)$$

で表わされる。 (1.24) は光波の複素振幅である。これを計

算することによって Fraunhofer 回折像の振幅と位相が定まる。

(1.1) に示した変換座標を用い、物体 $O(u)$ を変換座標で表わしたものと $O(u)$ とすれば (1.24) は

$$O(x) = \int_{-\infty}^{\infty} O(u) \exp(-ixu) du \quad (1.26)$$

となり、Fraunhofer 回折像は物体のフーリエ変換の形で与えられる。 (1.26) の x は回折面の座標であると共にフーリエ変換の意味から物体の持つている空間周波数であり、両者は一致している。

点光源が x' なる位置にあれば Fraunhofer の回折光は $x=x'$ を中心にして分布し

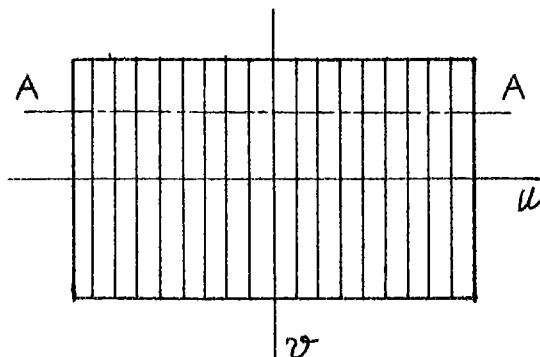
$$O(x-x') = \int_{-\infty}^{\infty} O(u) \exp\{-i(x-x')u\} du \quad (1.27)$$

となる。したがって回折面の座標を x' だけ移動したものが、空間周波数となる。

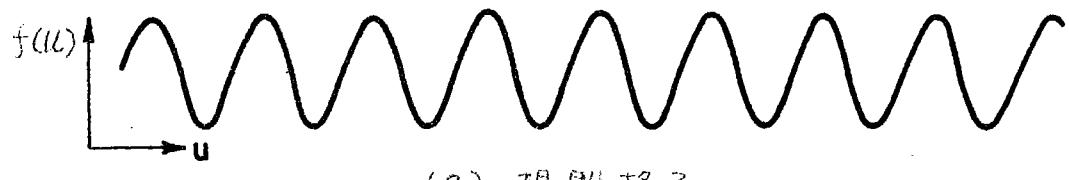
1.2 応力歪により周波数変調を うけた回折格子

回折格子 (diffraction grating または単に grating) は平面あるいは凹球面上に 1mmあたり 1~1200 本くらいの割合で等間隔に平行な明暗の線、あるいは溝を持っているもの。分光学の研究に分散系として用いられてきた。分光学の分野において回折格子は平面あるいは凹球面などに分類されるが、写像光学上の物体として回折格子を考えた場合、明暗の線を持っていて、そこを透過(反射)する光波の振幅に影響を与える明暗格子と、規則正しい形状の溝を持っていて、光波の位相に影響を与える位相格子に分類することができる。回折格子を歪測定に応用する場合、何らかの方法で試料上に格子を作らなければならぬが、ruling engine で各試料に刻線することは非常に手間がかかる、實際的な方法ではない。格子作成方法としては、試料上に感光材料を塗布して写真的に格子を転写する方法が最も簡単である。したがって本研究では平面の明暗格子を使用することとし、これについて取扱う。

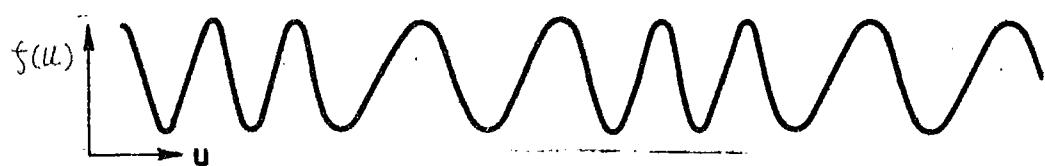
第 1.3 図に示したよ
うな平面の明暗格子を
考へ、格子線の方向を



第 1.3 図 回折格子の格子線
と座標軸



(a) 規則格子



(b) 歪んだ格子

オ1.4図 周波数変調をうけた回折格子。

$f(u)$ は振幅透過率を示す。

u軸に平行に置く。その回折格子の明暗の透過率分布が正確に変化するすれば、u軸に平行な断面、例えはAAの透過率分布はオ1.4図(a)のようである。いまここで何らかの原因、例えは回折格子に不均一な荷重が加えられたとき、その断面の透過率分布はオ1.4図(b)に示したごとく各部分によって異った格子間隔を持つようになる。オ1.4図において横座標のuは場所を表わす空間的な座標であり、また $f(u)$ は振幅透過率分布で、通信系における時間、電圧にそれぞれ対応させて考えることができる。したがって通信系の場合の周波数と対応して、格子間隔を周波数と言い換えてもさしつかえなく、厳密には空間周波数と言う。これによれば「歪んだ」回折格子は場所、場所によって変化する空間周波数を持つた状態である。したがってもとの規則格子の透過率分布を空間的な搬送波と考えると、歪んだ回折格子は空間周波数変調をうけた状態である。

あるとみなすことができる。この場合、信号すなわち変調波はどのようなものと考えればよいかを以下に考察する。

先のオ1.3図のように、格子線の方向がび軸に平行に置かれている格子間隔 ω_c の明暗格子の振幅透過率分布 $f(u, v)$ は

$$f(u, v) = f(u) = A_0 + A_1 \cos \omega_c u + A_2 \cos 2\omega_c u + \dots \quad (1.28)$$

とフーリエ級数に展開できる。例えばオ1.5図に示したような明および暗が交互にある矩形状の透過率分布を持っている格子の場合は

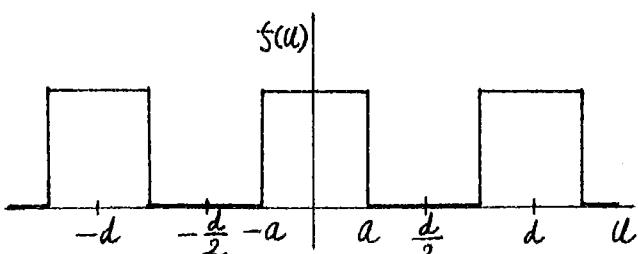
$$f(u) = 1 + 2 \frac{\sin \omega_c}{a \omega_c} \cos \omega_c u + 2 \frac{\sin 2\omega_c}{2a \omega_c} \cos 2\omega_c u + \dots \quad (1.29)$$

のこととなる。ここに $\omega_c = 2\pi/d$ である。格子の函数をフーリエ級数に展開した場合、その各項のフーリエ係数とフーリエ位相とが各々回折像の各次数の振幅と位相を与えている²⁵⁾ が、(1.28)の各項の A_0, A_1, A_2 などはこの回折格子による Fraunhofer の回折像の振幅を示している。で、0次光の振幅が A_0 、1次光のものが A_1 、2次光のものが A_2 などとなり、投影レンズ面上に生じる。ここで“投影レンズ”には2次光よりも高次の回折光を入れないとすれば(1.28)の3項以上の各項は結像に関係せず、回折格子は

$$f(u, v) = A_0 + A_1 \cos \omega_c u \quad (1.30)$$

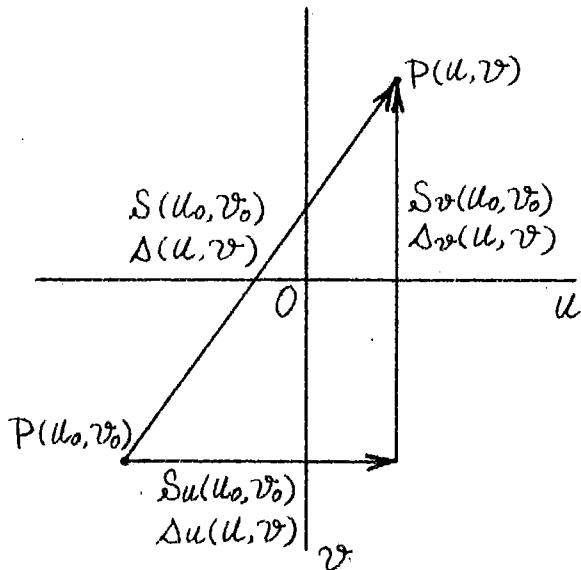
となる。したがって上

記の条件のもとで明暗格子は、すべて(1.30)



オ1.5図 矩形状の透過率分布を持つ回折格子

で示される正弦状の透過率分布を持っているものと考えてよ
う。



第1.6図 荷重による回折格子面上の点の変位

$P(u_0, v_0)$: 変形前の位置

$P(u, v)$: 変形後の位置

ここで第1.6図に示したごとく、回折格子上の点 $P(u_0, v_0)$ が荷重により $P(u, v)$ まで変位したとする。ここに $S_u(u_0, v_0)$ および $S_v(u_0, v_0)$ は各々 u 方向および v 方向の変位成分で、 $\Delta_u(u, v)$ および $\Delta_v(u, v)$ はそれを変形後の座標点 (u, v) の函数として表わしたものである。したがって

$$\left. \begin{array}{l} u_0 = u - \Delta u \\ v_0 = v - \Delta v \end{array} \right\} \quad (1.31)$$

である。変形後の回折格子の透過率分布は(1.30)の u に

$u - \Delta u$, v に $v - \Delta v$ と置き換えて得ることができます

$$f(u, v) = A_0 + A_1 \cos \omega_c (u - \Delta u) \quad (1.32)$$

となる。変形後 v が一定の断面の周波数は

$$\omega = \frac{\partial}{\partial u} \{ \omega_c (u - \Delta u) \} = \omega_c - \omega_c \frac{\partial \Delta u}{\partial u} \quad (1.33)$$

となる。

通信系にありける周波数変調の場合の変調波 $m(t)$ は

$$\omega = \omega_c + k m(t) \quad (1.34)$$

の関係で示され、 t は時間であり、 k は定数である。したが

って(1.33)における変調波 $m(u, \varphi)$ は

$$m(u, \varphi) = \frac{\partial \Delta u}{\partial u} \quad (1.35)$$

$$k = -\omega_0 \quad (1.36)$$

と考えてよい。一方、歪は変形前の座標点 (u_0, φ_0) で定義され¹⁵⁾ u 方向の歪成分は

$$\varepsilon_u = \frac{\partial \Delta u}{\partial u_0} = \frac{\partial \Delta u}{(1 - \frac{\partial \Delta u}{\partial u}) \partial u} = \frac{\partial \Delta u}{\partial u} \quad (1.37)$$

となる。ゆえに歪んだ回折格子は、その u 軸に平行な歯面を考へると u 方向、すなわちその格子線と直角方向の歪成分を変調波として周波数変調されていると考えてよいことが明らかになつた。

1.3 歪分布検出方法としての Spatial filtering

§1.2で"歪んだ"回折格子は歪分布を変調波として周波数変調されておりることを述べたが、その変調波を試料である回折格子の像画面上に何らかの方法で光の強度分布として検出すれば、すなわち復調すれば、その歪分布を知ることができる。以下復調するにはいかなる方法をとればよいかについて考察を加える。

光源は点光源とし、光軸上 $x=0, y=0$ に置かれておりとする。いま簡単のために一次元の場合について議論を進める。回折格子の透過率分布は(1.30)に示したとく

$$f(u) = A_0 + A_1 \cos \omega_c u \quad (1.38)$$

で与えられ、変位を

$$\Delta(u) = a_m \sin \omega_m u \quad (1.39)$$

とする。荷重が加えられた変形した後の回折格子の透過率分布は(1.39)を(1.32)に代入して

$$f(u) = A_0 + A_1 \cos \omega_c(u - a_m \sin \omega_m u) \quad (1.40)$$

となる。この場合、変調波は(1.35)および(1.37)により

$$m(u) = \varepsilon = \frac{d\Delta(u)}{du} = a_m \omega_m \cos \omega_m u \quad (1.41)$$

である。(1.40)を変形して

$$f(u) = A_0 + A_1 \sum_{p=-\infty}^{\infty} \{ J_p(m_f) \cos(\omega_c + p\omega_m) u \} \quad (1.42)$$

となる。ここに $m_f = -\omega_c a_m$ で、通信系では周波数変調指數と呼ばれているものである。ここでの意味は ω_c は各々の回折格子について定まっているから、(1.39)より明らかのように最

大変直に比例したものであり、また(1.41)より振幅に比例したものでもある。(1.42)において γ は整数であり、 $\delta_p(m_f)$ もまた次のベッセル函数である。(1.40)のこととく周波数変調をうけた回折格子によって投影レンズ上に生じる Fraunhofer の回折像は(1.40)のスペクトルであり、(1.42)より

$$O(\chi) = 2A_0\delta(\chi) + A_1 \sum_{p=-\infty}^{\infty} \delta_p(m_f) \{ \delta(\omega_c + p\omega_m - \chi) + \delta(\omega_c + p\omega_m + \chi) \} \quad (1.43)$$

となる。ここに δ はデルタ函数である。この(1.43)を図に表わしたもののが图1.7例である。規則格子の場合には、そのスペクトルは $-\omega_c, 0, \omega_c$ の位置に現われるが、周波数変調をうけた格子の場合には、搬送波の周波数の両側に側帶波が生じることがわかる。すなわち -1 次および 1 次の線スペクトルである Fraunhofer の回折像は、いわゆるゴーストと呼ばれる名がりを持ってくるようになる。

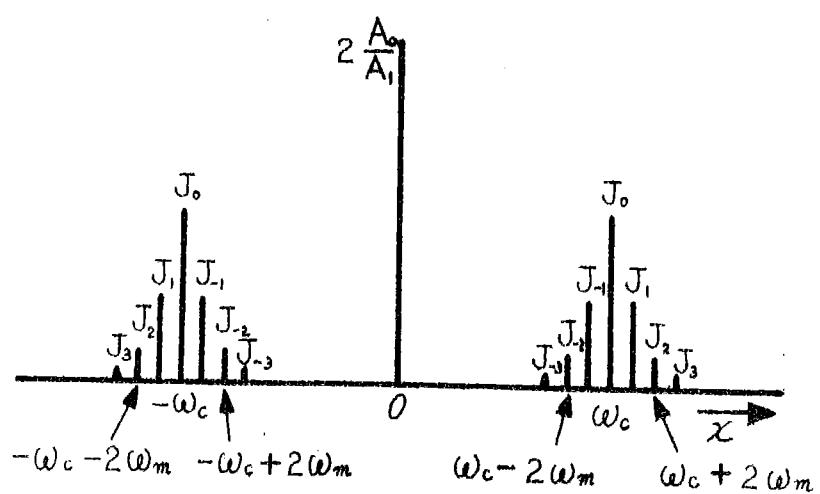


图1.7 図 $A_m \omega_m \cos \omega_m u$ なる変調波で周波数変調をうけた回折格子のスペクトル。 J_0, J_1, J_{-1} などは各々 $\delta_0(m_f), \delta_1(m_f)$ などとの略。

いま投影レンズを無収差とする。このときその瞳函数 $\tilde{C}(x)$ は定数係数は別として (1.3) より

$$\begin{aligned}\tilde{C}(x) &= 1 & |x| \leq 1 \\ &= 0 & |x| > 1\end{aligned}\} \quad (1.44)$$

となる。したがって (1.16) の $C(x_1, x_2)$ は

$$\begin{aligned}C(x_1, x_2) &= 1 & x_1, x_2 \text{ が共にレンズの瞳内} \\ &= 0 & x_1, x_2 \text{ のうち少なくとも一方} \\ & & \text{がレンズの瞳外}\end{aligned}\} \quad (1.45)$$

である。試料-像面上の強度分布は (1.15) より

$$I(u) = \iint_S O(x_1) O^*(x_2) \exp\{i(x_1 - x_2) u'\} dx_1 dx_2 \quad (1.46)$$

となり、ここに積分範囲 S はレンズの瞳内である。 (1.46) は

$$\begin{aligned}I(u') &= \int_S O(x_1) \exp(ix_1) dx_1 \int_S O^*(x_2) \exp(-ix_2) dx_2 \\ &= E'(u') E'^*(u')\end{aligned} \quad (1.47)$$

と書き換えることができ、ここに

$$E'(u') = \int_S O(x) \exp(ix) dx \quad (1.48)$$

である。 $E'(u')$ は (1.47) より明らかのように像の振幅分布であり、Fraunhofer 回折像のフーリエ変換で与えられている。

いま $O(x) = A(x) + iB(x)$ とし、图 1.7 図に示したような線入子クトルの場合、これら各入子クトルの周波数の組合せ (x_1, x_2) として (1.46) より一般に

$$\begin{aligned}I(u) &= \sum_{x_1} \sum_{x_2} O(x_1) O^*(x_2) \exp\{i(x_1 - x_2) u'\} \\ &= \sum_{x_1} \sum_{x_2} \{A(x_1) + iB(x_1)\} \{A(x_2) - iB(x_2)\} \\ & \quad \times \{\cos(x_1 - x_2) u' + i \sin(x_1 - x_2) u'\}\end{aligned}$$

$$= \sum_{x_1} \sum_{x_2} \left[\{ A(x_1) A(x_2) + B(x_1) B(x_2) \} \cos(x_1 - x_2) u' + \{ A(x_1) B(x_2) - A(x_2) B(x_1) \} \sin(x_1 - x_2) u' \right] \quad (1.49)$$

である。 $O(x)$ が"虚数部を含まない実函数"であれば $B(x) = 0$, $A(x) = O(x)$ であって

$$I(u') = \sum_{x_1} \sum_{x_2} O(x_1) O(x_2) \cos(x_1 - x_2) u' \quad (1.50)$$

となる。さうに (1.50) は

$$\begin{aligned} I(u') = & \sum_{x_1 > 0} \sum_{x_2 > 0} O(x_1) O(x_2) \cos(x_1 - x_2) u' \\ & + \sum_{x_1 < 0} \sum_{x_2 < 0} O(x_1) O(x_2) \cos(x_1 - x_2) u' \\ & + \sum_{x_1 \geq 0} \sum_{x_2 \leq 0} O(x_1) O(x_2) \cos(x_1 - x_2) u' \\ & + \sum_{x_1 \leq 0} \sum_{x_2 \geq 0} O(x_1) O(x_2) \cos(x_1 - x_2) u' \end{aligned} \quad (1.51)$$

となる。图1.7 図に示したスペクトルは $x=0$ に関して対称、すなわち偶函数であるから (1.51) の第1項と第2項とは等しく、また第3項と第4項は格子線の像が生じるが、格子線は搬送波と考えているからその像は対象としなくてよい。

したがって (1.51) は

$$I(u') = \sum_{x_1 > 0} \sum_{x_2 > 0} O(x_1) O(x_2) \cos(x_1 - x_2) u' \quad (1.52)$$

と考えれば十分である。

いま投影レンズには ω_c とその側常波だけが入るとする。これは $x > 0$ の領域だけを考えることであり、(1.52) にしたがって結像計算を行うことを意味しているので本研究の目的に対しては一般性を失っていなり。その時の像面上の強度分布は (1.43) および (1.52) より

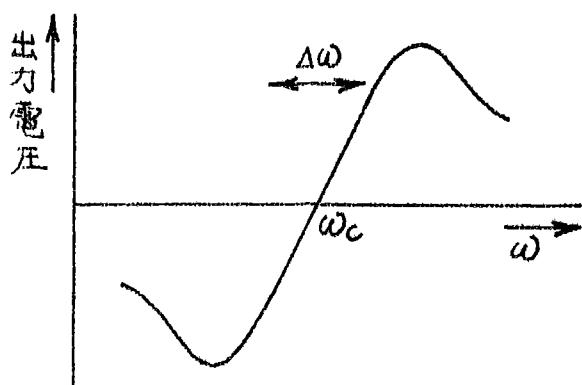
$$\begin{aligned}
 \langle (U') \rangle = & \sum_{p=-\infty}^{\infty} \{ \bar{J}_p(m_f) \}^2 + 2 \sum_{p=-\infty}^{\infty} \bar{J}_p(m_f) \bar{J}_{p+2}(m_f) \cos 2\omega_m U' \\
 & + 2 \sum_{p=-\infty}^{\infty} \bar{J}_p(m_f) \bar{J}_{p+4}(m_f) \cos 4\omega_m U' + \dots \\
 & \dots + \{ 1 + (-1)^n \} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \bar{J}_p(m_f) \bar{J}_{p+n}(m_f) \cos n\omega_m U' + \dots
 \end{aligned} \tag{1.53}$$

となる。ここにベッセル函数の性質

$$\sum_{p=-\infty}^{\infty} J_p(m_f) J_{p+m}(m_f) = 0 \quad n: \text{奇数}$$

を証明した。(1.53) をみると変調波 $a_m w_m \cos \omega_m t$ に対する $n=1$ の基本波形が表われてりなりの(即ち復調は達成されてい)る、且の分布は光の強度分布として見られなり。

通信系において周波数変調波の復調は半1.8回に示した特性と同様周波数判別器(discriminator)によつて行われる。²⁶⁾光学系と通信系との対応から本研究の目的に対してもこのような周波数判別器が有効であると思われる。1.2で述べたとく、通信系における電圧および時間が光学系ではそれぞ



第1.8回 通信系における周

波数毎別特性²⁶⁾。△ ω はその直線部分で、復調に有効な領域である。

れ振幅透過率および距離に対する影響について述べた。この図は空間周波数に対する振幅透過率を直線的に減じればよいことがわかる。すなわちX軸に対して振幅透過率は直線的に変化していくものをFraunhofer回折面に補入すればよい。このように

透過率が変化しているものを光学楔と育うが、いま用いる光学楔の透過率を

$$d(x) = h \left(\frac{x - \omega_c}{\omega_m} - g \right) \quad (1.54)$$

とする。ここで"変調波にかかる定数"は(1.36)のごとく
 $h = -\omega_c < 0$ の場合についての復調を考えているから $h < 0$ とする。このとき $x \geq x_c + g\omega_m$ で "d(x) = 0" であるから、g は光学楔の挿入位置を示している。投影レンズには ω_c とその側帯波だけが入ると考えているから(1.43)の $O(x)$ も $n=2$ 項のみを考えればよく、光学楔を透過した直後の光波の複素振幅は

$$O(x)dx = A_1 h \sum_{p \leq g} J_p(m_g) (p - g) \quad (1.55)$$

となる。ここに座標 x は $x = \omega_c + p\omega_m$ の関係で示される p で書き換えた。この $O(x)dx$ を Fraunhofer 回折面上の光波の複素振幅を示す(1.52)の $O(x)$ に代入して、像面上の強度分布は定数係数 $(A_1 h)^2$ を省略して

$$\begin{aligned} I(u') = & \sum_{p \leq g} \{ J_p(m_g) (p - g) \}^2 \\ & + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left\{ \sum_{p+m \leq g} J_p(m_g) J_{p+m}(m_g) (p - g) (p + m - g) \right\} \cos m \omega_m u' \right] \end{aligned} \quad (1.56)$$

となる。 $|m_g| < 1$ の場合、すなわち荷重による最大変位が、1 格子間隔を越えない程度に小さければ、* ベッセル函数値は次数の増加と共に急激に減少する。したがって(1.56)の $n \geq 2$ の項は $n=1$ の項にくらべて十分小さないと考えることができ、近似的に

* 詳しくは §3.4 参照。

$$I(u') = \sum_{p < g} \{J_p(m_f)(p-g)\}^2 + \{2 \sum_{p+1 < g} J_p(m_f) J_{p+1}(m_f) (p-g)(p+1-g)\} \cos \omega_m u' \quad (1.57)$$

となる。この式の第1項は像面全体にわたり一様な強度であり、平均的な明るさを示している。第2項は変調波 $a_m \omega_m \cos \omega_m u'$ と対応した強度分布を表わしている。したがって(1.54)で示されるような光学機を Fraunhofer の回折面に挿入してやれば復調が達成され、歪分布は回折格子の像面上に光の強度分布として観測、測定される。

このように光学系に種々の改変を行い、空間周波数に対する透過特性を切除したり、減らしたりして目的に合致する像を得ようとする試みを一般に *spatial filtering* と呼んでおり、ノイズの減少¹²⁾、コントラストの増大¹³⁾、収差の除去¹⁴⁾、レンズズームによる回折効果の除去¹⁵⁾などとして光学像の改良に用いられて來た。ここでも上述のようにスペクトル面である Fraunhofer の回折面に種々の *spatial filtering* を施して復調を達成することとする。(1.56) の n ≥ 2 以上の項を無視した影響および光学機の方法を変形した他の復調方法など、その詳細は次の第2章において実験結果と共に示すこととする。

1.4 まとめ

本研究で用いる写像光学系の結像関係を二つの形に導いた。一つは像の強度分布を物体を照明する光の *coherence* を示す *coherence factor* を含めて、物体面の座標の函数として表わし、他はそれを物体の持っている空間周波数の函数として表わした。

物体による Fraunhofer の回折像はフーリエ変換の形で与えられるところから Fraunhofer の回折面は物体のスペクトル面であり、光軸上に点光源を置いた場合、回折面上の座標 XY との周波数とは正しく一致することが確かめられた。

次に物体として回折格子を考え、通信系との対応から考察した結果、荷重により歪んだ回折格子は、もとの格子線に直角な断面を考えると、規則格子を搬送波とし、その断面方向の歪成分を変調波として空間周波数変調されていると考えてよりことが明らかとなる。

これより変調波を復調すれば歪分布を知ることができるが、このまゝでは試料である回折格子の像面には歪分布を検出することはできない。復調は通信系において周波数被変調波の復調に用いられている周波数分割器と同じ作用をするようにスペクトル面で spatial filtering を施せば達成されると言う考え方が示された。

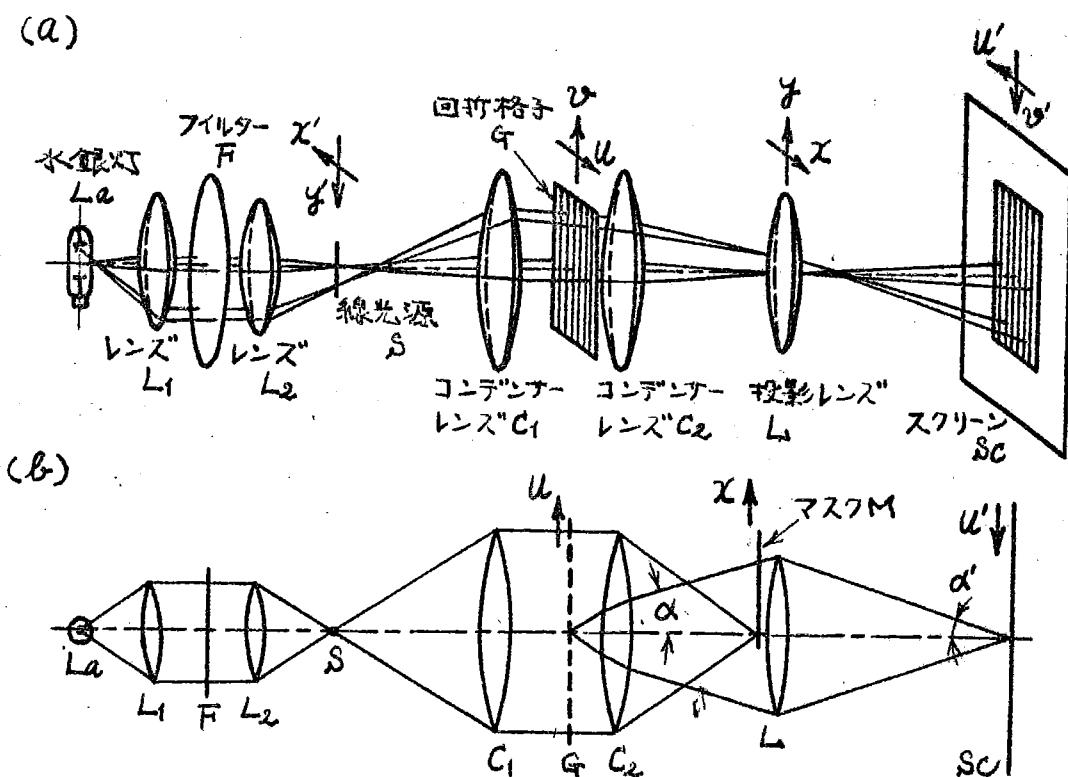
第2章 歪をうけた回折格子 からの歪の検出

应力歪を変調波として周波数変調をうけた回折格子から試料像面上に歪分布を検出する、すなわち復調するには回折格子のスペクトル面である Fraunhofer の回折面に振幅透過率が直線的に変化している光学楔を挿入して *spatial filtering* を施せばよりことを §1.3 で述べた。しかし変調波と得られた像面上の強度分布との対応は近似的であり、実際は高調波の影響によってやや異ってくる。本章では高調波の影響なども考慮して詳細に理論的検討を加え、実験結果と共に考察する。またさうに光学楔以外のものを用いた復調方法についても同様な検討を加え、それら各復調方法についての特徴を比較する。

実際の測定光学系は光源として線光源を用いる。このように線光源を用いることにより、回折格子は線光源方向にはほとんど "incoherently" に照明され、線光源に垂直な各断面を独立に考えることができ、理論的取扱いは一次元となるて簡単化される。またこれよりニ次元应力による歪の測定も可能となる。§2.1 では実際に用いる測定光学系の光学要素の配置を述べ、特に線光源として用いられる光源スリットについて詳しく検討する。

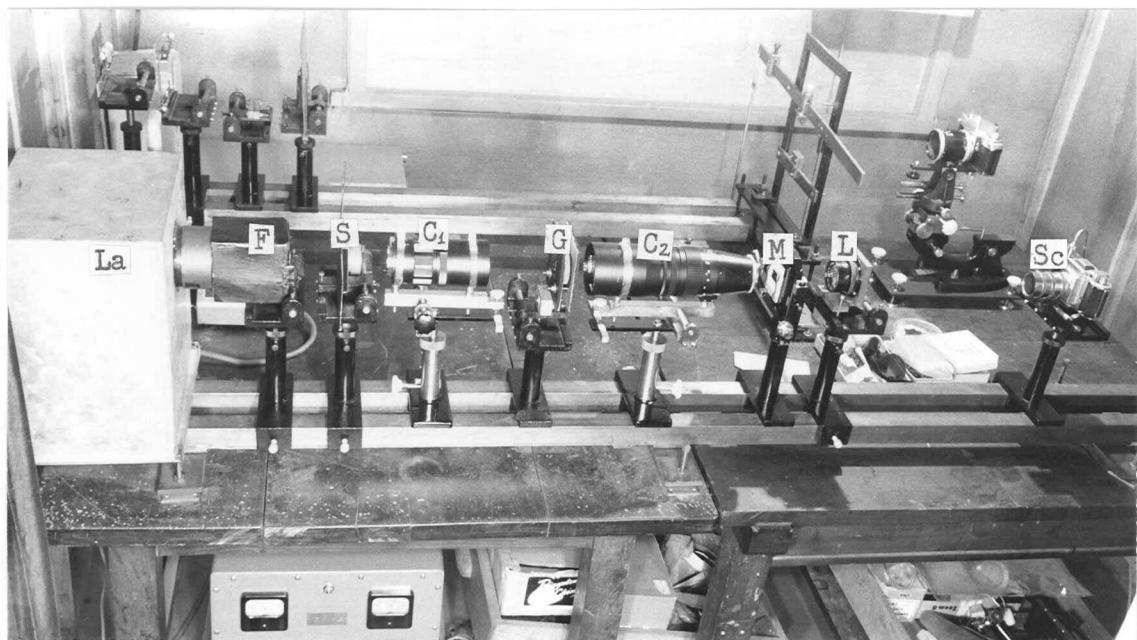
2.1 光学要素の配置

測定光学系の光学要素の配置はオ1.1図の光源を光軸上にある線光源に置き換えたもので、実際には水銀灯で照明されるスリットを用いた。その配置図はオ2.1図に示したとおりで、(a)は線光源から出た任意の光線が、回折格子を透過した後、回折格子の像面であるスクリーン上に達するとき、その光線を含むように光軸に平行な折平面で切った断面を表わし



オ2.1図 回折格子を用いた歪測定のための光学要素の配置

(b) ある任意の光線を含むように光軸に平行な平面で切った断面



オ2.2図 測定装置

La: 水銀灯 F: 集光レンズ" L_1, L_2 および干渉フィルター

S: 光源スリット C₁ および C₂: コンデンサーレンズ

G: 試料 M: マスク L: 投影レンズ Sc: カメラ本体

てあり、図にはその二例を示した。オ2.1図にありて像面上の振幅分布は(1.48)に示したごとく物体の *Fraunhofer* 回折像のフーリエ変換で与えられ、フーリエ変換は *Fraunhofer* 回折に相当するから、物体による *Fraunhofer* 回折像の *Fraunhofer* 回折像と考えることができる。この意味からオ2.1図の光学系は再回折光学系あるいは二重回折光学系と呼ばれている。

実際の装置はオ2.2図の写真に示したもので、線光源としては幅 20μ 、高さ 3mm のスリットを用いた。スリットを照らすための光源としては超高压水銀灯東芝 SHL-100UV を定電圧装置を通して点灯し、レンズ L_1 の焦点上に水銀灯を置いた。

したがって L_1, L_2 間は光源のたまりの範囲でほど平行光線であって、そこに多層膜干涉フィルターを挿入して $546 \text{ m}\mu$ の単色光を得た。コンデンサーレンズ C_1 および C_2 はスペクトル面にありて生じる収差を避け、*spatial filtering* の性能を向上させるために平行光に対して収差補正されている写真機用望遠レンズを用い、それを $f_1 = 200 \text{ mm}, f_2 = 300 \text{ mm}$ の焦点距離のものを使用した。*Fraunhofer* 回折面に置かれているマスクは顕微鏡用メカニカルステージを利用して移動し、その挿入位置の正確を期した。投影レンズは物体から発散してくる光波を収束し、像面の位置および倍率を規制するために置かれているものであり、焦点距離 180 mm 、直径 40 mm のボックスカメラ用のレンズを用いた。マスクを透過した光がすべてその径の中に入るならば必ずしもマスクと一体に置く必要はないが、実験の正確のために普通マスクの直後に置いた。スクリーンの位置にはカメラ本体を置いて、そのファインダーを利用して観測すると共に検知記録器として写真フィルムを用い、得られた图形を記録した。

ここでスリットを照明している照明光の *coherence*について考える。水銀灯によってオルイ園のレンズ L_2 は一様に照明される。 L_2 を出た光が収束光であれば L_2 の代りに同じ大きさ、形、強度分布を持つ *incoherent* 光源を置いたときと同じであり、レンズ L_2 の半径を δ 、 L_2 とスリットとの距離を R とし、 $\alpha = \delta/R$ とおけば、ほとんど *coherent* に照明される面積の直径 d は次式で与えられる。⁹⁾

$$d = 0.16 \lambda / \alpha \quad (2.1)$$

ここで"ほとんど" coherent に照明される領域とは coherence factor $|\gamma_{12}| \geq 0.88$ とした。装置の条件 $\lambda = 0.546 \mu$, $f = 17.5 \text{ mm}$, $R = 110 \text{ mm}$ を (2.1) に代入すれば

$$d = 0.55 \mu \quad (2.2)$$

となる。したがって coherently に照明される領域は非常に狭く、光源スリットはほとんど incoherently に照明されていいると考へてよい。

次にこのスリットを明りたとき、回折格子はどのような coherency をもって照明されるかを考へる。スリットは矩形光源であるから光源の強度分布を示す函数 $B'(x', y')$ は

$$\left. \begin{array}{ll} B'(x', y') = 1 & (x', y') \text{ がスリット内の場合} \\ = 0 & (x', y') \text{ がスリット・外の場合} \end{array} \right\} \quad (2.3)$$

となる。スリットは光軸に対称に置かれているとし、その幅を $2a$ 、高さを $2b$ とすれば、回折格子上の二点、 $P_1(u_1, v_1)$ および $P_2(u_2, v_2)$ 間の coherence factor γ_{12} は (1.12) より

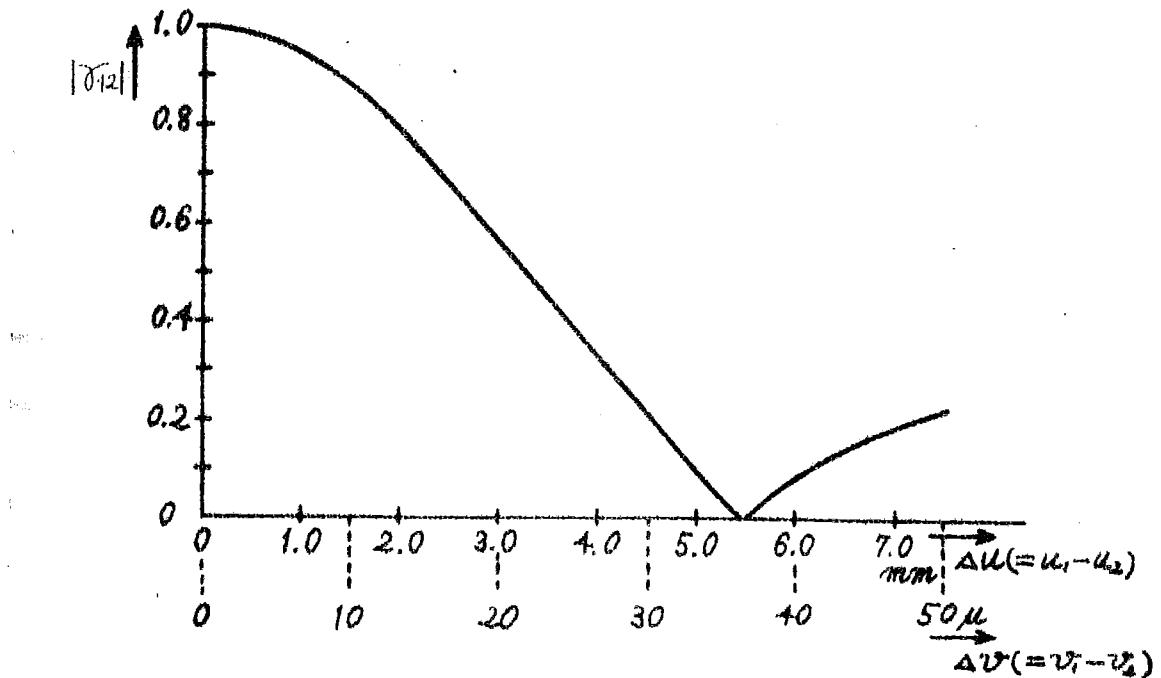
$$\gamma_{12} = \frac{\sin M}{M} \cdot \frac{\sin N}{N} \quad (2.4)$$

となる。ここに M, N は各々

$$M = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{a}{f_1} (u_1 - u_2), \quad N = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{b}{f_1} (v_1 - v_2) \quad (2.5)$$

である。

回折格子上 $v = \text{一定}$ の断面内にある二点間の coherency について考へる。 $v = \text{一定}$ 、すなわち $v_1 = v_2$ であるから $\sin N/N = 1$ となり、装置の条件であるスリット幅 $2a = 20 \mu$ 、高さ $2b = 3 \text{ mm}$ 、および波長 $\lambda = 0.546 \mu$ 、コンデンサーレンズ C_1 の焦点距



第2.3図 幅 20μ 、高さ 3mm の光源スリットで照明された回折格子の u 軸および v 軸に平行な断面上の二点、 $P_1(u_1, v_1)$ 、 $P_2(u_2, v_2)$ 間の coherence.

距離 $v_1 = 200\text{mm}$ を (2.4) および (2.5) へ代入し $|F_{12}|$ を計算したものが第2.3図の横軸 $\Delta u (=u_1 - u_2)$ のものである。また $u =$ 一定の断面内にある二点間の coherence についても同様に計算したもののが第2.3図の横軸 $\Delta v (=v_1 - v_2)$ のものである。任意の点、 $P_1(u_1, v_1)$ 、 $P_2(u_2, v_2)$ 間の coherence は (2.4) より成分 $u_1 - u_2, v_1 - v_2$ の coherence の積となる。ここで $|F_{12}| = \left| \frac{\sin x}{x} \right|$ の x 2極大は 0.217 であるから $|F_{12}| < 0.217$ をほとんど incoherent を範囲と考えれば、 u 軸方向に関しては incoherent を範囲は $\Delta u > 4.5\text{mm}$ であり、 v 軸方向に関しては $\Delta v > 30\mu$ となる。したがって、 v 軸方向には照明光はほとんど incoherent であると考えることができる。これより本装置内に置かれた回折格子は光学的に

はい軸に平行な断面がそれを独立に積み重なると存在しているとみなすことができます、図2.1図(b)に示したごとく、ある任意の光線を含むようにい軸に平行な断面で切った断面の光学系を考えて一次元的に取扱っても一般性は失わぬ。

試料)はひがある特定の値を持つ断面について像面上での共軸位置で測定を行うことになるから、この断面の面折格子の透過率分布を $f(u)$ 、その断面方向の歪成分布を $\psi(u)$ として計算を進めてよい。2.1.3で)は一次元的に考えて計算を行ったが、以上よりこれは一般性を失っていなく、また以下の光学的取扱いも一般性を失うことなくすべて一次元で行うことができる。

2.2 試料の作成

使用した回折格子はモ1.2で"述べたごとく明暗格子である。平面ガラス上に溝を切り、その溝中に黒色塗料を埋込んだ大日本スクリーン製作による規則格子で10本/mmのものを masterとして用いた。この規則格子をポリカーボネート樹脂ベースの写真フィルムあるいは乾板に密着し、回折格子全面にわたって一様な明るさの照明光で露光を与え、現像後得られた写真フィルムあるいは乾板を実験に供した。回折格子のように周波数の高いものは密着のわずかな不完全によつても、その像は不鮮明となるが、ここではその影響を避けるために露光時の照明光は平行光とした。

以上のように回折格子を写真法によって複製する場合に感光乳剤として要求される条件は

- (1) 微粒子であること
- (2) 高濃度、硬調であること
- (3) 適当な安全光のもとで取扱えること

である。これら3の条件を満たすものとして、本研究では小西六写真工業製のオルソ型コニリス乳剤を用い、高濃度、硬調現像が可能である伝染現像液コニドールリソによって現像を行つた。用いたコニリスオルソフィルムの特性を表2.1表に示した。

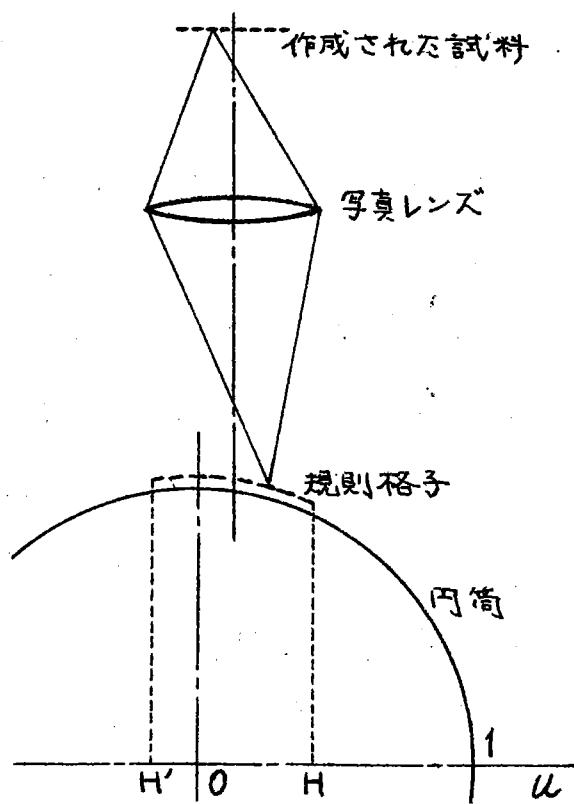
ここではベースとしてポリカーボネート樹脂を用いた。このポリカーボネートは水、薬品などに対して安定であり、無伸

表2.1表 コニリスオルソフィルムの特性

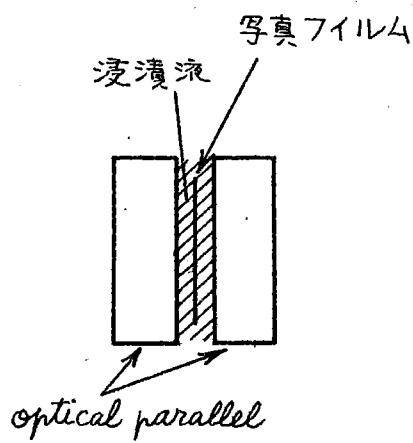
波長感度	580m μ まで
感度 カーボンアーク タンゲステン電球	ASA 20
	ASA 12
解像力	D-19による標準現像で"12.5本/mm
最高濃度	コニドーレリソによる標準現像で"4
ガンマ	コニドーレリソによる標準現像で"10 ~ 15
乳剤および保護膜の厚さ	8 μ
ハレーション防止膜の厚さ	6 μ

縮性の写真フィルムベースとして現在開発されているものである。写真法によって回折格子を複写する場合、フィルムベースの伸縮は直接に格子線の速をもたらすので、本研究では特に小西大写真工業で製作された厚さ 0.12mm および 3.0mm のポリカーボネットベースのコニリスオルソフィルムおよび乾板を用いた。さらにポリカーボネットは力学的にも他の樹脂にくらべて弹性領域が高く、弹性理論より求めた歪分布と比較できるので本実験に適している。その性質は表3.2 のや表3.1表に記した。

このように回折格子を表面に転写した写真フィルムを表2.4図に示したように格子線の方向を母線の方向と一致させて内筒上に密着して置く。この格子を上方からかくとも焦点深度内にあるように写真撮影すれば、撮影方向に垂直な面への投影像が得られ、撮影された格子の格子間隔は内筒の形にしたがって連続的に変化していくものとなる。このフィルム



第2.4図 円筒上に密着して置かれた規則格子を写真撮影することによって周波数変調をうけた試料を作成する方法。



第2.5図 写真フィルムの厚さむらを浸漬によって除く方法。

を模型的に荷重により周波数変調をうけた回折格子と考え、測定光学系の試料位置に置く。このときフィルムベースの厚さむらによって生じる光波の位相変化の影響を避けるために第2.5図に示したごとく、フィルムと optical parallel との間にフィルムベースと屈折率の等しい液を入れ*、二枚の optical parallel でフィルムを保持する。

格子の撮影は 1/3.3 倍で行い、写真レンズとして接写を目標に設計された焦点距離 50mm のミノルタマクロロッコール QF を F2.2 に絞って用いた。撮影の際、レン

* 浸漬液については第3.2 参照。

表2.2表 撥写用写真レンズ
マクロロッコールの歪曲収差
倍率: 1/3.3

像高(mm)	歪曲(%)
0	0
7.99	-0.04397
11.98	-0.10106
14.97	-0.16318
17.95	-0.24536
19.93	-0.31321
21.51	-0.37605

ズに歪曲収差があれば格子は正規の位置よりもずれるが、レンズの中心を通る光に対してその歪曲収差値を表2.2表に示した。これより測定光学系の試料とする格子にはフィルム周辺で0.3~0.4%程度の負の変位があり、その値に対応した縮みを持っている変調波を測定していることになる。

本実験で、これは一つの測定誤差を生じているが、特に精度を要する実験では、既知の収差値から補正を行うことも可能である。

表2.4図のように写真撮影することによって得られた試料は一次元的な変化をしており、図に示したようにu座標をとり、用いる円筒の半径を1とし、また $u=0$ での格子間隔を d_0 とすれば u での格子間隔 d は

$$d = d_0 \sqrt{1 - u^2} \quad (2.6)$$

となる。したがって空間周波数 ω は

$$\omega = \frac{1}{d} = \frac{1}{d_0 \sqrt{1 - u^2}} \quad (2.7)$$

である。 (1.33) と (2.7) とを対比して変調波を求めると

$$m(u) = A - \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} \quad (2.8)$$

となる。ここに A, B は定数であり、 $B > 0$ である。

以下の実験例では、円筒として半径 73mm および 367mm

のものを用いた周波数変化の大きいものと小さいものとの二試料である。半径 73 mm の円筒を用いた試料を T_e、36.7 mm の円筒を用いたものを T_dと略記する。T_e、T_dの大きさを定める撮影範囲 HH' と最小周波数に対する変調波の周波数変動の値* を表 2.3 表に示した。

回折格子に荷重を加えた試料の作成に関しては § 3.1 について述べるが、簡単に説明すれば次のとおりである。規則格子を転写したオリガーブネートベースの写真フィルムあるいは乾板を蓋の入るぬのように注意深く所定の形に成形し、その後荷重を加えた。次に荷重が施された格子像を *incoherently* に照明し、上記のレンズで 1/3.3 倍に写真撮影したこのフィルムを実際の試料として用い、フィルムの厚みの不均一による影響を取除くために浸漬して測定に供すると言う方法をとる。

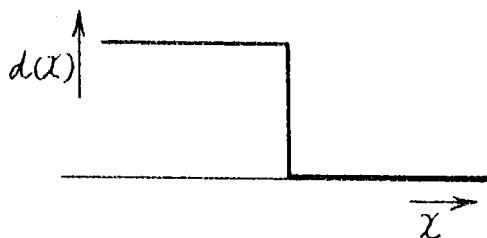
表 2.3 表 変調波の最小周波数に対する周波数変動

試料	撮影範囲	周波数変動(%)
T _e	-0.16 ≤ u ≤ 0.44	11.2
T _d	-0.14 ≤ u ≤ 0.19	1.8

* $\frac{m(u_{max}) - m(0)}{m_{u=0}}$ で表わされる。

2.3 ナイフエッジによる復調

§1.3において光学楔の透過率はある一定の勾配をもって変化しており、その値は無限大でないことを暗に仮定して計算を行った。しかしオ2.6図に示したごとくその勾配が無限大である不透明なマスクも考えられ、これは鋭い pass-band を持つ band-pass filter としての作用をする。実際的にはこれはナイフエッジであって、光学楔のように特にその製作は必要でなく簡単に得られるものであり、種々の点で有用である。以下このナイフエッジによる復調について検討する。



オ2.6図 ナイフエッジの透過率 $d(x)$

2.3.1 復調理論

§1.3で考えたとおり投影レンズには ω_c とその側帯波が入るとして、歪の分布すなわち変調波はここでも (1.41)

$$\epsilon = m(u) = a_m \omega_m \cos \omega_m u$$

と同じとする。いま $x > \omega_c + g\omega_m$ のスペクトルを取除くようにナイフエッジを Fraunhofer の回折画に挿入するとナイフエッジの透過率は

$$\left. \begin{array}{ll} d(x) = 1 & x \leq \omega_c + g\omega_m \\ = 0 & x > \omega_c + g\omega_m \end{array} \right\} \quad (2.9)$$

で表わされる。したがって回折面直後の光波の複素振幅は定数係数は別として

$$O(x) d(x) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} J_p(m_f) \delta(\omega_c + p\omega_m - x) \quad (2.10)$$

となる。像面上の強度分布はこれを (1.52) の $O(x)$ に代入して

$$I(u) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} \{J_p(m_f)\}^2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \sum_{p+m=-\infty}^{\infty} J_p(m_f) J_{p+m}(m_f) \cos n\omega_m u \right\} \quad (2.11)$$

となり、変調波すなわち歪の分布 $a_m \omega_m \cos \omega_m u$ に対応した $m=1$ の基本波图形を得ることが出来る。これより復調が達成され、歪の分布は光の強度分布として現わることがわかる。

$m \geq 2$ の項である高調波は復調された変調波の图形とやや変化せらるが、これは変調指数 $m_f = -\omega_c a_m$ 、すなわち歪の程度とナイフエッジを置く位置 u によって左右される。この影響を調べるために復調された图形の変調波に対する寄与度と Kliss factor (歪率) で表わし、数値計算を行ふ。Kliss factor は波形の純正弦性を示すものである、函数 $f(x)$ を

$$f(x) = a_0 + a_1 \cos \omega x + a_2 \cos 2\omega x + \dots \quad (2.12)$$

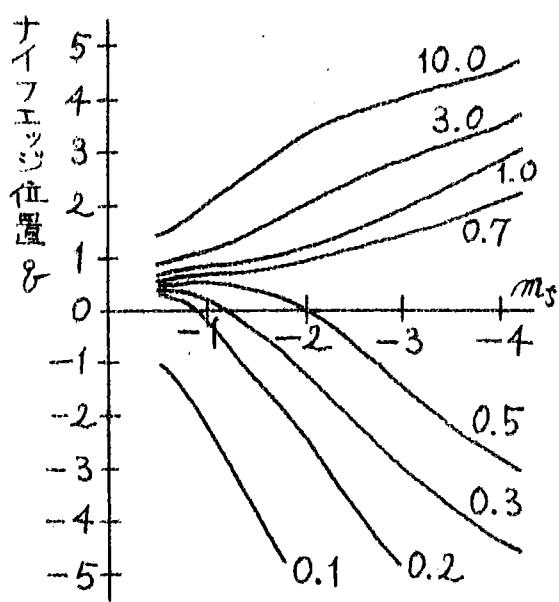
とフーリエ級数に展開して表わしたとき

$$K.F. = \sqrt{\sum_{m=2}^{\infty} a_m^2 / a_1^2} \quad (2.13)$$

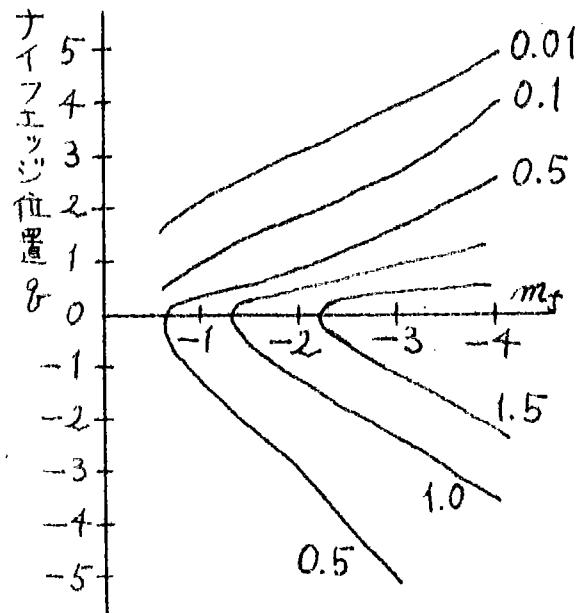
で定義される。したがって Kliss factor が大なる程、寄与度は零である。(2.11) の場合は

$$K.F. = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} \left\{ \sum_{p+m=-\infty}^{\infty} J_p(m_f) J_{p+m}(m_f) \right\}^2}}{\sum_{p+1=-\infty}^{\infty} J_p(m_f) J_{p+1}(m_f)} \quad (2.14)$$

となる。この (2.14) にしたがって Kliss factor を数値計算したものと第 2.7 図に示した。第 2.7 図より $m_f = -\omega_c a_m$ であるか



第2.7図 復調された图形の
Klin factor



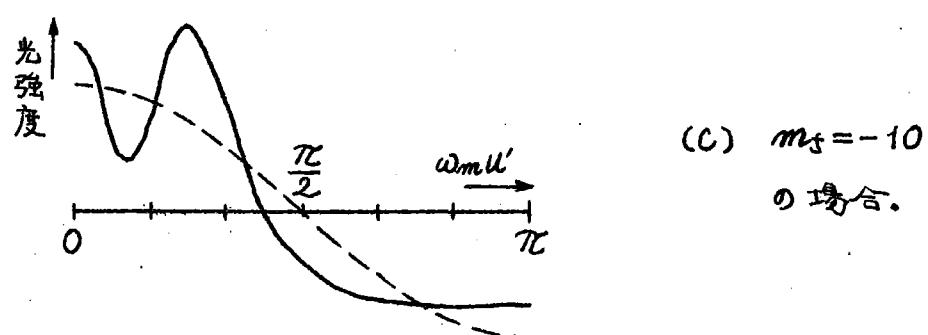
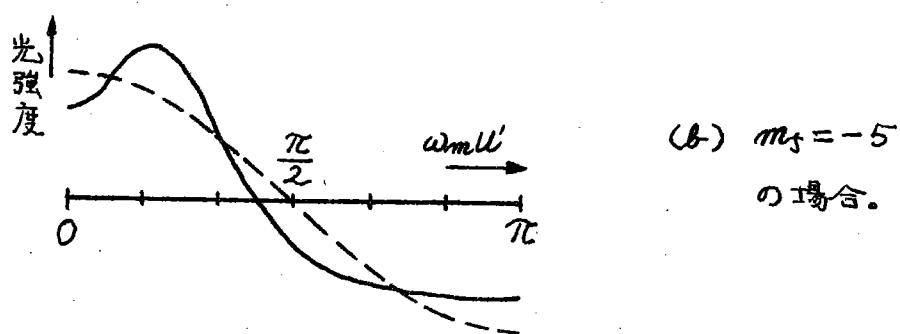
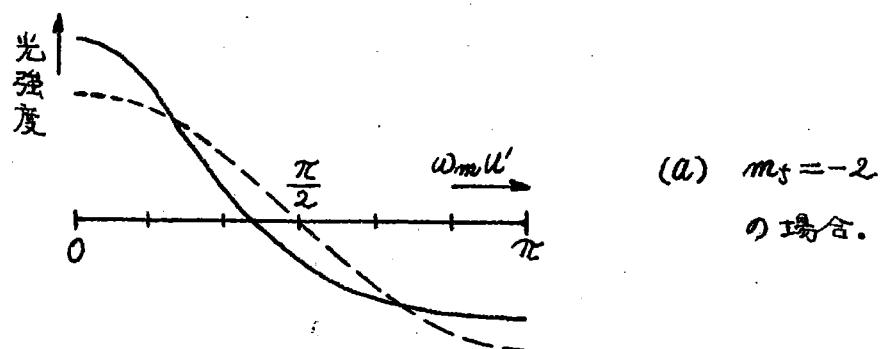
第2.8図 復調された图形の
コントラスト

5 重量が大なる程、Klin factor は大きさの値をとり、光実度が悪くなっていることがわかる。またナイフエッジの挿入位置に関しては γ が大なる程、すなわちナイフエッジが高周波側にある程光実度は悪くなり、特に $\gamma > 1$ ではこの傾向が著しい。一方、(2.11) で直流成分と信号成分である $m_f = 1$ の上に

$$\text{コントラスト} = \frac{2 \sum_{p=1}^{\infty} \sqrt{p} (m_f) \sqrt{p+1} (m_f)}{\sum_{p=-\infty}^{\infty} \{ \sqrt{p} (m_f) \}^2} \quad (2.15)$$

をコントラストとして考える*。同様くこれは m_f と γ に影響されるが各 m_f および γ に対して数値計算を行った結果を第2.8 図に示した。第2.8 図においてナイフエッジを $\gamma = 0$ の附近に置いた場

* コントラストは正確には $\frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$ で定義され、(2.15) は (2.11) で高周波の影響を無視したものとなつてゐる。



第2.9図 ナイフエッジを用いて $\chi \approx \omega_c$ のスペクトルを取除いたとき
変調指数と像面上の強度分布との関係。 $m_f = -\omega_c a_m$ 。

----- 歪分布および強度分布の基本波
—— 高調波の影響を考慮した実際の強度分布

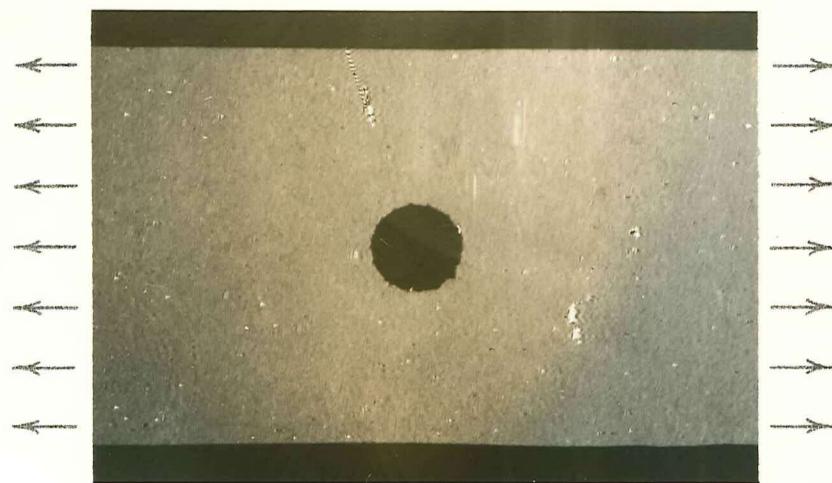
合が最もコントラストが高いことがわかり、そこから高周波側、低周波側のいずれへ移動してもコントラストは低下する。しかし $\gamma > 0$ の位置へ挿入位置を移動した方が低下の度合は著しい。

以上より図形の忠実度とコントラストの両者を共に考えた場合、ナイフエッジは $\gamma = 0$ あるいは $\gamma = -1$ の位置に挿入するのが最も良いことが結論される。

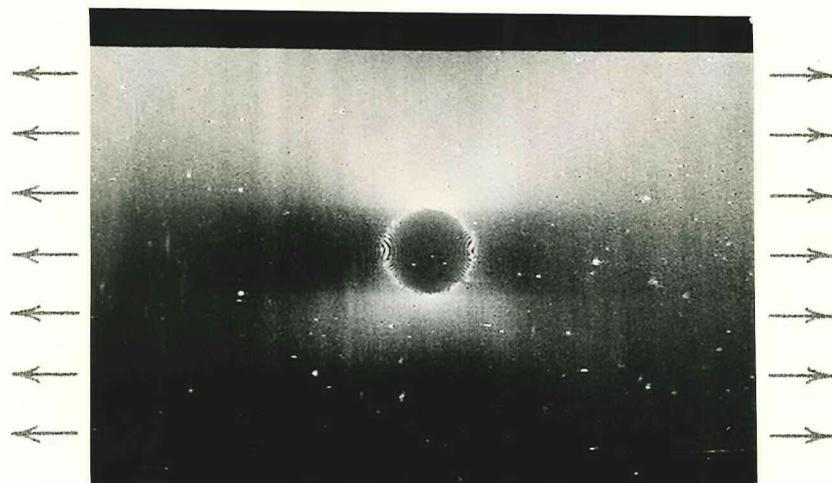
$\gamma = -1$ とした場合、すなわち $\varepsilon \geq \omega_c$ のスペクトルを取除いた場合、 $m_f = -2, -5, -10$ に対して (2.11) の強度分布を計算し、左右対称であるから $1/2$ 周期だけを描いたものが图2.9(a), (b), (c) である。图2.9图は图2.7图の $\gamma = -1$ の断面において $m_f = -2, -5, -10$ の強度分布を描いたものに相当し、荷重による変位が大きさ場合には高周波のために基本図形が変化している。 $\varepsilon > 0$ の部分では強度の振動が見られ、伸張部から圧縮部へ移り変る $\varepsilon = 0$ 附近で、強度は急に変化していることがわかる。

2.3.2 実験結果および考察

上に述べた理論的考察を確かめるために行った実験結果を以下に示す。その一例として 10本/mm の明暗格子を転写した厚さ 0.12mm のポリカーボネートフィルムを 70mm × 30mm の矩形に切断し、その中央に直径 6mm の内孔を穿った。格子線の方向はひ軸に平行とした。その後ひ軸方向から 1.5 Kg/mm^2 の一様な引張り荷重を加えて作成した試料による結果を图2.10に示す。



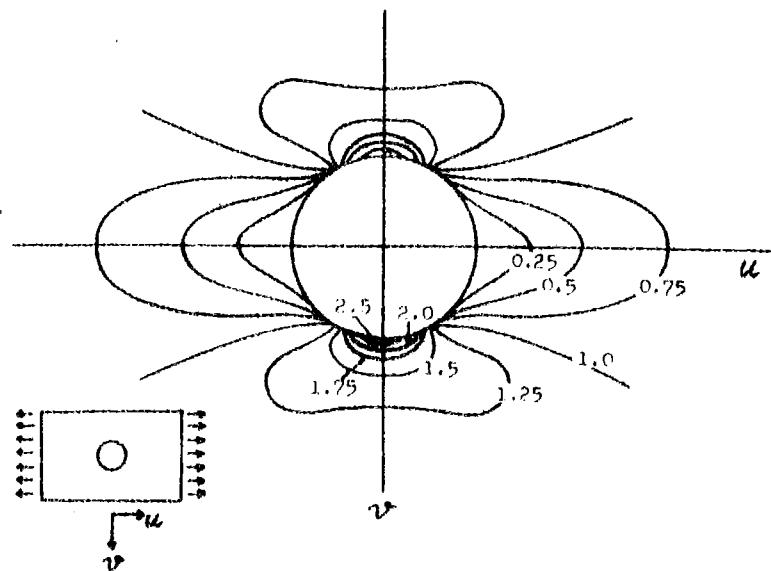
(a)



(b)

第2.10図 引張り荷重を加えられた円孔を有する平板の像。

- (a) ω_c とその側帯波のスペクトルがすべて投影レンズを通過した場合。
- (b) ナイフエッジを Fraunhofer の回折面に挿入して $\lambda \geq \omega_c$ のスペクトルを除外した場合。



第2.11図 一様引張り荷重を加えられた平板の内孔附近における
u方向の歪 ϵ_u 。内孔から十分離れた点の ϵ_u の値を 1 とした。

た。第2.10図(a)は投影レンズに入る ω_c とその側帶波のスペクトルをすべて通したときに得られたもので、歪による图形は観測されない。第2.10図(b)は Fraunhofer の回折面にナリフエッジを挿入して ω_c のスペクトルを取除いたときに得られた图形である。ここに ω_c は試料の平均周波数と考えた。

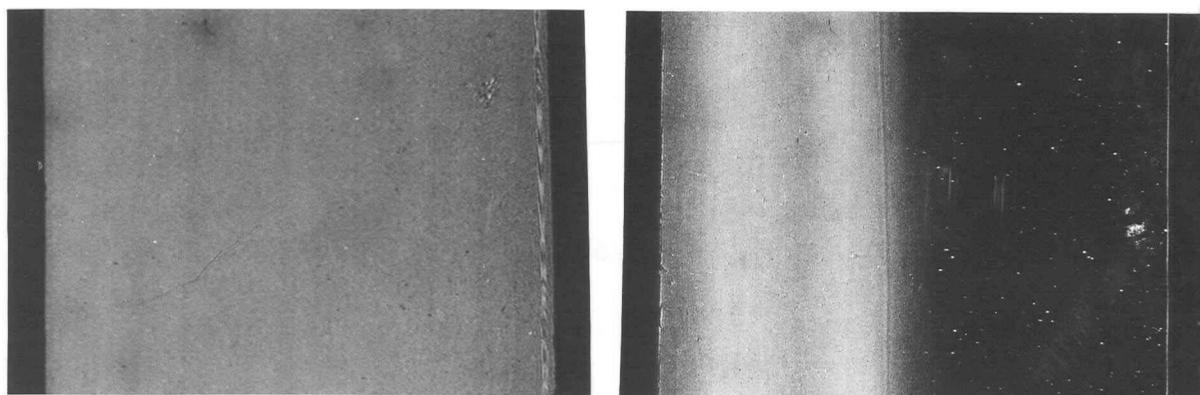
このような内孔を有する平板にかかる引張り荷重を加えた場合、 σ_{max} は内孔の線で作る σ_{max} は 30° である。ポリカーボネート樹脂の弹性限の荷重は約 5 kg/mm^2 であるから、加えた 1.5 kg/mm^2 の荷重によって試料はその全範囲にわたって弹性変形のみを生じていると考へられる*。いま弹性論から理論的に歪分布を求め、ポリカーボネート樹脂のボガソン比 $\nu = 0.35$ として以下の

* 詳しくは 93 頁参照。

歪 ϵ_u を計算し、その等しい点を連ねた曲線群を ϵ_u 図に示した。^{*} ϵ_u 図の图形で濃度が一定のところは ϵ_u 図の等歪曲線の形とよく一致しており、忠実度よく復調が達成されて歪の分布が光の強度分布として直視できることがわかる。

次に §2.2 で述べた試料 T₂ についての実験結果を示す。

ϵ_u 図 (a) は投影レンズに入る ω_c とその側帯波のスペクトルをすべて通したときに得られたもので ϵ_u 図 (a) と同じく一様な明かるさで変調波に基づくコントラストは生じていない。これに反して Fraunhofer の回折面にナイフエッジを挿入して $x \geq \omega_c$ のスペクトルを取除いたときには、先程と同じく图形が観測され、それを ϵ_u 図 (b) に示した。いま格子線に直角な方向

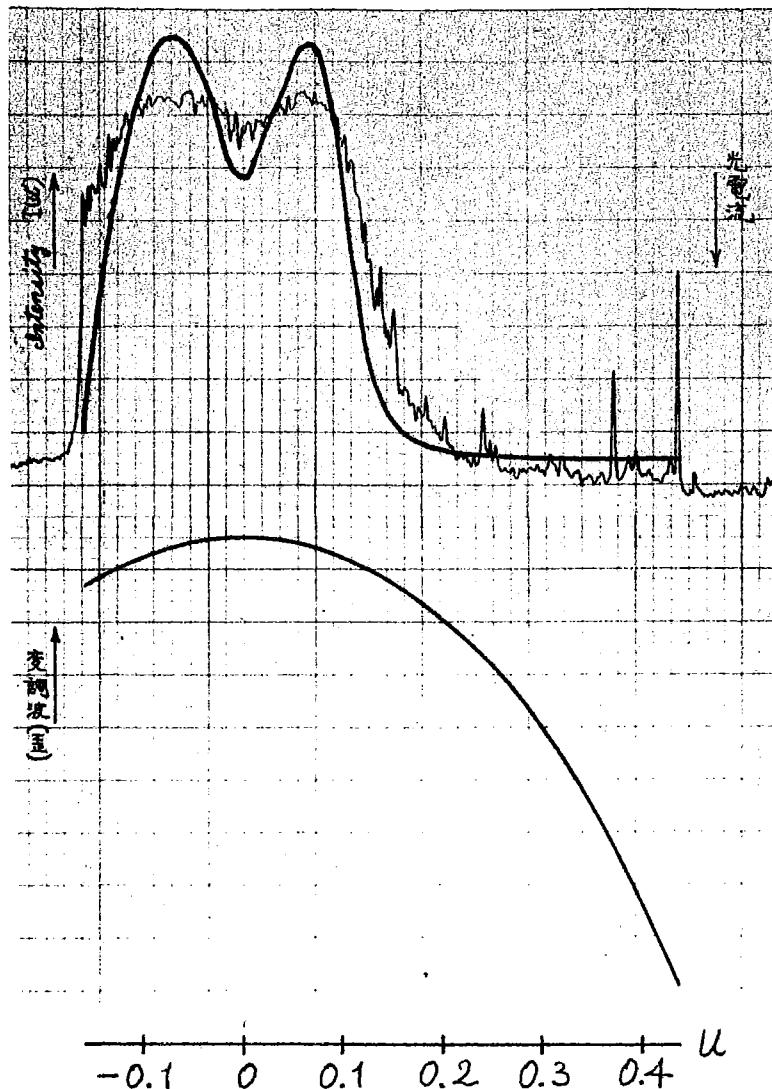


(a) ω_c とその側帯波のスペクトルがすべて投影レンズを通過した場合。

(b) $x \geq \omega_c$ のスペクトルをナイフエッジで取除いた場合。

ϵ_u 図 周波数変調をうけた試料 T₂ の像。格子線は縦方向である。

* 計算の詳細については §3.1 および §3.2 参照。



(a) 細線：図形を撮影したファイルを走査して得られた光電流曲線。

太線：光電流曲線より得られた強度分布。

(b) 試料Teの変調波。

図2.13 図 ナイフエッジを用いて得られた試料Teの像面上の強度分布。

にこれを、透過光量と記録された光電流との直線性を十分検討した microphotometer で走査した。得られた光電流曲線は図2.13 図(a)に細線で示されたものである。図形の撮影に用いた写真ファイルは富士ネオパン SS であるが、仮にそのカシマを 1 として光の強度に変換したものを図2.13 図(a)中に太線で示した。また同時に試料 Te の変調波と (2.8) および図2.3 表に基づいて図2.13 図(b)にグラフとして示した。この図にお

いて $u=0$ 附近で強度に振動が見られ、また $u=0.15$ 附近でその強度は急に変化している。この傾向は図2.9(6)と一致しており、この試料Teは図2.3表に示したとおり最大11.2%の歪があるから高調波の影響によって変化をうけ、変対度が悪く存在しているものと結論される。

上に示した実験において Fraunhofer 回折面に挿入されたナイフエッジの位置を ω_c とすると、これは次のように説明できる。いま変調波を $m(u)$ とすれば

$$\omega = \omega_c - \omega_c m(u) \quad (2.16)$$

の関係があることは図1.2 で既に述べた。いまナイフエッジを ω_c' なる位置に置けば ω_c との関係は

$$\omega_c' = \omega_c + \omega_c g \quad (2.17)$$

と書くことができる。ここに $g > 0$ はナイフエッジを ω_c よりも高周波側に置くことを意味し、 $g < 0$ は低周波側に置くことを意味する。(2.17) と (2.16) に代入して

$$\omega = \omega_c' - \omega_c \{ m(u) + g \}$$

を得る。この(2.18)と(2.16)とを対比して考えれば、搬送波の周波数を ω_c' と想えることによって $m(u) + g$ なるように定数 g を加えたものを測定することになる。ナイフエッジの挿入位置とその時得られる图形の変対度およびコントラストとの関係は図2.7図および図2.8図にすでに示し、 ω_c なる平均周波数以上のスペクトルを取除くのが最も良い方法であることを述べた。図2.10図の実験例のように差はすべて伸びて $m(u) > 0$ なるような場合にはもとの ω_c の位置は x 軸上で平均周波数よ

りも高周波側であり、 $\beta > 0$ なるようにナイフェッジを挿入した場合に相当し、忠実度が非常に悪くなると共にコントラストも急に低下する。したがってナイフェッジを低周波側に移動させて平均周波数のところまで持ってくる必要がある。その平均周波数を ν ま搬运波の周波数とみなせば (2.17) で示される $\beta < 0$ なる定数を加えて β/ν をその間に含むようになった $m(u)$ + β を測定することになり、良好な測定が可能となる。

2.4 光学模による復調

§2.3では不透明なマスク、すなわちナイフエッジと鋭い pass-bandを持つ band-pass filterとして用い、復調を達成したが、ここでは§1.3において述べた光学模による復調についてさらに詳細な検討を加え、実験結果と共に考察する。

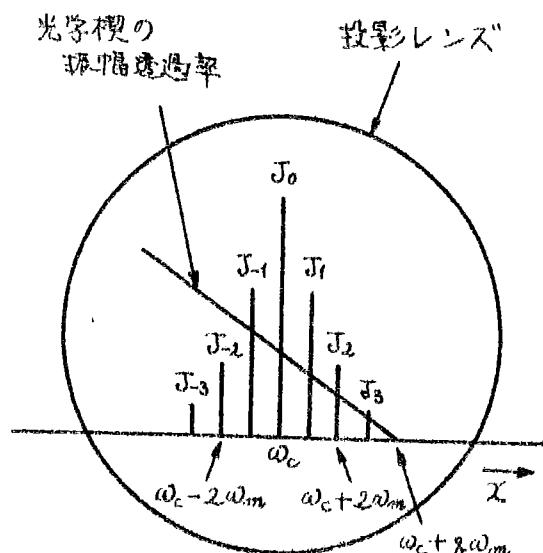
2.4.1 復調の忠実度

変調波を $a_m \omega_m \cos \omega_m t$ とし、光学模を第2.14図に示すごとく挿入した場合の像面上の強度分布は近似的に(1.57)で示された。しかし(1.57)では無視した(1.56)の $m \geq 2$ の項である高調波のために復調された変調波は実際のものと大きく異なってくる。

ここでは復調して得られ

た歪分布を示す图形の忠実度とコントラストについて
§2.3のナイフエッジを用い
た場合と比較対照して検討する。

光学模の透過率分布を
よび「使用記号など」は §2.3
でこれまでのものと同じ
とする。ここで復調して
得た图形の忠実度を調べ
るために §2.3で述べた、



第2.14図 光学模を挿入されたスペクトル面。 J_0, J_1, \dots はスペクトルの振幅であり、 $J_0(m_3), J_1(m_2), \dots$ の略。

Klirr factorを計算する。光学楔を用いたときの Klirr factor は (1.56) および (2.13) より

$$K.F. = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} \left\{ \sum_{p+m < g} J_p(m_f) J_{p+m}(m_f) (p-g)(p+m-g) \right\}^2}}{\sum_{p+m < g} J_p(m_f) J_{p+1}(m_f) (p-g)(p+1-g)} \quad (2.19)$$

となる。一方、像面上の強度分布 (1.56) のコントラストは (2.15) で示したのと同じ定義によつて

$$\text{コントラスト} = \frac{2 \sum_{p+1 < g} J_p(m_f) J_{p+1}(m_f) (p-g)(p+1-g)}{\sum_{p < g} \{ J_p(m_f) (p-g) \}^2} \quad (2.20)$$

となる。(2.19) および (2.20) は変調指數 m_f と光学楔の挿入位置 g によってその値は変化するが、 $m_f = -0.5$ やび -2 について計算を行つた結果を表2.4表に示した。これを計算する際に g の値として $m_f = -0.5$ に対しては $g = 3$ 、 $m_f = -2$ に対しては $g = 6$ と選んだが、これは次の理由による。光学楔の透過率は ± 1.3 で述べたごとく $x \geq \omega_c + g\omega_m$ でゼロとなるが、いまやべてのスペクトル全体に光学楔が作用するようにする。すなわち表2.14図に示したスペクトルのうち、最大振幅を持つ $J_0(m_f)$ の 1% の振幅値を持つスペクトルの位置に光学楔のゼロ点 g がくるように選んだ。また表2.4表にはナイフエッジを $g = -1$ に置

表2.4表 周波数変調をうけた格子から得られた信号像の Klirr factor とコントラスト。

変調指數 m_f	-0.5		-2	
	光学楔	ナイフエッジ	光学楔	ナイフエッジ
Klirr factor	0.042	0.084	0.089	0.357
コントラスト	0.001	0.251	0.632	1.133

りて $\omega_m u$ のスペクトルを取
除いた場合の Kline factor と
コントラストの値も (2.14) お
よび (2.15) にしたがって計
算して備記した。

$m_f = -2$ で $\beta = 6$ のごとく
光学楔を挿入したときに得
られる像面上の強度分布と
(1.56) にしたがって計算し
たものと Fig. 2.15 図に示した。
この曲線の Kline factor が、

Fig. 4 表の 0.089 に相当している。Fig. 4 表のうち光学楔を
用いた場合とナイフエッジを用いた場合の Kline factor を比較し
てみると、光学楔を用いた場合の方が Kline factor の値は、は
るかに小さく、容実に復調されることがわかる。特に $m_f = -2$
のときはナイフエッジで 0.357 であったものが 0.089 となり、著
しく改善される。したがって大きい変位が導入されるような
場合には光学楔を用いれば非常に有益である。一方、 $m_f = -0.5$
のとき、コントラストは光学楔を用いた場合には 0.001 まで下
する。実際上 0.01 以下のコントラストを感知、測定することは
ほとんど不可能であり、小さい変位しか加わらないような場
合には光学楔を用いるのは望ましくない。小さい変位しか加
わらない場合にはナイフエッジを用いる方法は忠実度が高いの
で、この方を用いるべきである。

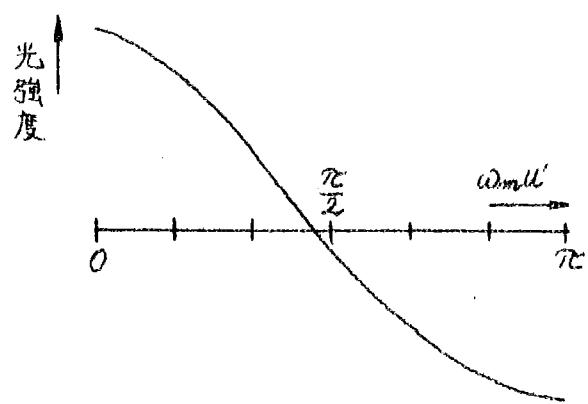


Fig. 2.15 図 光学楔を用いた場合の
像面上の強度分布。

$$\text{変調波: } a_m \omega_m \cos \omega_m u$$

$$m_f = -\omega_c a_m = -2$$

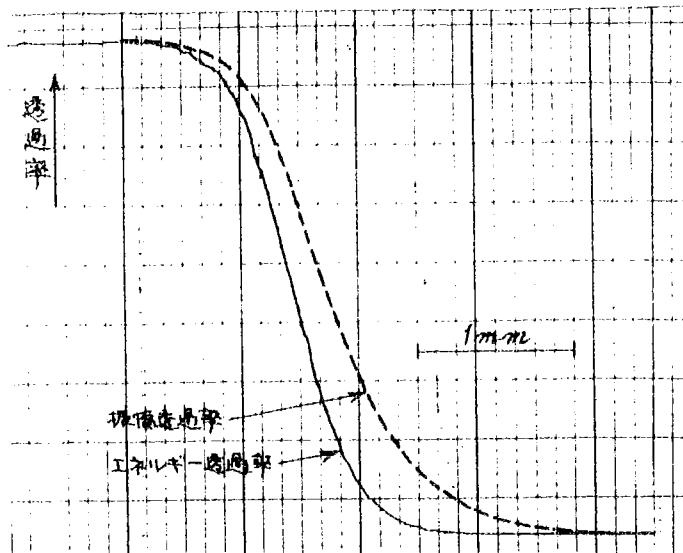
以上のように光学楔を復調素子として用いれば忠実度が改善されることがわかつたが、コントラストと兼ね合わせて考へれば、大きい変位が導入されるような場合には復調素子として光学楔を用いるのがよく、また小さい変位しか加わらないような場合にはナイフエッジを用いるのが良い方法であると結論される。

2.4.2 光学楔の作成

本研究に必要な光学楔はその振幅透過率が直線的に変化するものであり、またその幅は側帯波の周波数程度のもので非常に狭い。したがってここでは特にその作成を行った。歪の程度によって側帯波の広がりは異なるので、数種の幅を持つものを作成することとし、二つの方法をとった。

その一つは *straight edge** を焦点はずれにして写真撮影する方法であり、得られたネガフィルムを光学楔として用いた。写真フィルムを光学楔として用いたときに写真粒子による光の散乱をできるだけ避けるために使用フィルムとしては微粒子のものが望ましく、また到達濃度の高いものを用いれば透過率0~1間の範囲が広いので光学楔としての利用度が良い。したがってここでは微粒子、硬調である富士ミニコピーフィルムを用い、その指定現像液であるコピーナーレによって現像を行った。

*ナイフエッジのことであるが、復調素子として用いたナイフエッジとの区別を明確にするために *straight edge* と呼ぶ。

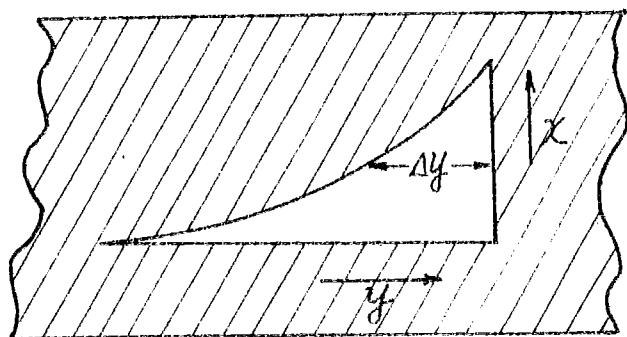


第2.16図 Straight edge の像を焦点外で撮影して作成した光学楔の透過率。

それから算出した振幅透過率を示している。この振幅透過率の直線部を光学楔として用いる。

他の作成方法は次のようである。第2.17図に示したように不透明物体中に適当な形の窓をあけ、下方から incoherently に照明して y 方向に等速度で走る。又 x 方向には窓が通過することによって Δy の大きさに比例した光量を透過させるが、いまこの不透明物体面に焦点を合わせて窓の通過する間、露光をすれば不均一フィルムは濃度差を生じ、

光学楔の幅は焦点はすれの程度および露出時間によつて変化するが、その組合せを適当に変えて各種撮影し、その透過率曲線を調べて望ましいものを選んだ。第2.16図はその一例で、実線が microphotometer で測定したエネルギー透過率であり、破線は



第2.17図 光学楔作成のために用いた光量調節方法。不透明物体中にあけられた窓を下方から照明して等速度で y 方向へ走る。

光学楔が作成され
る。作成された光
学楔の透過率分布
はこの窓の形状と
使用フィルムの特
性に影響されるが、
フィルムは先のと
同じ富士ミニユニー
フィルムを用い、
窓の形状を撮影さ
れたフィルムの透

過率曲線を参考にしながら少しずつ変えて、振幅透過率が直
線的な変化をする光学楔を得た。窓の形状はほぼ 図2.17 に
示したもののが良好な直線関係を示し、得られた光学楔の透過
率曲線を 図2.18 に示した。

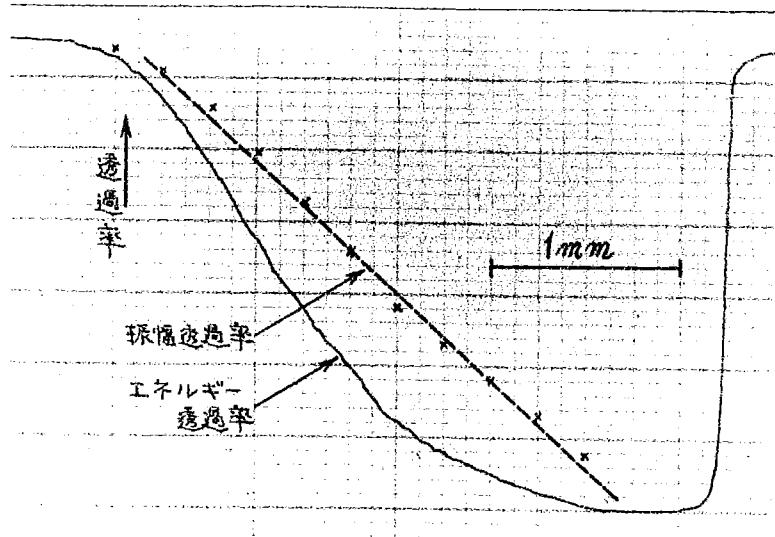


図2.18 不透明物体中にあけられた窓
を使用して作成した光学楔の透過率。

2.4.3 実験結果および考察

試料T2による一次のFraunhoferの回折像、すなわち w_0 とその
側薄波のスペクトルは 図2.19 に示したとおりであり、焦点距
離 $f_2 = 300\text{mm}$ のコンデンサーレンズ C_2 によって 0.92mm の広がり
を持つている。ここで 図2.20 に示した勾配の急な透過率を
持っている幅の狭い光学楔と、振幅透過率が0.5のところを
回折光の広がりの中心へ持ってくるように回折面に挿入した。

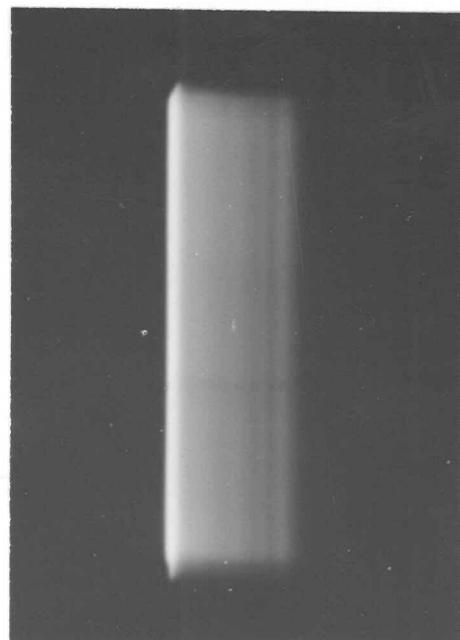
そのときに得られた像を第2.21図に示した。回折面に何も操作を加えなかつて第2.12図(a)とくらべると変調波に基づく图形が現われてあり、光学楔を用いても復調が可能であることがわかる。图形を撮影したフィルムを格子線に直角なら方向に microphotometer で走査したときに得られた光電流曲線が第2.22図

(a)の細線で示したものである。第2.3の第2.13図で行、石と同じ様に写真フィルムのガ

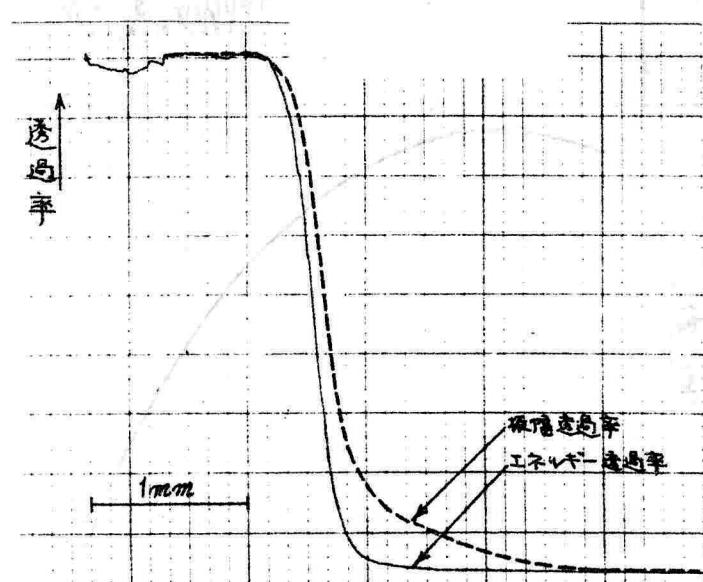
ンマミナとして像面上の強度分布に変換したもののが第2.22図

(a)の太線で示したものである。第2.22図(b)には試料Tの変調波を描いた。

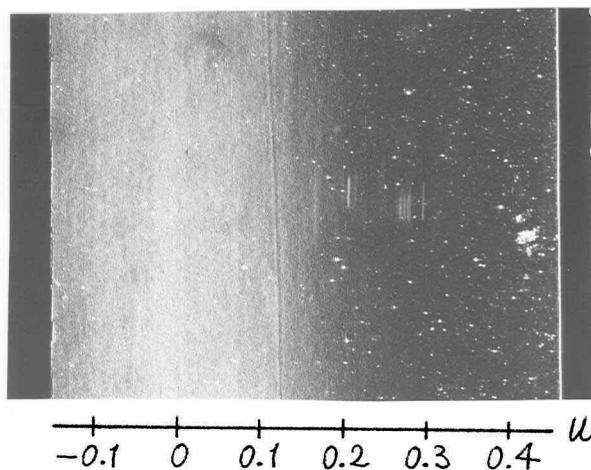
第2.20図の光学楔より幅の広い第2.16図にその透過率を示した光学楔を回折光がすべて



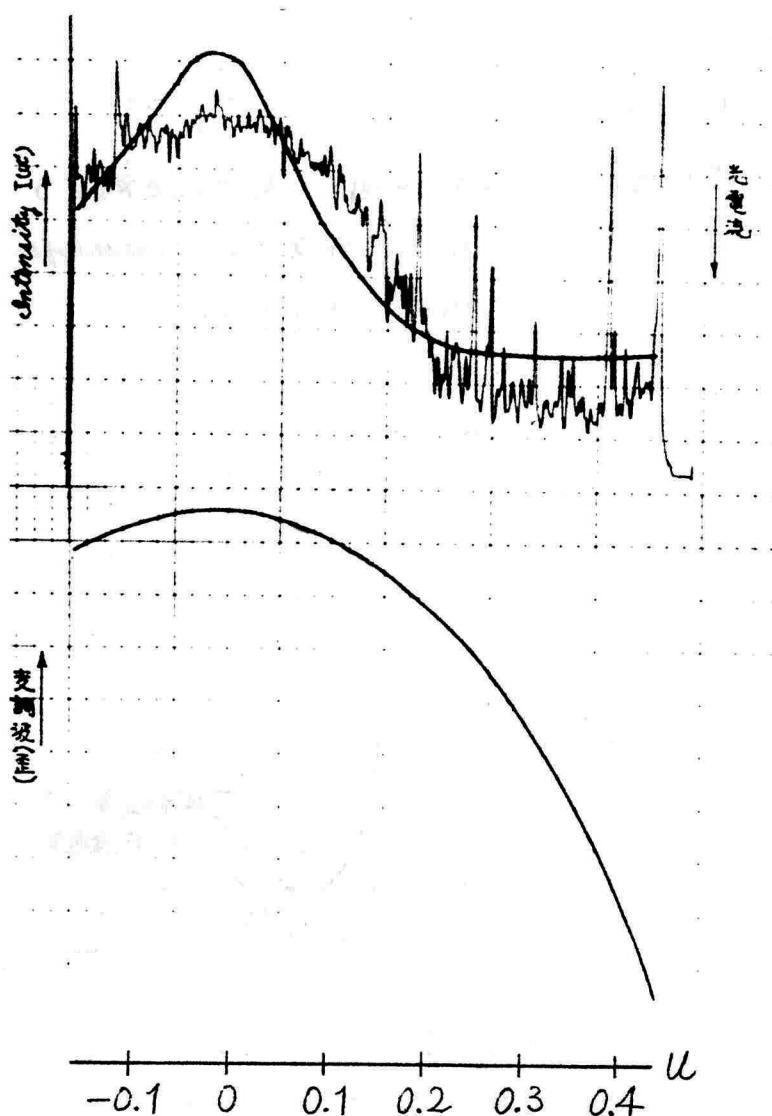
第2.19図 周波数変調をうけた試料Tによる Fraunhofer 回折像の広がり。



第2.20図 straight edge の像と焦点外で撮影して作成した幅の狭い光学楔の透過率。



第2.21図 幅の狭い光学楔を
Fraunhofer回折面に挿入して
得られた試料Teの像。
格子線は縦方向である。

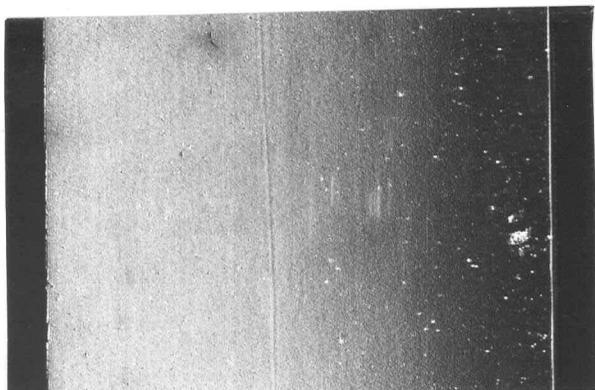


(a) 細線: 図形を撮影したフィルムを走査して得られた光電流曲線。

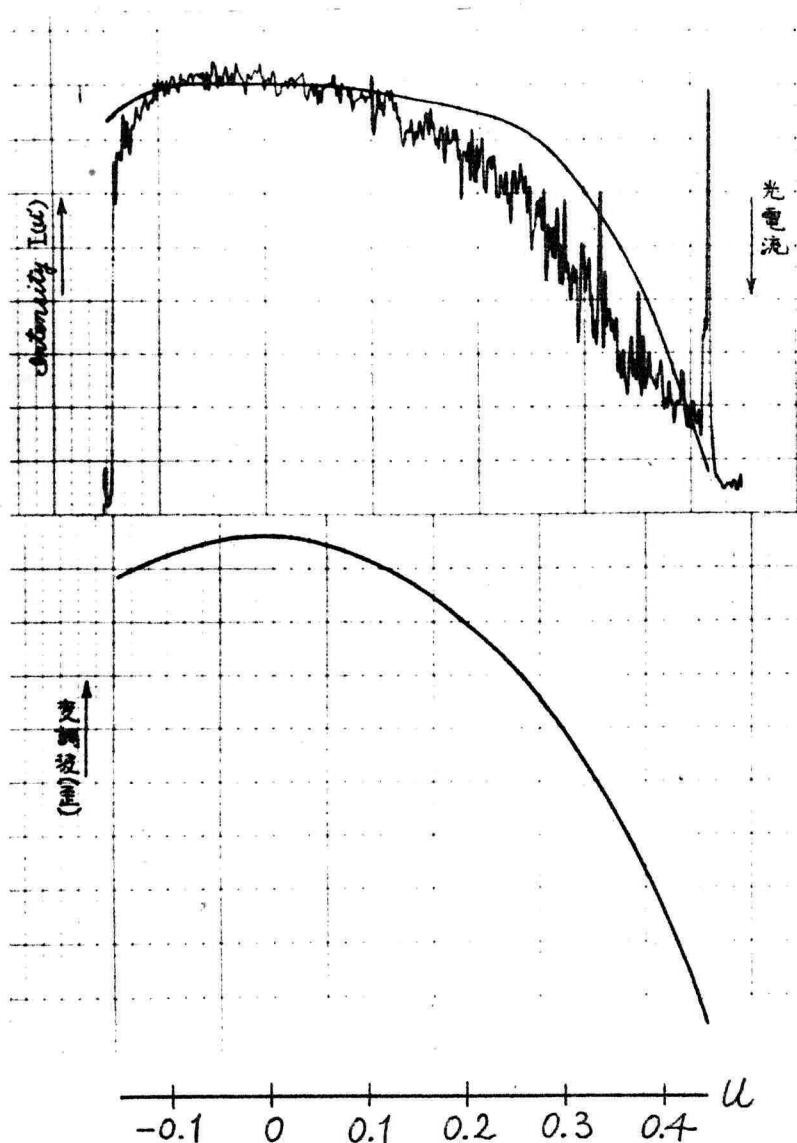
太線: 光電流曲線より得られた強度分布。

(b) 試料Teの変調波。

第2.22図 幅の狭い光学楔を用いて得られた試料Teの像面上の強度分布。



第2.23図 幅の広い光学楔を
Fraunhofer回折面に挿入して
得られた試料Teの像。
格子線は縦方向である。



(a) 細線: 図形を撮影したフィルムを走査して得られた光電流曲線。

太線: 光電流曲線より求めた強度分布。

(b) 試料Teの変調波。

第2.24図 幅の広い光学楔を用いて得られた試料Teの像面上の強度分布。

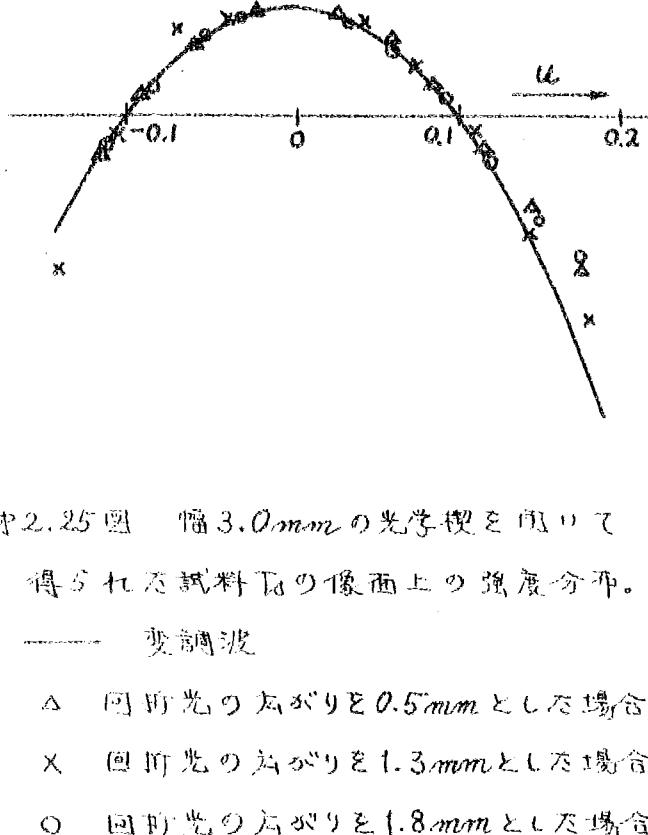
その透過率の直線部に入るように挿入したときに得られた同じものをそれぞれオ2.23図およびオ2.24図に示した。

ナイフエッジを用いた場合の強度分布とオ2.22図(a)のそれとを比較してみると、光学楔を用いた場合は光強度の振動が見られなくなっている。光強度の変化も比較的ゆるやかとなって変調波に近づけている。オ2.24図(a)の強度分布はさうに変調波に近づけている。これは次のように説明される。オ2.20図の光学楔は勾配がきつく、その直線部はスペクトルの広がりの範囲をすべて被っていない。したがって存在するスペクトルの空間周波数に対する透過特性がナイフエッジのようにゼロあるいは1のままで残っている部分がある。これに反してオ2.16図の光学楔はその直線部によってスペクトルをすべて被うことができているために忠実度が上がっているものと解釈される。

以上はだいたいの傾向を知るために実験例であるが、用いた写真フィルムのH-D曲線を使用波長、露出時間など実験条件と全く同じにして正確に作成し、光学楔も十分スペクトルの広がり内にあるようにして定量的に行った実験例を示す。用いた試料はオ2.3表に示したとおり直径の大きさり内筒を使用したためにその範囲も小さく、また撮影された格子の焦点はそれの影響もほとんどないと考えられるものである。使用した光学楔はその透過率曲線をオ2.18図に示したものである。ここでは光学楔の勾配と幅を変化させる代りに顕微鏡対物レンズを光学的筒長附近の結像をするように使用して回折光を拡大

し、その拡大率を変えて相対的に光学楔の勾配と幅を変える。光学系としては、先の第2.1図において *Fraunhofer 回折面* と投影レンズ間に顕微鏡対物レンズが加わり、回折面の顕微鏡対物レンズによる共軸面が光学楔の挿入面となるのみで、結像関係は同じである。いま回折光の広がりを拡大してそれを 0.5mm , 1.3mm および 1.8mm とした。したがってこの回折光全体は第2.18図で示される幅 3.0mm の光学楔で十分被うことができる。そのように光学楔を挿入したときに複調されて現われた像面上の強度分布を先に述べたごく正確に写真測光して得られた結果を試料 T₀ の複調波と共に第2.25図に示した。測定は相対強度について行われるので第2.25図においては強度を表す縦軸の倍率を揃えるために $u=0$ および $u=0.1$ で複調波と一致するように換算して打点した。

第2.25図によれば、いずれもよく複調波と一致しており、



第2.25図 幅 3.0mm の光学楔を用いて得られる試料 T₀ の像面上の強度分布。

— 複調波

- △ 回折光の広がりを 0.5mm とした場合
- ×
- 回折光の広がりを 1.3mm とした場合
- 回折光の広がりを 1.8mm とした場合

第2.25図に示した。測定は相対強度について行われるので第2.25図においては強度を表す縦軸の倍率を揃えるために $u=0$ および $u=0.1$ で複調波と一致するように換算して打点した。

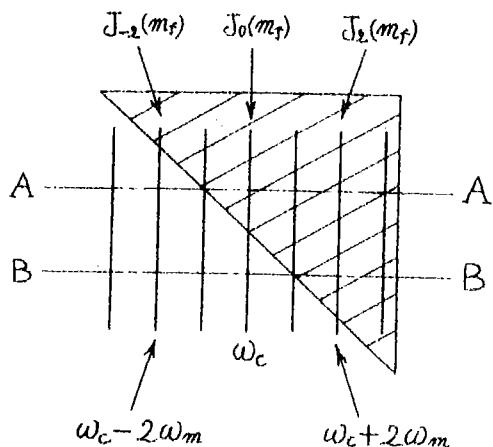
わずかに見られるすれば、作成した光学楔の振幅透過率の直線性からのずれ、散乱光の影響、試料と作成に使用した円筒のゆがみおよび測光誤差などの要因に基づくものと思われる。したがって振幅透過率が直線的に変化する光学楔を Fraunhofer の回折面に全スペクトル範囲を被うように挿入すれば、忠実に変調波すなわち歪の分布が復調されることがわかる。

2.5 面積型楔による復調

§2.4で"は又軸にとって振幅透過率が直線的に変化する光学楔を Fraunhofer 回折面に挿入して忠実な復調を達成した。線光源は互に *incoherent* な点光源が $\pm y'$ 方向に並んで"いると見なされる。したがって線光源による回折像は考えた各点光源要素の共轭な位置で $\pm x$ 方向に並んで"いるために、一例を §2.19 図に示したとおり矩形状の広がりを持つ。ここに §2.26 図に示したように、不透明なマスクの形によって面積的に回折スペクトルの各空間周波数に対する透過光量を調節しても復調が可能である。このようなマスクは回折スペクトルの各周波数に対する透過光量を直線的に減じて"いるものであるから面積型楔と呼び、以下に忠実度、コントラストなどについて理論的、実験的に考察する。

2.5.1 復調理論

回折格子の透過率分布(1.30)、歪分布を表わす変調波(1.41)および使用記号などはすべてこれまでのものと同じとする。§2.14図に示したスペクトルはその振幅を表わしたものであるが、実際に現われる回折像はスリット像の広がったもので、その様子を §2.26 図に示した。ここで斜線を施して示したようにその線が直線である面積型楔を図のよう Fraunhofer 回折面に挿入する。スリットは §2.1で"考案したように *incoherently*



第2.26図 Fraunhofer回折面に挿入された面積型楔。 w_c などはスペクトルの位置を示し、 $J_0(m_f)$ などはその振幅を示す。

に照明されているが、互に独立な点光源がスリット方向に並んでいると想えられ、この各点光源の輻位置で回折像は左右に並んでている。いま例えば断面AAを考えると、それはナイフエッジが $w_c - w_m$ の位置にある場合に相当し、同じく断面BBならば $w_c + w_m$ の位置にある場合に相当する。

したがって面積型楔は第2.26図の上方から順次考えれば、ナイフエッジを順次移動させてその pads-band を変えたときに得られる像面上の各々の強度分布を組み合わせたものに等しい。

ナイフエッジの位置と得られる像面上の強度分布との関係は、すでに §2.3において求め、それは (2.11) で示された。面積型楔を用いたときの像面上の強度分布はこの強度分布を上に述べたごとくナイフエッジの位置 g について加えて合わせて

$$\begin{aligned}
 I(u') &= \sum_{g=g_1}^{g_2} \left[\sum_{p=-\infty}^p \{ \bar{J}_p(m_f) \}^2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \sum_{p+n=-\infty}^p \bar{J}_p(m_f) \bar{J}_{p+n}(m_f) \cos n\omega_m u' \right\} \right] \\
 &= \sum_{g=g_1}^{g_2} \left[\sum_{p=-\infty}^p \{ \bar{J}_p(m_f) \}^2 \right] \\
 &\quad + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sum_{g=g_1}^{g_2} \left\{ \sum_{p+n=-\infty}^p \bar{J}_p(m_f) \bar{J}_{p+n}(m_f) \right\} \cos n\omega_m u' \right] \quad (2.21)
 \end{aligned}$$

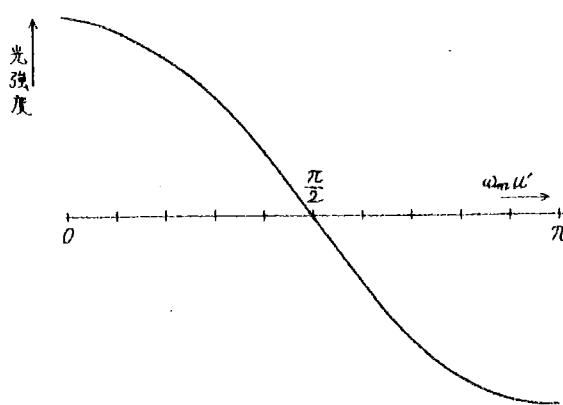
となる。この (2.21) を見ると整調波 $\cos n\omega_m u$ に対応した

$n=1$ の基本波图形が現われてあり、復調が達成されていることがわかる。係数が複雑であるから、このまゝでは高調波の影響によって基本波图形がどのように変化するか判別しにくいいので、いま一例として $m_f = -2$ および $g_1 = -2, g_2 = 2$ として (2.21) の強度分布を計算した。その結果を図に描いたものが第2.27図である。ここに $g_1 = -2, g_2 = 2$ は第2.26図の面積型楔が $\omega_c - 2\omega_m \sim \omega_c + 2\omega_m$ の範囲を被うように置くことを意味している。

面積型楔を用いた場合の強度分布 (2.21) の Klipp factor は (2.13) の定義にしたがって

$$K.F. = \frac{\sqrt{\sum_{m=2}^{\infty} \left[\sum_{\ell=0}^{g_2} \left\{ \sum_{p+n=-\infty}^{\ell} J_p(m_f) J_{p+n}(m_f) \right\} \right]^2}}{\sum_{\ell=g_1}^{g_2} \left\{ \sum_{p=1}^{\ell} J_p(m_f) J_{p+1}(m_f) \right\}} \quad (2.22)$$

であり、また第2.32



第2.27図 $\omega_c - 2\omega_m \sim \omega_c + 2\omega_m$ 内を被う
ような面積型楔を用いたときの像画
上の強度分布。横軸は直流成分の値
のところへ引いた。

$$\begin{aligned} \text{変調波(歪)} \quad & a_m \omega_m \cos \omega_m t \\ m_f = -\omega_c, a_m = -2 \quad & \end{aligned}$$

定義したコントラストは

コントラスト

$$= \frac{2 \sum_{\ell=g_1}^{g_2} \left\{ \sum_{p=1}^{\ell} J_p(m_f) J_{p+1}(m_f) \right\}}{\sum_{\ell=g_1}^{g_2} \left[\sum_{p=-\infty}^{\ell} \{ J_p(m_f) \}^2 \right]} \quad (2.23)$$

となる。第2.27図の強

度曲線の場合、すなわち $m_f = -2, g_1 = -2, g_2 = 2$ の場合の Klipp factor およびコントラストは (2.22) および

(2.23)にしたがって計算を行ひ、その結果を表2.5表に示した。

表2.4表に示したナイフエッジを用ひて復調を行ったときの Klirr factor およびコントラストと表2.5表のこれとを

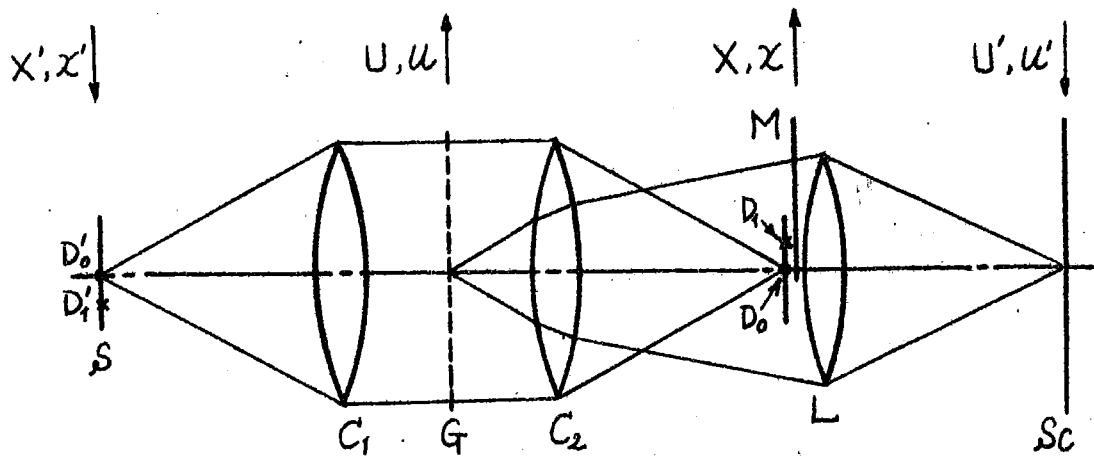
比較すれば、面積型楔を用いたときはナイフエッジを用いたときよりもコントラストは減少するが Klirr factor は小さくなり、忠実に復調できることがわかる。このことは表2.27図の強度曲線と表2.9図(a)のこれとをくらべても明らかで、面積型楔を用いた方がその強度分布は変調波である余弦曲線に近づき、ほど等しくなって来ている。

表2.5表 周波数変調とうけた格子から得られた信号像の Klirr factor とコントラスト。

変調指数 m_f	-2
復調素子	面積型楔
Klirr factor	0.036
コントラスト	0.664

2.5.2 面積型楔を改良した方法による復調

面積型楔の原理はナイフエッジをスペクトル面で移動させたものに相当したが、これと同じことは次のようにしても可能である。表2.28図に示したように、いま光源スリットの幅を広げ、このスリットは *incoherently* に全面一様強度で照明されていふとする。光源上 $x'=0$ にある D'_0 で示された点に垂直な線光源要素による一次回折光の中心がスペクトル面上で D_0 の位置にあるとする。このとき $x'=\Delta x$ にある例えは D_1 で示した線光源



第2.28図 光源幅を持つた測定光学系。

S: 矩形光源 C₁, C₂: コンデンサーレンズ L: 投影レンズ

M: マスク SC: スクリーン G: 試料の回折格子

要素による一次の回折光の中心は D_0 から ΔX だけ離れた D_1 となる。光源は *incoherent* であるから、その位置を連続的に変化している独立な線光源要素の集まりと見なされ、図示したようにナイフエッジを挿入すれば各線光源要素の位置に応じて相対的にナイフエッジの位置が変化したものとなり、ナイフエッジを移動させたのと同じ効果が得られる。このようにすればその原理は面積型楔と全く同じであり、忠実度よく復調できる。この場合、面積型楔の幅に相当するものは光源幅であるが、実験上それを調節する必要はない。例えば光源Sが $X' > 0$ の方向に広がっているとしても、 X' が大きければそこにある線光源要素によるスペクトルはすべてナイフエッジによって遮へられ、結像に関与しない。これより光源幅はナイフエッジの位置によって調節されることばかり、その調節は容易である。

また以下に述べる方法によつても面積型楔と同じ効果が得られる。これまではずつて単色光であるたゞ、ここで波長幅を持つてゐる光を用いた場合を考へる。光源は線光源としたとき Fraunhofer 回折面上で観測されるのは波長によつてその位置を異にする。すなはち回折格子によつて分光される。いま説明の簡単のため光源中入₁く入₂く入₃の三波長の光に注目する。試料によつて生じる回折光の ω_c の位置を Fraunhofer 回折面の実座標 X 軸上に描けば图2.29のようになる。例えばナイフエッジを図示した位置に置けば、波長入₁および入₂の回折光に対してナイフエッジは高周波側にあり、波長入₃のものに対しては低周波側にあり、相対的にナイフエッジの位置が異つてゐる。光源に含まれてゐる全波長について考へればナイフエッジを回折面で連続的に移動したものに等しくなつてあり、波長が異なれば光は *incoherent* であるから像面で各波長によつて生じた图形の強度は加え合はれ、波長依存性のない写真フィルムあるいは検知器にての強度を測定すれば面積型楔の場合と全く同じとなる。

前述した方法は光源幅を広げて ω_c の位置の広がりを得たが、後の方法は用いる光の波長幅を持たせて同じことを行つたも

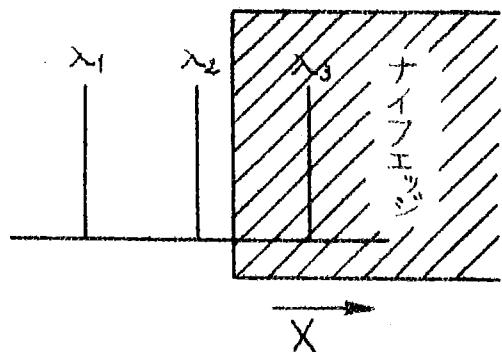


图2.29 図 波長幅を持つ線光源を用いた復調。図は波長入₁、入₂、入₃の光による ω_c の位置を示す。

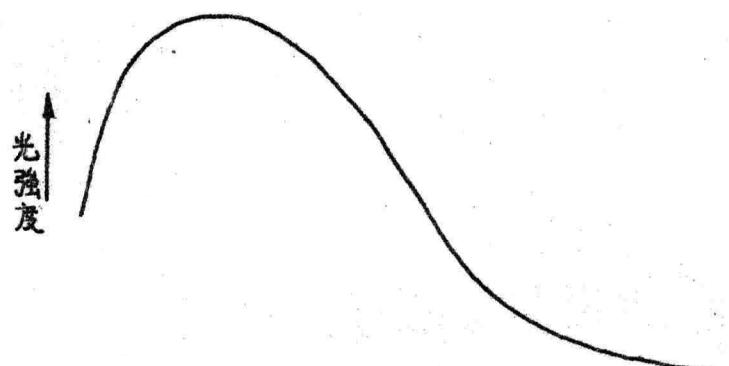
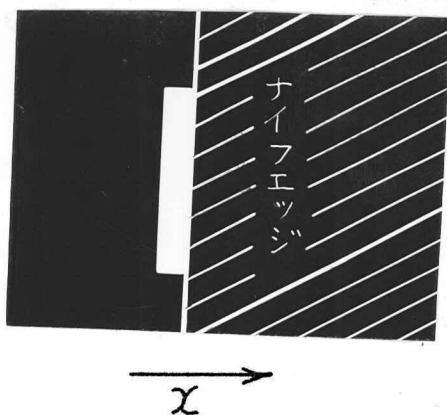
のである。したがって光源の各波長に対する強度は使用する全波長について同じであることが必要であり、また短波長側はその波長分布曲線が矩形的な立ち上りを持たなくてはいけない。この場合、面積型楔の幅は波長幅となるが、光源幅を広げた場合と同様に実験上波長幅を調節する必要はなく、ナイフエッジの位置によって行われる。

以上の二方法によれば単色の線光源を用いるよりも光学系を非常に明るく使用でき、格子線のコントラストが悪くて回折光が弱いような場合に有利となる。

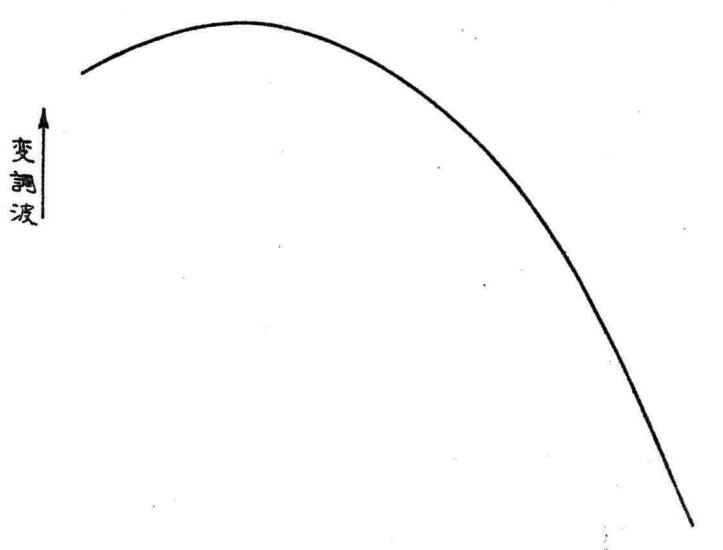
2.5.3 実験結果および考察

以下に示す実験例の試料は第2.3表のT₂で、光源幅を広げ、ナイフエッジを挿入する方法によって面積型楔の原理を達成した。第2.1で述べたごとく本実験装置にありて、光源面はほとんど *incoherently* に照明されている。ここで光源面を一様に照明するために光源面上に結ばせる水銀灯の像はやゝ焦点はずれとした。一次回折光のマスク状態を第2.29図に示したが、この写真は極硬調に仕上げてあるために、一つの線光源要素による回折光を考えれば第2.19図に示した回折光の左右にある最大強度のみが現われており、それが光源の広がりだけ撮影されている。第2.29図に示されている部分の光源幅は 0.56 mm であり、回折面ではコンデンサーレンズ C₁ および C₂ の組合せによって 0.84 mm に拡大されている。したがって図で

図2.30 図 差がりを持った光源を
用いたときのマスク状態。



(a) 写真測光によつ
て求めた強度分布。



(b) 試料Teの変調波。

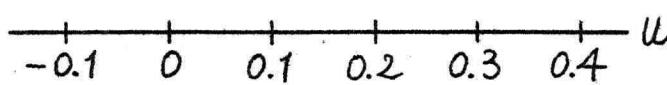


図2.31 図 幅を持った光源とナイフエッジを組合わせて面積型楔の
原理を達成して得られた試料Teの像面上の強度分布。

最も左の線光源要素について考えれば、回折光はそこから右へ約0.92mmの広がりを持っているのでナイフェッジによってその高周波側の一部はマスクされている。ナイフェッジの端にある線光源要素については、そのほぼ全部のスペクトルがマスクされ、左への広がりはほとんどないと考えられる。したがって光源幅は約0.56mmで、本実験では通常を2.1で示したごとく幅20μの光源スリットを用いているから、この場合光学系は約30倍の明るさを持っており、像の撮影は低感度フィルムで可能であった。

像面上の強度分布を写真測光して得た結果を写2.31図(a)に示し、比較のためにこの試料Tcの変調波を写2.31図(b)に描いた。この(a)および(b)を比較してみると $\mu > 0.25$ ではやや変調波の形とずれてきているが、ナイフェッジを挿入したときに得られた強度分布写2.13図(a)と対比して考えてみると光強度の振動が見られなくなっている。また $\mu = 0.15$ 附近の強度変化もゆるやかとなって変調波に近づいており、ナイフェッジを用いた場合よりも忠実に復調できていることがわかる。

このように面積型楔を用いた方法、あるいはそれを改良した光源幅を広げる方法などによる復調は、ナイフェッジを用いたものよりも忠実度が高いたが、面積型楔は専らその製作は必要でなく、単にナイフェッジを傾ければよりの方法としても簡単である。

2.6 色差による復調

これまでの復調方法は、変調波すなわち歪の分布を試料の像面上に光の強度分布である歪图形として取出し、測定を行うものであった。ここでは以下の歪图形を色差として取出す方法について検討を加える。

2.6.1 復調の原理

いま説明の簡単のために光源は二つの波長入₁および入₂のみを含んでおり、入₁ < 入₂とする。Fig. 2.29 図で示したように Fraunhofer 回折面で観測される ω_0 の位置は波長によって異なり、入₁、入₂が十分離れておれば入₂のみに光学楔を挿入するなど種々 spatial filtering を施すことができる。その結果、波長入₂の光による強度分布が像面上に生じる。波長入₁の光による ω_0 とその側帯波は回折面で何ら操作を加えられることなく、投影レンズを通過するために、一様強度の入₁なる波長の色を試料の像全面に与える。したがって像面では波長入₁の色の上に波長入₂の色が加わるが、波長入₁の色の強度は試料像全面にわたって一様であり、波長入₂の色は歪分布に応じて強度分布を持っているので、混合色となるものには色差が生じる。

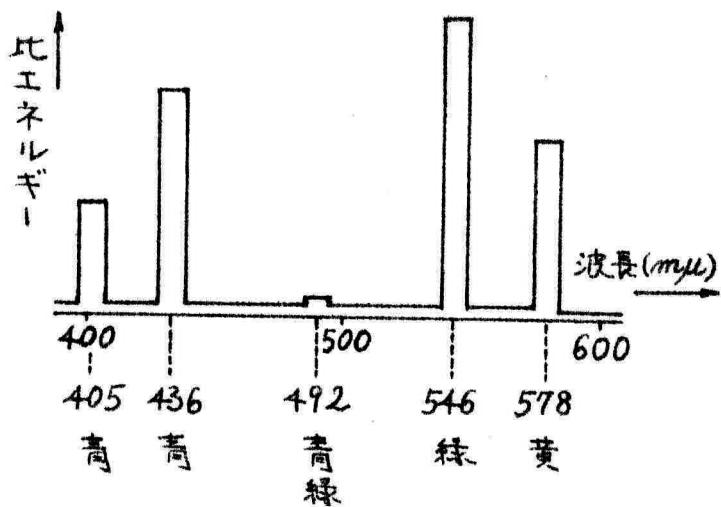
このような原理のもとに変調波を色差として検出することができるが、背景を与える色は必ずしも単色光による色である必要はなく、混合色であってよい。また白色光を用いるこ

とも可能であるが、回折画面上で特定の位置に置かれた光学機など”の復調素子による filtering のされ方は波長によって異なる。したがってこの場合、背景の色に加える图形の強度分布は各波長によって異なるようになる。

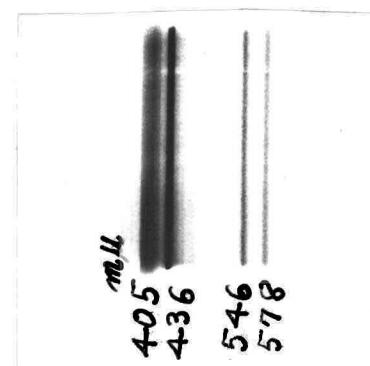
2.6.2 実験結果 および 考案

光源として用いた超高压水銀灯の波長分布は第2.32図のとおりである。試料の回折格子によって図に示したような横軸、縦軸の割合で青色から赤色まで分光され、その一次光を第2.33図に示す。これまでの実験では多層膜干涉フィルターを用いて、そのうち $546\text{m}\mu$ の単色光の分を使用していたが、ここではその干涉フィルターを取除いて実験を行った。

第2.34図および
第2.35図に示した結果



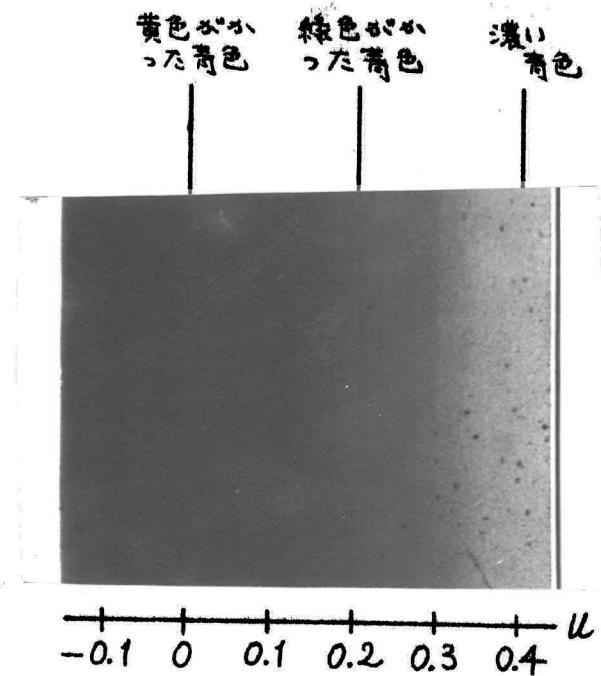
第2.32図 超高压水銀灯の波長分布。



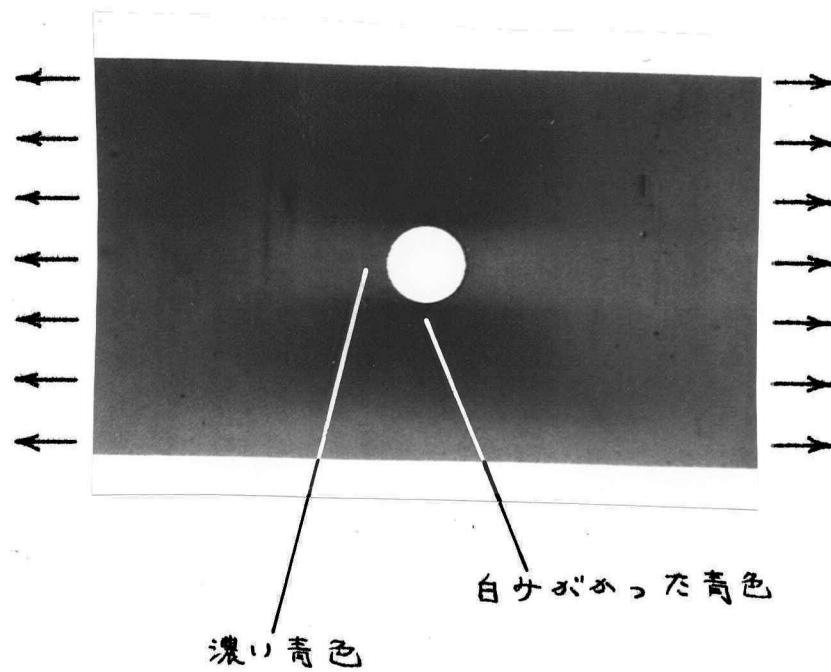
第2.33図 回折格子によって得た超高压水銀灯の波長分布。
(第2.32図に対応する)

は、先のオ2.10図と同じ試料によって得たものであり、円孔を有する平板に一様な引張り荷重が加えられている。これまでと同じように一次光のみを投影レンズに入れることとし、オ2.34図は赤色側から緑色の波長 $546\text{m}\mu$ の位置にナイフエッジを挿入したものである。この場合青色の光は Fraunhofer 回折面でナイフエッジから十分離れているのでそのスペクトルは何ら操作を加えられることなく投影レンズを通過し、試料全面に一様な青色を生じる。この上にオ2.10図(b)に示した緑色の图形が重なって現われている。色としてはオ2.36図に示した CIE 色度図で $405\text{m}\mu$ および $436\text{m}\mu$ の混色の A 点と $546\text{m}\mu$ の B 点とを結ぶ直線 AB 上の色となる。最もよく伸びている円孔直下あるいは直上では緑色が多く、色度図の中心部へ寄った白みがかった青色となる。また、最も伸びり少ない円孔の左右では A 点の色つまりの濃り青色となって、オ2.11図に示した歪量すなわち変調波に応じて色が異なっている。したがって変調波は色差として復調されると見える。

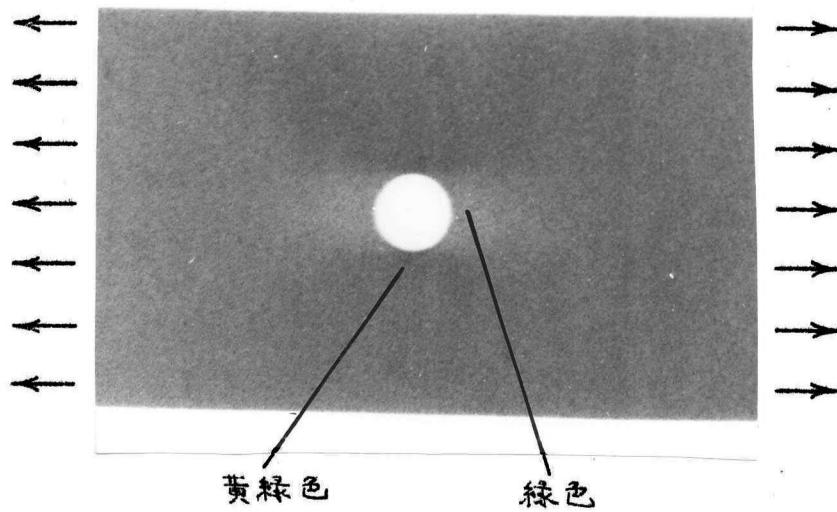
オ2.35図はオ2.33図に



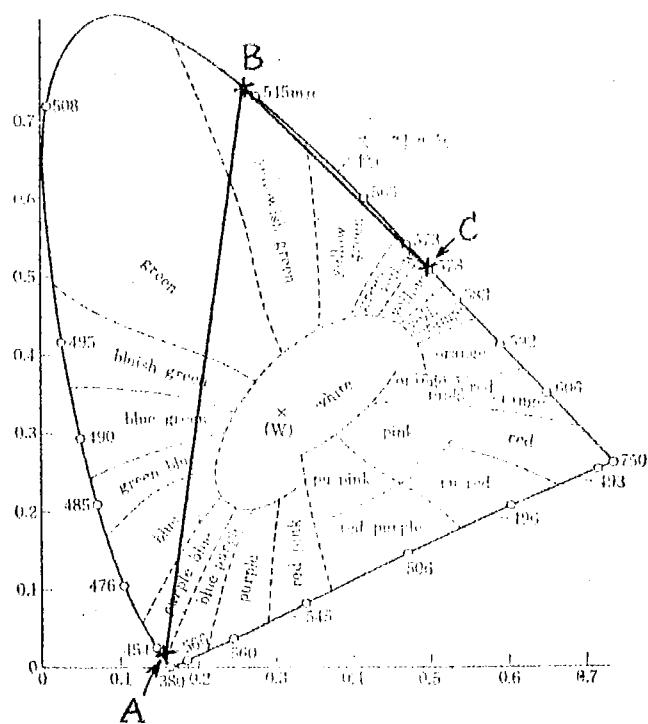
オ2.38図 光学楔を用いて得られた試料T₁の像の色。格子線は縦方向である。



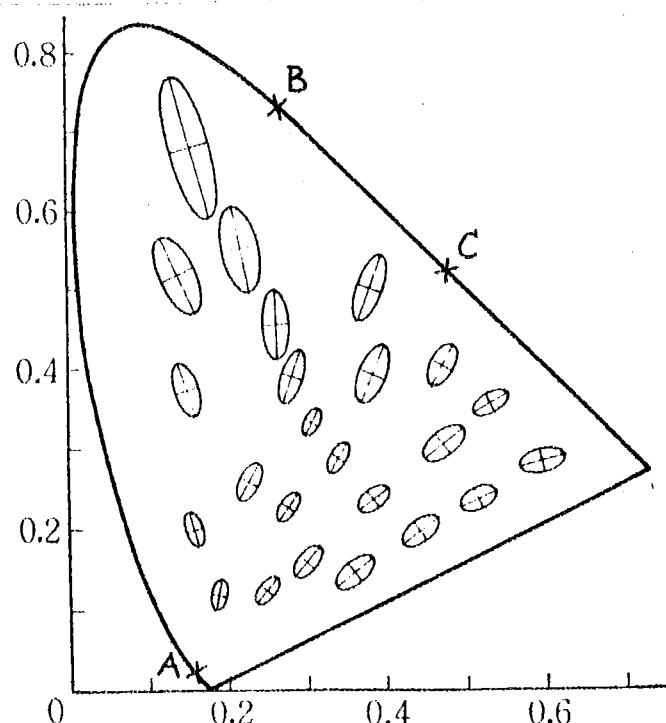
オ2.34図 円孔を有する平板に一様な引張り荷重を加えたときの色图形。青色の光を通し、緑色の光 $546m\mu$ の位置にナイフエッジを挿入した。写真はカラーリバーサルフィルムから直接印画紙へ焼付けたものである。



オ2.35図 円孔を有する平板に一様な引張り荷重を加えたときの色图形。緑色の光を通し、黄色の光 $578m\mu$ の位置にナイフエッジを挿入した。



第2.36図 CIE色度図



第2.37図 マッカーダラの識別域
図。

(A, B, C は第2.36図のもの
に対応する)

示した波長のうち青色を除去し、赤色側から黄色の位置にナイフエッジを挿入して得たものである。したがって緑色の地の上に黄色の凹形が重なっているものとなる。この場合 CIE色度図で $546 m\mu$ の B 点と $578 m\mu$ の C 点とを結ぶ直線 BC 上の色とみなす。観測された图形の色差としては第2.34図にくらべてやゝあつてゐる。

上の例で背景を与える色は、ナイフエッジなどによってその一部を除去されたりしなりでそのよき投影レンズを通してゐるためにはその強度は

大で、色としてはそれぞれ $\lambda 2.34$ 回のものはA点附近、 $\lambda 2.35$ 回のものはB点附近となっている。マッカータムの識別域構内を $\lambda 2.37$ 回に示したがB点附近の識別域構内はA点附近のものよりも大きく、また直線ACは直線ABよりも短くなりためにB点附近は色の識別が悪い。これより $\lambda 2.34$ 回に示した青色と緑色の組合せの方が識別の感度がよいと言うことが説明されると共に、適当な色の組合せを選ぶことによってさうに感度よく観測できる可能性がある。

色差による復調も背景に色を加えるのみであって原理的にはこれまでの復調方法と同じである。したがって图形を出すには、忠実度などこれまで述べた各復調方法の特徴を生かすようにしなければいけない。 $\lambda 2.38$ 回は光学楔を用いた例で、試料は $\lambda 2.3$ 表のT₆である。青色の光をすべて投影レンズに入れ、光学楔の透過率0～1の範囲が $546 m\mu$ の緑色および $577.~579 m\mu$ の範囲を被るようにして得られた。試料像面では青色の上に緑色と黄色の混色の图形が加わることになり、 $u=0$ 附近では黄色がかった青色、 $u=0.2$ 附近では緑色がかった青色となって、変調波に応じて色差となって現われている。

2.7 まとめ

Fraunhofer の回折面に種々のマスクを挿入して搬送波の ω_c とその側帯波に *spatial filtering* を施せば歪をうけた回折格子から試料の像面上に歪分布を検出できることが理論的、実験的に明らかとなった。その場合、測定は線光源に垂直方向の試料断面について行っており、像面上その断面の共軸位置で検出される。したがって光学系全体を考えれば、平面回折格子はその各断面の積み重ねで全面を測定していると考えることができる。

マスクとして鋭い立上りの *pass-band* を有するナイフェッジを用いた場合は方法として簡単であり、復調されて現われる图形は歪量の小ささとともに良好なコントラストを持っており、また忠実度も良い。しかし歪量が大きくなるとその忠実度は悪くなる。图形の忠実度とコントラストとを兼ね合わせて考えれば歪をうけた回折格子の平均周波数のスペクトル位置に、そのナイフェッジを挿入してそれよりも高周波数のスペクトルを除去するが最も良い方法である。

またマスクとして直線的な変化をしている振幅透過率を持つ光学楔を用いたときは、ナイフェッジを用いたときよりも忠実度が良く、特に回折光の方なり、すなわち側帯波の方なりをその透過率の直線部で完全に被うようすれば正しく復調される。しかしコントラストはナイフェッジを用いた場合よりも低下し、それは歪量の小ささときに著しい。したがって歪量の

小さりときにはナイフエッジを、大きりときには光学楔を用いる
ようになるのが望ましい。

さうに Fraunhofer の回折像は矩形状の応ぶりを示すから、
ここへ面積型楔を挿入する方法によつても復調でき、ナイフ
エッジを用いた場合よりも復調の忠実度は向上する。この面積
型楔の原理と同じことが、光源スリットの幅を増しても達成で
き、また波長幅を持った光源を使用しても同様に達成できる
ことが示された。この場合、復調の忠実度などは当然面積型
楔を用いた場合と同じであるが、単色の線光源を用いるより
も光の利用率が高く、光学系を非常に明るく使用でき、格子
のコントラストが低くて回折光が弱りような場合には有利とな
る。

以上の諸方法によつて歪分布は試料の像面上で光の強度分
布として検出されたが、これに特定の色を一様に加えること
により色差として歪分布を検出でき、加える色を適当に選べ
ば感度良く測定されることが明らかとなった。

第3章 平面応力による歪の測定

第2章では線光源に垂直な試料断面についての歪分布が、像面上その断面の央軸位置で光の強度分布あるいは色差として測定されることを変調波の復調という立場で述べた。平面試料の場合、加えられる荷重は平面応力であるのが一般で、そのとき線光源に垂直な断面方向の歪分布だけでは試料内任意方向の歪を決定することができない。ここでは回折格子を用いた本測定法によっていかにその任意方向の歪を決定するかについて考察する。これには三試料を用いる方法および一試料を用いる方法の二つが考えられ、それぞれを3.2および3.3で述べる。

平面応力とは二次元応力のことであって、 ϵ_x 、 ϵ_y 、 ϵ_{xy} の三応力成分による記述される。いまこの平面応力が試料に加えられたとき、平面試料は厚み方向にも変化し、そのために試料を通る光波に位相変化が与えられ測定に大きく影響する。まず3.1ではこの荷重に基づく試料の厚み変化を補正する方法について検討を加える。

最後に3.4で、本測定法による測定感度について考察を行う。

3.1 荷重に基づく試料の厚み変化の補正

試料平面は μ 両面で ν あったが、いまこれと垂直方向に μ 軸をとつておく。試料に平面応力が加えられた場合、存在する歪成分数は歪成分数と応力成分の関係より

$$\left. \begin{array}{l} \varepsilon_u = \frac{1}{E} (\sigma_u - \nu \sigma_v) \\ \varepsilon_v = \frac{1}{E} (\sigma_v - \nu \sigma_u) \\ \varepsilon_w = -\frac{\nu}{E} (\sigma_u + \sigma_v) \\ \gamma_{uv} = \frac{1}{G} \tau_{uv} \end{array} \right\} \quad (3.1)$$

となる。¹⁵⁾ ここに E はヤング率、 ν は剛性率、 G はボアソン比である。このうち ε_w は (3.1) より

$$\varepsilon_w = -\frac{\nu}{1-\nu} (\varepsilon_u + \varepsilon_v) \quad (3.2)$$

となり、 $\varepsilon_u, \varepsilon_v$ が定まれば一義的に定まるものであって、平面応力による歪の測定は $\varepsilon_u, \varepsilon_v$ および γ_{uv} を対象とすることになる。しかしこの ε_w の存在のために荷重を加えられた平面回折格子の試料は μ 方向にも変化し、場所によって厚さが異なってくる。そのため試料と通過(あるいは反射)する光波には位相の変化が与えられ、得られる像の強度分布に誤差が生じくる。物体は (1.17) で示されたとおり、明暗分布および位相分布の結合された形で書き表わすことができるが、試料の厚み変化は物体の位相分布となる。Fraunhofer の回折像は (1.26) のとおり物体 $\mathcal{O}(u)$ のフーリエ変換の形で表わされるが、回折像の振幅分布には変化が生じ、それを函数として示される像の強度分布は実際と違ったものとなる。

また物体の位相分布を変化させるものは厚み変化だけではなく、例えは表面に回折格子を転写した樹脂材料に荷重を加えた場合、歪に応じて屈折率の変化も生じ、試料を通る光の光路差が変化するため同じことが起る。

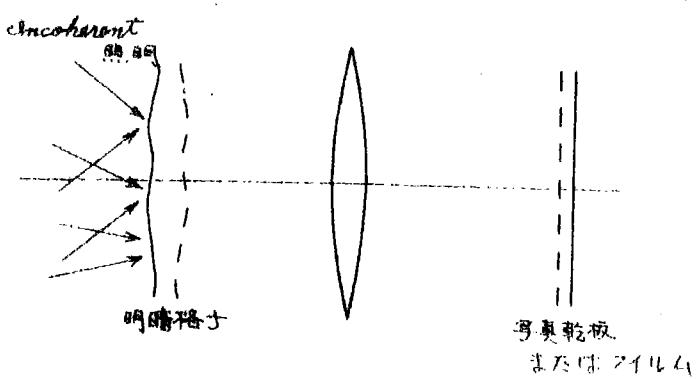
このような光波の位相変化の影響を補正するためには次に述べる方法をとる。1.1の結像理論は一般的なものであるから本研究の測定光学系以外のものに対しても成立する。いま物体を照明する光が *incoherent* である場合を考える。このとき coherence factor γ_{12} は $u_1 = u_2$ で $v_1 = v_2$ のときは $\gamma_{12} = 1$ 以外は $\gamma_{12} = 0$ であり、 $u_1 = u_2$ で $v_1 = v_2$ のときは $\gamma_{12} = 1$ であるから (1.17) は

$$I(u', v') = \iint_{-\infty}^{\infty} |\Theta(u, v)|^2 |t(u-u, v-v')|^2 du dv. \quad (3.3)$$

となる。この式によれば、物体を *incoherently* に照明した場合像の強度分布は物体の明暗分布 $|\Theta(u, v)|$ のみに関係して、位相分布には無関係となる。したがって、いま荷重を加えられた試料を第3.1図の

とく *incoherently* に照明し、その格子像を写真撮影すれば、得られる格子像は厚み変化などによる物体の位相分布に関係のない歪んだ状態の明暗格子である。

写真撮影を行うこと



は uv 面へ撮影された格子像を得ることであるが、 ϵ_u , ϵ_v および γ_{uv} はそれぞれ Fig. 1.6 に示した記号を用いて

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_u &= \frac{\partial S_u}{\partial u_0} = \frac{\partial \Delta u}{(1 - \frac{\partial \Delta u}{\partial u}) \Delta u} = \frac{\partial \Delta u}{\Delta u} \\ \epsilon_v &= \frac{\partial S_v}{\partial v_0} = \frac{\partial \Delta v}{(1 - \frac{\partial \Delta v}{\partial v}) \Delta v} = \frac{\partial \Delta v}{\Delta v} \\ \gamma_{uv} &= \frac{\partial S_u}{\partial v_0} + \frac{\partial S_v}{\partial u_0} = \frac{\partial \Delta u}{\Delta v} + \frac{\partial \Delta v}{\Delta u} \end{aligned} \right\} \quad (3.4)$$

のことと w 方向の変位成分には無関係に求まり、何うさしつかえがなりことがわかる。

したがってこのように *incoherently* に照明し、歪んだ状態の格子像を撮影した写真フィルムを実際の測定光学系に対する試料として用いた。この場合、写真フィルムにも Fig. 3.2 図に一例を示したようにシリーレン法で十分認められる程度の厚みむらがある。したがって Fig. 2.5 図で説明したようにフィルムを二枚の *optical parallel* で保持し、その

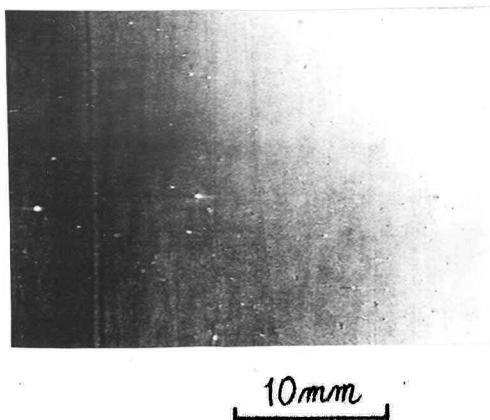


Fig. 3.2 図 シリーレン法に

よって得られた写真フィルムベースの厚さむら。

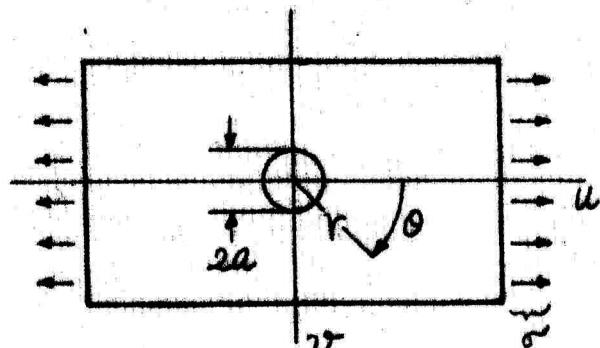


Fig. 3.3 図 一様な引張り荷重を加えられた中央に内孔を有する平板。

フィルムと optical parallel 間にフィルムベースと層接率の等しい液で浸漬して用いることが必要である。

いま第3.3図のごとく中央に円孔を有する平板に一様な引張り荷重が加えられたとき、変形が弾性変形であればその応力は弾性論より極座標表示して

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= \frac{\sigma}{2} \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) + \frac{\sigma}{2} \left(1 - 4 \frac{a^2}{r^2} + 3 \frac{a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta \\ \sigma_\theta &= \frac{\sigma}{2} \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) - \frac{\sigma}{2} \left(1 + 3 \frac{a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta \\ \tau_{r\theta} &= -\frac{\sigma}{2} \left(1 + 2 \frac{a^2}{r^2} - 3 \frac{a^4}{r^4} \right) \sin 2\theta \end{aligned} \right\} \quad (3.5)$$

で与えられる。¹⁵⁾ ここに記号は第3.3図に示したとおりである。

これを直角座標 uv に変換すれば

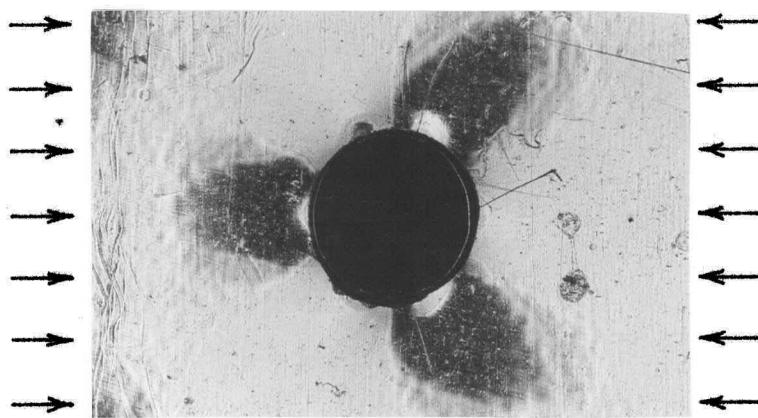
$$\left. \begin{aligned} \sigma_u &= \sigma_r \cos^2 \theta + \sigma_\theta \sin^2 \theta - 2 \tau_{r\theta} \sin \theta \cos \theta \\ \sigma_v &= \sigma_r \sin^2 \theta + \sigma_\theta \cos^2 \theta + 2 \tau_{r\theta} \sin \theta \cos \theta \\ \tau_{uv} &= (\sigma_r - \sigma_\theta) \sin \theta \cos \theta + \tau_{r\theta} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \end{aligned} \right\} \quad (3.6)$$

となる。これを(3.1)に代入して ϵ_u を求めれば

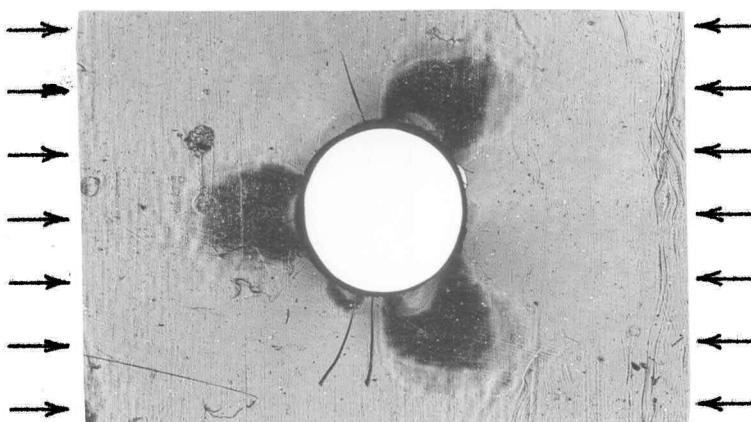
$$\begin{aligned} \epsilon_u &= \frac{\sigma}{2E} \left[\left\{ \left(2 + 2 \frac{a^2}{r^2} - 3 \frac{a^4}{r^4} \right) - 3 \frac{a^2}{r^2} \cos 2\theta - \left(4 \frac{a^2}{r^2} - 6 \frac{a^4}{r^4} \right) \cos^2 2\theta \right\} \right. \\ &\quad \left. - \nu \left\{ \left(-2 \frac{a^2}{r^2} + 3 \frac{a^4}{r^4} \right) - \frac{a^2}{r^2} \cos 2\theta + \left(4 \frac{a^2}{r^2} - 6 \frac{a^4}{r^4} \right) \cos^2 2\theta \right\} \right] \end{aligned} \quad (3.7)$$

である。(3.7) は $\cos 2\theta$ の函数であるから u 軸および v 軸に関して対称、すなわち原点に関して対称である。

ここで 3.0 mm のポリカーボネートをベースとした写真乾板を用いて、その表面に 40 本/mm の明暗格子を転写した。これを成形して格子線に垂直方向に圧縮荷重を加え、Fraunhofer 回折面にナイフエッジを挿入して得られた图形を第3.4図に示した。圧縮荷重は(3.7) におりて ~ 10 であり、その歪分布は



第3.4図 内孔を有する平板そのものを試料としたときに得られた图形。格子線は縦方向である。



第3.5図 シュリーレン法によって得られた图形。ナイフエッジの端は圧縮方向に直角である。

引張り荷重のときにくらべて符号が逆となるだけであるが、この图形を見ると原点に対称でなく、上方向の歪成分を現わしていなり。

第3.5図は第3.4図に示したのと同じ試料について、Fraunhofer回折面でゼロ次光の位置に同じ方向からナイフエッジを挿入して得られた图形である。すなわちシュリーレン法によって得たものである。

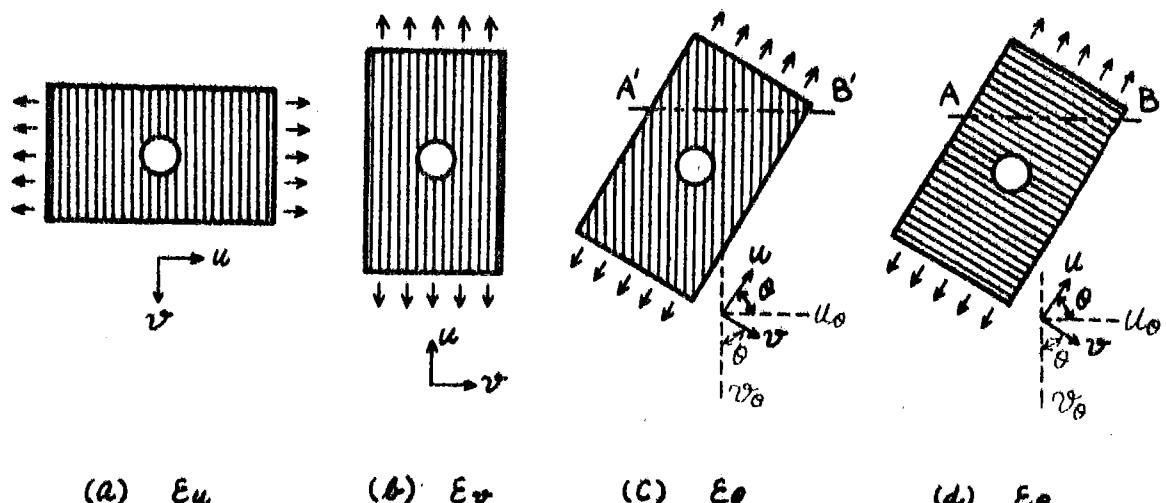
現われているこの图形は圧縮軸方向に関する厚み変化に基づくもので、²⁹⁾ 第3.4図の图形とその形は一致している。したがって第3.4図の图形は厚み変化に基づくものであることがわ

かる。これに反して上に述べたごとく厚み変化などの補正をして実験を行った結果は次の図3.2の亦3.7図の图形で、実験誤差の範囲で原点に関して対称であり、また図3.10の等歪曲線と比較してみると正しく測定できていることがわかる。

以上のように荷重状態にある格子を *incoherently* に照明して撮影した写真フィルムを実際の測定光学系に対する試料とすれば試料の厚み変化などの影響を取除くことができるが、その他に次のような特徴も持っている。回折格子によって発生した空間的搬送波の変調、復調というこれまで述べて来た専柄は透過光学系あるいは反射光学系の区別なく考えられるものであるが、このように並んだ格子像を写真撮影する方法をとれば、不透明試料に対する測定も特に反射光学系を必要としない。また荷重装置と光学系とを分離することができる、そのため荷重装置に対する制限がなくなり、複雑な荷重を加えることも可能となる。さらに試料に加える荷重を順次増していくような場合、その各段階の並んだ格子の状態が写真フィルムに撮影されてそのまま保存でき、必要に応じて後から測定光学系に供して検討することができる。また試料に転写した回折格子の格子間隔を撮影倍率を変えることによって測定光学系に適するように調節することができる。

3.2 三試料を用いる方法

§1.2で考察したように搬送波を与える荷重前の回折格子の格子線をひ軸に平行に置いたとすれば、荷重によって直んだ回折格子のひが一定の断面はu方向の歪成分 ϵ_u を変調波として空間周波数変調されるとみなされる。いま才3.6図(b)のごとく格子線の方向をu軸に平行に置く。このとき§1.2に示した各式においてuとひが互に入れ換わるものであり、ひが一定の断面を考へると ϵ_u によって周波数変調されることはわかる。また格子線の方向を才3.6図(c)のごとくひ軸とのなる角度だけ傾むけて置いた場合を考え、その方向の座標軸を u_0 、それに直角方向の座標軸を v_0 とする。この場合も§1.2に示した各式においてuを u_0 、vを v_0 に入れ換えて考へ



才3.6図 歪成分測定における格子方向と試料配置。
線光源は図の縦方向である。

ればよく、2%が一定の断面はどの方向の歪成分とよって周波数変調されたりることがわかる。

いま 図3.6 図にそれぞれ示したように格子線の方向を線光源の方向と一致させるよう試料を置く。2.1ですでに述べたように試料は線光源方向には *incoherently* に照明され、線光源に垂直方向の試料断面についてのものが各々独立に像面上、その断面の共

図3.9 図 ポリカーボネート樹脂の
应力-歪曲線³⁰⁾。

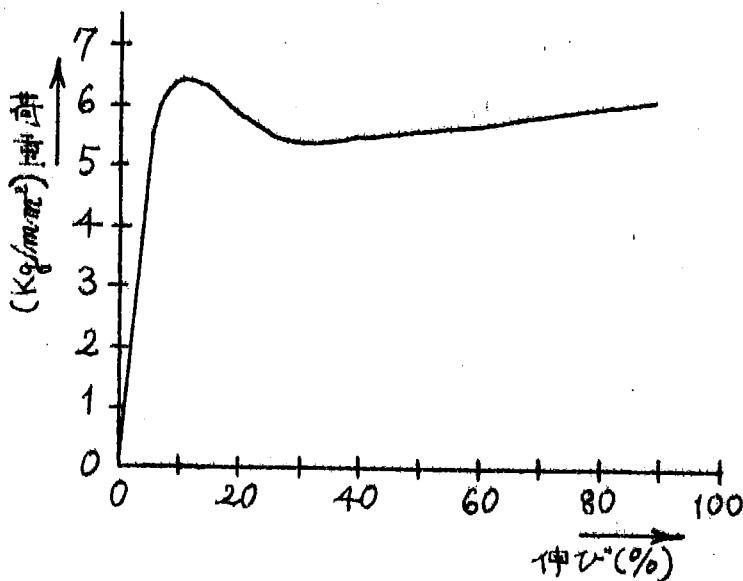


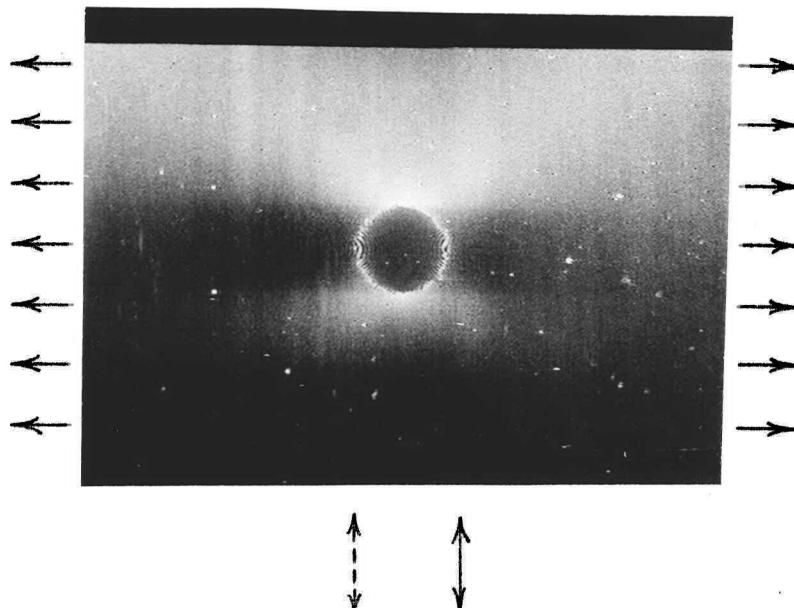
図3.1表 ポリカーボネート樹脂の性質³¹⁾。

引張り強さ(降伏)	6.45 kg/mm ²
引張り強さ(破断)	6.05 kg/mm ²
伸び (降伏)	11.1 %
伸び (破断)	89.0 %
引張り弾性率	191 kg/mm ²
圧縮強さ	7.80 kg/mm ²
圧縮弾性率	218 kg/mm ²
剪断強さ (降伏)	3.8 kg/mm ²
剪断強さ (破断)	6.6 kg/mm ²
ボアソン比	0.35 ± 0.07
硬 度	ロックウェル M63
光弾性感度	1.46 mm/Kg
屈折率	1.5869
光の透過率	500,μ以上で 90 %

軸位置で測定される。したがって第3.6図に示したごとく試料を配置すれば、それぞれ E_u , E_v , E_θ が測定されることがわかる。第2章では試料上に線光源と垂直方向にル座標をとて、理論的、実験的に検討を加えたが、その記号をひある u は u と書き換えてもさしつかえなリのはもちろんである。

上に述べたことを確かめるために行った実験の一例を以下に示す。試料は 10 本/mm の明暗格子を転写した厚さ 0.12 mm のポリカーボネートベースの写真フィルムを用いた。その写真フィルムを矩形に成形し、中央に直径 6 mm の穴を穿った後、 u 方向である長手方向から 1.5 Kg/mm^2 の一様引張り荷重を加えた。その後第3.1で述べたように荷重による試料の厚み変化などの影響を取除くために散乱光で *incoherently* に照明して、その荷重状態の

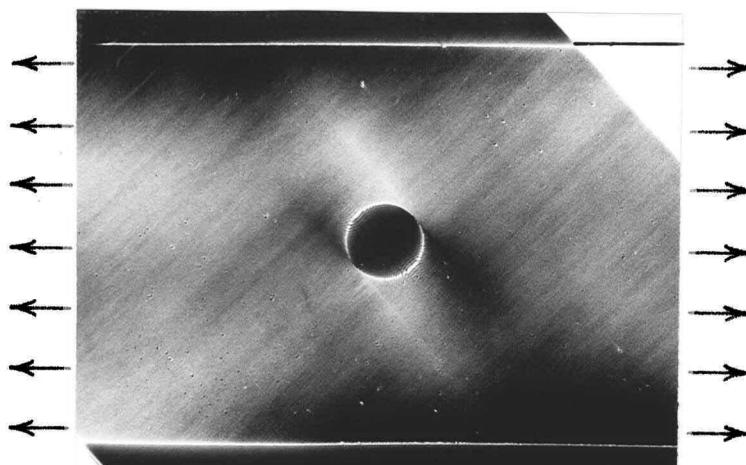
格子像をミニ
ルタマクロロッ
コ-レレンズ*
で $\frac{1}{3.3}$ 倍に撮
影した。その
歪んで格子が
撮影されたフ
イルムを第3.1
で述べたよう



第3.7図 引張り方向に直角な格子線を持った内孔を有する平板内の歪图形。

↑ は格子線の方向、↓ は線光源の方向を示している。

* 歪曲収差は
第2.2表参
照。



第3.8図 引張り方向に45°の格子線をもつた
円孔を有する平板内の歪形。

↑は格子線の方向、↓は線光源の方向を
示している。

に浸漬して測定光学系に対する実際の試料とした。この場合、フィルムとしては硬調、微粒子の富士ミニコピーフィルムを用いたが、浸漬液としては流動パラフィンが適当である。

いま第3.1図(a)に示したように格子線の方向をひ方向とした試料をその方向を線光源に平行に置いた。マスクとしてはナイフエッジを用い、一次光の平均周波数以上のスペクトルを取除いて得られた图形を第3.7図に示した。同じく格子線の方向をひ軸に対して45°方向とした試料により得られた图形を第3.8図に示した。

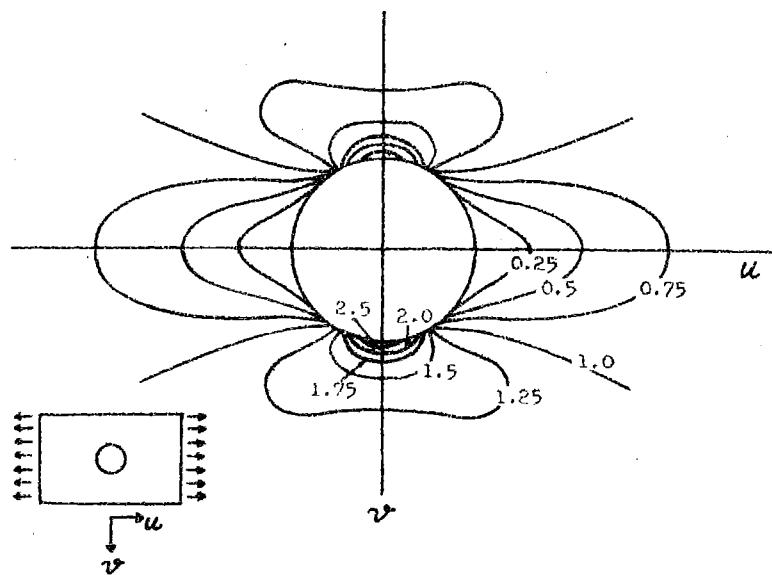
10本/mmの明暗格子を転写して写真フィルムベースのポリカーボネットは直接試料物体となっており、ポリカーボネット樹脂の応力-歪曲線および性質をそれぞれ第3.9図および第3.1表に記した。このように中央に円孔を有する平板に一様な引張り荷重が加えられたとき、その最大応力は円孔の縁で $\theta = 90^\circ$

および 270° の場所に起り、⁽¹⁵⁾その値は(3.5)より 3σ となる。亦3.9図の応力-歪曲線によればポリカーボネットの弾性限は約 5Kg/mm^2 とみなせる。したがって $\sigma=1.5\text{Kg/mm}^2$ の引張り荷重によってこの試料は全面にわたって弾性変形のサビをうけているとみなされる。亦3.1表よりポリカーボネット樹脂のポアソン比 $\nu=0.35$ とし、円孔附近の歪分布を(3.6)を用いて計算し、 α 方向の歪 ε_α の分布および α 方向と 45° 方向の歪 ε_{45° の分布をそれぞれ3.10図(a)および(b)に描いた。ここに曲線は歪の等しい点を連ねたものであり、その数値は円孔から十分離れた点の値を1とした。ここで実験例として示した $\sigma=1.5\text{Kg/mm}^2$ の一様な引張り荷重による $\varepsilon_\alpha=1$ の実際の値は亦3.1表の引張り弾性率を用いて $\varepsilon/E = 1.5/191 \times 100 = 0.8\%$ である。亦3.7図の图形で上下や対称でないのは荷重装置としてレバー型のものを用いたので荷重が上下にありて一様にかかるなかつたのではないかと思われるが、強度の等しいところは亦3.10図(a)に示した等歪曲線とほぼ一致している。また同じことが亦3.8図の图形と亦3.10図(b)の等歪曲線についても言え、それぞれ $\varepsilon_\alpha, \varepsilon_{45^\circ}$ が測定されることがわかり、先に述べた考察を実証している。

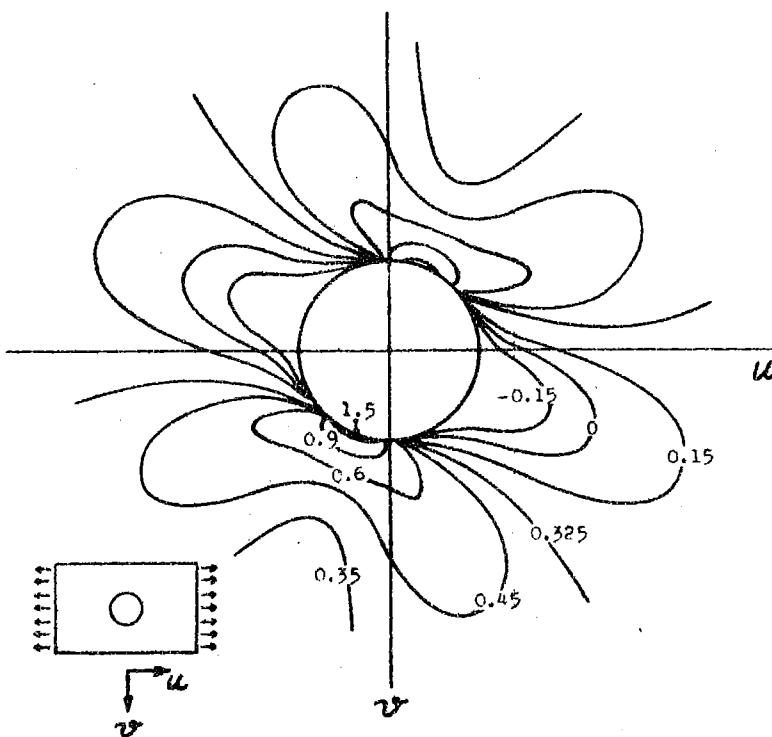
平板内に存在する微小部分の任意方向の歪は一般に三つの歪成分で

$$\varepsilon = \varepsilon_{\alpha\alpha} l^2 + \varepsilon_{\alpha\alpha} m^2 + \gamma_{\alpha\alpha} lm \quad (3.7)$$

のよう⁽¹⁵⁾に表わされる。ここに l および m はそれぞれその注目した任意方向の α 軸および β 軸に関する方向余弦である。



(a) u 方向の
歪 E_u 。



(b) u 方向と
45° 方向の
歪 E_{45} 。

第3.10図 u 方向に一様引張り荷重を加えられた平板の円孔附近における等歪曲線。左下の図は荷重を加えられた全体の状態を示している。円孔から十分離れた点の E_u の値を 1 とした。これより円孔から十分離れた点の E_{45} の値は 0.325 となる。

(3.7) より ϵ を決定するには三つの異った方向の歪成分を知ればよい。例えば上に述べた方法で ϵ_u, ϵ_v およびある特定の θ 方向の歪 ϵ_θ を測定したとする。この測定した $\epsilon_u, \epsilon_v, \epsilon_\theta$ および $\cos \theta, \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$ をそれぞれ (3.7) の $\epsilon_u, \epsilon_v, \epsilon$ および ℓ, m に代入すれば ϵ_{uv} を知ることができ。したがって $\epsilon_u, \epsilon_v, \epsilon_{uv}$ が知られただけであるから (3.7) の関係で示される任意方向の歪を完全に知ることができ。この場合、必ずしも ϵ_u, ϵ_v を知る必要はなく、 $\epsilon_{\theta_1}, \epsilon_{\theta_2}, \epsilon_{\theta_3}$ の三方向の歪を知ればこれで (3.7) に代入した連立方程式を解いて $\epsilon_u, \epsilon_v, \epsilon_{uv}$ を求めることができ。

以上より歪を完全に知るには各々異った格子方向を持つ三個の試料を作成して三方向の歪を知ればよいことがわかった。

3.3 一試料を用いる方法

3.2で述べた方法によれば歪を完全に決定するためには三個の同じ試料を必要とする。光弾性法のように対象とするものの模型を作成して測定する場合にはこの方法が有効であるが、直接対象物を試料としようとする場合にはこの方法は使用できぬ。このような場合には試料上に格子を三交差させて転写し、そのうち一方向の格子を線光源と平行になるように試料を回転して測定を行えばよい。もちろんこの場合、試料はそのまま線光源と光学櫻などのマスクとを回転しても相対的には同じである。

別の方法とし

て3.6図(d)の

ごとく格子を線

光源とだけ傾

けた試料の例え

ば断面ABを考え

る。この場合、

3.6図(c)の

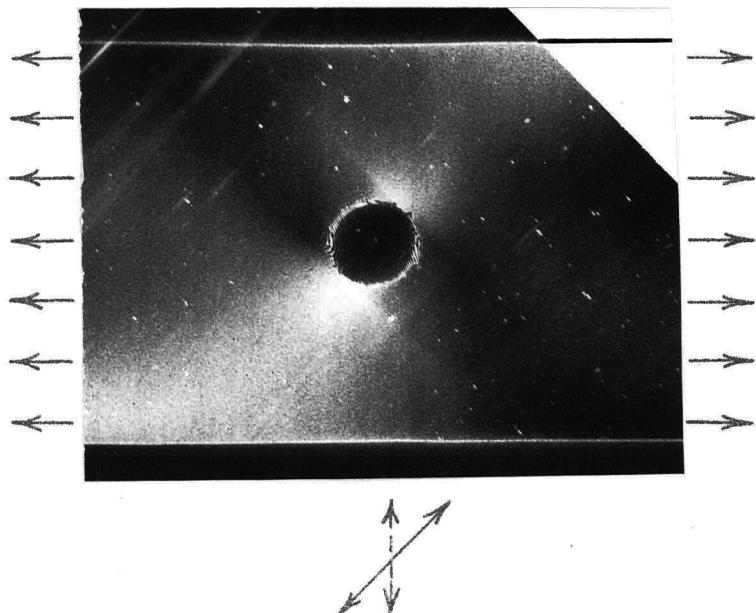
同じ断面A'B'を

くらべてみると

格子間隔が $1/\cos\theta$

だけ大きくなっ

ているが、もち



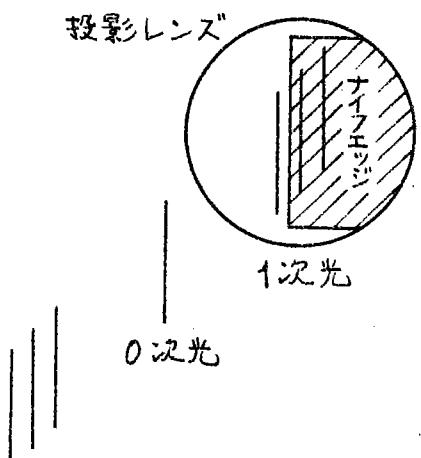
3.11図 線光源を引張り方向に対して 45° 傾けた場合の歪图形。

↑は格子線の方向、↓は線光源の方向を示している。

ろん同じ歪分布であるか
も同じ変調波で変調され
ている。先に述べたよう
に測定は線光源に垂直な
各断面についてのみ行わ
れるから、この場合もが
測定される。第3.11図は
第3.7図にその結果を示し
たりと同じ試料について
格子線の方向を線光源と
45°になるようにして得ら
れた图形である。この時

回折光は第3.12図に示し
たように45°方向に偏むが、投影レンズには一次光のみを入
れ、格子は線光源に垂直な成分を考えているから、図中に記
したように線光源に垂直方向からナイフエッジを挿入した。こ
の图形を第3.10図の等歪曲線と比較してみると光の強度の等
しいところは等歪曲線の形とはほぼ一致しており、45°方向の歪
を測定していることがわかる。

格子線の方向が線光源と平行でない場合は測定感度が低下
する(次の第3.4で考察する)けれども、このように格子を回転
することにより、一方向の格子を持つ方試料で仕向方向の歪
が測定でき、少くとも三方向を測定すれば試料内の歪は完全
に定まる。



第3.12図 格子線方向を線光源に
45°傾むけた場合の回折光とナイ
フエッジの挿入状態。

3.4 測定感度

第2章で歪量の小さいとき、ナイフエッジを用ひれば得られる圓形のコントラストがもっとも高いことを述べた。したがって測定感度が高く、最小測定限界について論じるにはナイフエッジを用いた場合について考えればよい。

歪の分布を $m(u) = a_m \omega_m \cos \omega_m u$ とし、投影レンズには ω_c との側帯波だけを入れるようにした場合、望ましいナイフエッジの位置は $x > \omega_c$ あるいは $x \geq \omega_c$ のスペクトルを取除くよう挿入するのであったが、いま $x > \omega_c$ のスペクトルを取除い場合を考へる。そのとき得られる像面上の強度分布は(2.11)で示されたが、歪量の小さい場合を考えているから、荷重による格子の最大変位は搬送波であるもとの格子の1格子間隔を越えないと考えてよい。したがって

$$|a_m| < \frac{1}{\omega_c} \quad (3.8)$$

であり、これより

$$|m_f| = |- \omega_c a_m| < 1 \quad (3.9)$$

となる。また $\omega_m < \omega_c$ であるから

$$|a_m \omega_m| < 1 \quad (3.10)$$

である。(3.9)が成立するとき $J_p(m_f)$ はベッセル函数の性質か

$$\left. \begin{aligned} J_0(m_f) &= 1 - \frac{1}{4} m_f \\ J_1(m_f) &= -J_1(m_f) = -\left(\frac{1}{2} m_f - \frac{1}{16} m_f^3\right) \\ J_2(m_f) &= J_2(m_f) = \frac{1}{8} m_f^2 \\ J_3(m_f) &= -J_3(m_f) = -\frac{1}{48} m_f^3 \end{aligned} \right\} \quad (3.11)$$

などと近似的に表わされる。したがって(2.11)は

$$I(\omega) \approx 1 + \omega_c a_m \cos \omega_m t \quad (3.12)$$

となる。ここで $I(\omega)$ の平均強度の $\pm 2\%$ の強度変化まで測定しうると仮定すれば、測定限界では(3.12)より

$$\omega_c a_m = 0.02 \quad (3.13)$$

である。 $\omega_c a_m$ を実際の長さで示せば(1.1)より

$$\omega_c a_m = 2\pi F_c A_m \quad (3.14)$$

である。ここに F_c は回折格子の単位長さ当たりの格子の本数であり、 A_m は a_m を実際の長さで表わしたもので荷重による格子の最大変位である。

一例として 30 本/mm の格子を用いた場合、測定可能な変位量は(3.13) および(3.14) より

$$A_m = \frac{0.02}{2\pi F_c} = 0.11 \mu \quad (3.15)$$

となる。また $a_m \omega_m \cos \omega_m t$ なる歪が試料中 10mm の周期で生じていれば測定可能な歪量としては(3.15) より

$$a_m \omega_m = 2\pi A_m F_m = 0.0067\% \quad (3.16)$$

となる。ここに F_m は周期の逆数である。(3.15) あるいは(3.16)によればこの測定法は非常に感度の高い測定法であることがわかる。

30 本/mm の回折格子は、回折格子としては格子間隔の大きいものであって、写真的にも特別の注意を払わなくても作成できるので例として選んだが、さらに格子間隔の細かいものを使用すれば(3.15) より明らかのように測定感度は向上する。3.6 図(d) に示したように回折格子を回転して線光源と格子

線が θ なる角度を持つようにして測定を行った場合は、搬送波の周波数が $\cos\theta$ だけ小さくなつたものとみなせたから、測定限界の変位量および歪量は(3.15)および(3.16)により $\frac{1}{\cos\theta}$ だけ大きくなつて測定感度そのものは低下する。したがつて0.01%以下のような非常に微小な歪を測定しようとする場合には格子と試料上に三交差させて転写するか、あるいは各々異つた格子方向を持つ三個の試料を作成する方法をとらなければいけない。

以上の取扱いは空間周波数変調をうけた回折格子の透過率分布を(1.42)に示したごとくフーリエ級数に展開したもの、すなわち試料の回折格子は無限の広がりを持っているとした場合であつて、そのスペクトルは線スペクトルで表わされた。しかし実際の試料は有限であつて、線スペクトルで示されたものはある幅を持ってくるようになる。そのためにこれまで考えて来た感度などの取扱いが必ずしも成立しなくなる恐れがある。以下これまでの取扱いで考えられる範囲について考察する。試料の回折格子は $-l \leq u \leq l$ の広がりを持っているとすれば、それによるFraunhofer回折像の振幅分布は(1.11)の物体の透過率分布に(1.40)の周波数変調をうけた回折格子の透過率分布を直接代入して

$$\begin{aligned}
 O(\chi) &= \int_{-l}^l \{A_0 + A_1 \cos \omega_c(u - a_m \sin \omega_m u)\} \exp(-i\chi u) du \\
 &= 2A_0 \frac{\sin l\chi}{l\chi} + A_1 \sum_{p=-\infty}^{\infty} J_p(m) \left\{ \frac{\sin l(\omega_c + p\omega_m - \chi)}{l(\omega_c + p\omega_m - \chi)} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{\sin l(\omega_c + p\omega_m + \chi)}{l(\omega_c + p\omega_m + \chi)} \right\} \quad (3.17)
 \end{aligned}$$

となる。 $l=\infty$ に対しては $\frac{\sin l\chi}{l\chi} = \delta(\chi)$

などと線スペクトルになり、(1.43)

に一致する。 l が有限のときはその

線スペクトルを中心にして (3.17)

で示されるように各スペクトルは

幅を持ってくる。ここで、これまで

と同じように 1 次光に注目する。

すなわち (3.17) の第 2 項について

考える。 $\gamma = \beta$ についてのものの回

折像の強度 $\left\{ \frac{\sin l(\omega_c + \beta \omega_m - \chi)}{l(\omega_c + \beta \omega_m - \chi)} \right\}^2$ を

Fig. 3.13 図に示した。

これは $\chi = \omega_c + \beta \omega_m$ で最大となり、

その値に関して左右対称である。

半値幅 $\Delta\chi$ は

$$\left\{ \frac{\sin l(\omega_c + \beta \omega_m - \chi)}{l(\omega_c + \beta \omega_m - \chi)} \right\}^2 = \frac{1}{2}$$

より

$$\Delta\chi = \frac{2.78}{l} \quad (3.18)$$

となる。試料のたぐり $-l \leq u \leq l$ 間にこれまで考へて来た

$a_m \omega_m \cos \omega_m u$ なる歪み N_m 周期だけ含まれているとすれば

$$2l = N_m \frac{2\pi}{\omega_m} \quad (3.19)$$

であり、(3.19) を (3.18) に代入して

$$\Delta\chi = 0.89 \frac{\omega_m}{N_m} \quad (3.20)$$

となる。ここで、各々の γ についてのスペクトルの中心間の距離が (3.20) で示された半値幅よりも大であれば、各スペク

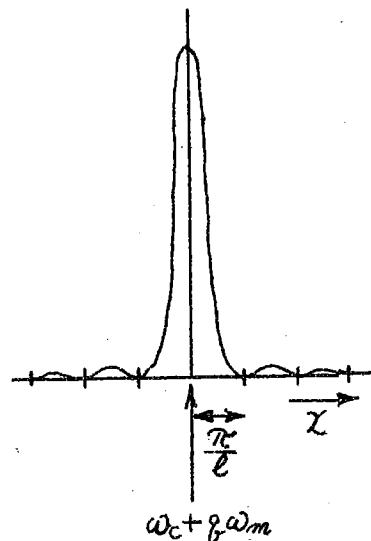


Fig. 3.13 図 $-l \leq u \leq l$ のたぐりを持つた回折格子による回折像。変調波は $a_m \omega_m \cos \omega_m u$ であり、中心のスペクトルより m 番目の側帯波の強度を示している。

$$\text{半値幅: } \frac{2.78}{l}$$

トルは分離されているとする。各々についてのスペクトルの中心距離は ω_m であるから、各スペクトルが分離するための条件は (3.20) より

$$N_m > 0.89 \quad (3.21)$$

となる。これより少くとも $N_m = 1$ 、すなわち歪が 1 周期だけ含まれておれば各スペクトルは分離されている。したがって各々 ω_c に関する側帯波として見分けがつき、線スペクトルと同様に考えて、復調の忠実度および感度などこれまで取扱ってきたことを適用しても大きな差は生じないであろう。

これより細かい周期で変動する歪でも試料がその 1 周期程度の大きさがあれば、これまでと同じ程度の感度、忠実度をもって測定される。

ポリカーボネートの光弾性感度は第 3.1 表に示したごとく 1.46 mm/Kg であり、他の樹脂材料に比して高い光弾性感度を持っている。³²⁾ 第 3.7 図、第 3.8 図および第 3.11 図にその結果を示した実験は 0.12 mm のポリカーボネートフィルムを用いたが、 0.12 mm のポリカーボネートフィルムで 1 フリンジの光弾性縞を生じるには

$$\frac{1}{1.46} \div 0.12 = 5.7 \text{ Kg/mm}^2 \quad (3.22)$$

の単軸応力、あるいは平面主応力差を加えることを必要とする。第 3.2 で述べたように第 3.7 図などの内孔を有する平板に一様な引張り荷重を加えた実験では、最大応力は内孔の縁で $\theta = 90^\circ$ および 270° の場所に起こり、その値は

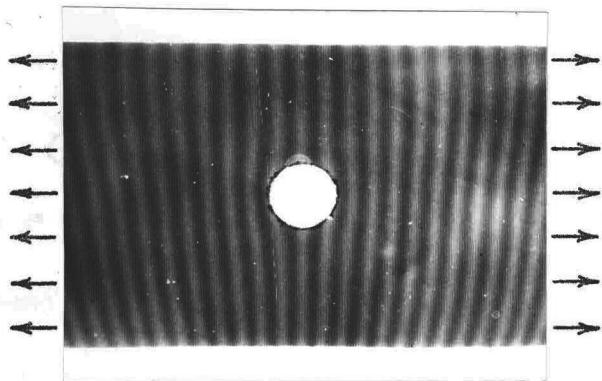
$$3\sigma = 4.5 \text{ Kg/mm}^2 \quad (3.23)$$

であった。ここでの応力は(3.6)より

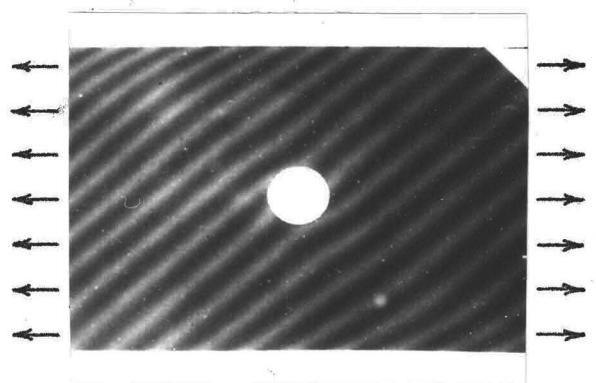
$$\sigma_{yy}' = 0, \quad \tau_{yy}' = 0 \quad (3.24)$$

であるから(3.23)の σ_y' は平面主応力差であり、しかもその最大値である。(3.23)の値 4.5 kg/mm^2 は(3.22)の値 5.7 kg/mm^2 よりも小であるから、亦3.7図に示した実験を光弾性法で行った場合、1フリンジ以下となる。

格子を用いた歪分布の測定法としては Post⁵⁾などの行ってい るように他の規則格子と重ね合わせてモアレを出して行う方 法がある。亦3.14図および亦3.15図はそれぞれ亦3.7図および 亦3.8図の結果を得たその試料を使用し、規則格子と重ね合わ せて得られたモアレである。この場合、重ね合わず規則格子 の格子間隔を試料の最も伸びている部分の格子間隔よりも大 きくしたので、モアレの間隔と伸びの程度とは対応している。 亦3.14図のモアレをみると円孔附近でやゝ縞間隔が変化して あり、また試料下部では縮みが起り、上部では伸びているこ とがわかる。しかしこれから亦3.7図のように歪分布を試料 全面にわたって直感的に知ることは困難であり、また縞間隔 の変化は非常にわずかであるので感度よく測定することは期 待できなり。試料の格子と重ね合わず規則格子の相対的な角 度変化を小さくすればモアレ縞の間隔は大きくなり、感度を 上げて測定できるが、この場合試料上近接した場所の歪の変 化を知ることが困難となる。亦3.15図のモアレを亦3.8図の 図形と比較しても上と同じことが言える。



第3.14図 円孔を有する平板に一様な引張り荷重を加えたときのモアレ。試料の格子線は引張り方向に垂直。



第3.15図 円孔を有する平板に一様な引張り荷重を加えたときのモアレ。試料の格子線は引張り方向に對して45°。

本測定法は細かい変動する歪でも(3.21)で示したように少くともその1周期程度の微小領域までは正確に感度よく測定することができます。これは第4章に示したアルミニウム粗大結晶を引張り変形させたとき、すべりによる細かい変動の歪が測定されていることからも明らかである。

実際の測定を写真測光で行う場合には、写真銀粒子の粒状性によって測定領域は制限をうける。これは用いる写真フィルムの種類および現像条件などによつ

て異なる。一例として富士ネオパンSSを液温20°Cのペンドールによって10分間現像して濃度0.62に仕上げた。それをmicro-photometerのピンホールを直径0.3mmとして走査したところ、粒状性に基づく光電流の変動は認められなかった。したがつて

このネオパンSSを用いた場合には直径 0.3 mm の領域までは測定できる。

3.5 まとめ

平面試料の荷重による厚み変化によって生じる光波の位相変化は、得られる像の強度分布に大きく影響することが明らかとなった。しかし試料を散乱光で *incoherently* に照明し、その荷重状態にある格子像を撮影した写真フィルムを実際の測定光学系に対する試料とすればその影響を完全に取除くことができる。このようにすれば厚み変化の影響を補正するばかりでなく、荷重装置と光学系とを分離することができるためには荷重装置に対する制限がなくなり、また不透明試料に対しても特に反射光学系を組立てることを必要としない。さらに測定光学系に適するように格子間隔を調節することができ、また順次荷重を変えて行なったときの状態が撮影された格子像として保存される。

平面応力による歪は三方向の歪を測定することによって決定されるが、この三方向の歪を測定するには、各々異った格子方向を持つ三個の試料を作成して一方向の歪を別々に測定するあるいは一試料上に格子を三交又させて転写し、そのうち一方向の格子が線光源と平行になるように試料を回転して測定を行えばよい。また別の方法としては一方向の格子を持った試料で格子を線光源とのだけ傾むければ線光源と垂直

方向の歪を測定でき、この方法によつても任意方向の歪を測定できることがわかつた。

理論的考察の結果、本測定法による測定感度は格子間隔に逆比例することがわかつた。用ひる格子の格子間隔を 30 本/mm とし、荷重によつて生じた歪分布が 10mm 周期であるとすれば、測定可能な変位量としては 0.11μ であり、また歪量としては 0.0067% となつて、非常に感度の良い測定法であることが明らかとなつた。

第4章 引張り変形されたアルミニウム 粗大結晶の歪分布の測定

ここではアルミニウム粗大結晶を引張り変形させた場合、どのようなふるまいをするかを実際の測定例として示すと共に、これまで考察してきたことをさらに確かめることとする。

4.1 試料の調製

歪焼鉄法によって作成したアルミニウム粗大結晶を試料として用いた。試料は各結晶粒によって光の反射率が異なり、そのためには例えば図4.1(a)に示したように各結晶粒が観測されるが、いまこの各結晶粒からの反射を一様とするために表面をエメリー紙で軽く荒らし、その表面に感光液を塗布した。使用した写真感光液はオリエンタル写真工業製の写真製版用感光性樹脂オリエンタル・フォトレジスト(略してOPR)でこれを手回しwhirler*によって試料表面に塗布した。塗布乾燥後の感光膜の膜厚が厚いと、露光したときの光が感光膜の表面だけ吸収されてしまい、下部まで十分硬になりないので、現像中に膜全体がとれてしまう恐れがある。^{**}したがってここでは乾燥後の膜厚が5μ以下となるようにした。この感光液を塗布した試

* 遠心力を利用して感光液を一様に塗布する塗布機で、通称タコと呼ばれている。

** OPR使用説明書による。

料上に 10 本/mm の明暗格子を転写し、一様な引張り荷重を加えた。この変形をうけたアルミニウム粗大結晶を散乱光で照明して変形の各段階の格子像を写真撮影した*。得られた写真フィルムを二枚の optical parallel で保持し、フィルムと optical parallel 間に流動パラフィンを入れ、浸漬して実際の測定光学系の試料とした。

4.2 実験結果および考察

§4.1 で述べた方法によって調製した試料について行った実験のうち一試料について変形量を順次増して行ったときに得られた結果を §4.1 図 (a) ～ (g) に示した。格子線の方向は引張り方向に垂直で、線光源方向は格子線方向と一致させた。図中に記した変形量は標線間隔の測定から算出したもので、試料全体の平均値である。

§4.1 図 (a) は試料としたアルミニウム粗大結晶の結晶粒の状態を感光乳剤塗布前に写真撮影したものである。また X 線ラウエ写真から方位を定めて §4.2 図に示した。試料の大きさは標線間隔 62 mm, 幅 11 mm および厚さ 1.4 mm であった。

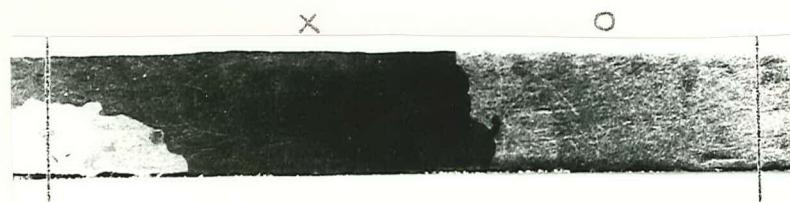
§4.1 図 (b) ～ (g) の图形は歪の分布が、平均的な伸びを中心として、光の強度分布として得られているので、写真でよく現われている部分は光の強度が大で伸びが大きい部分に相当する。逆に写真で黒く現われている光の強度が小の部分は相対的に縮みの部分、すなわち伸びの少ない部分に相当している。

* §3.1 参照。

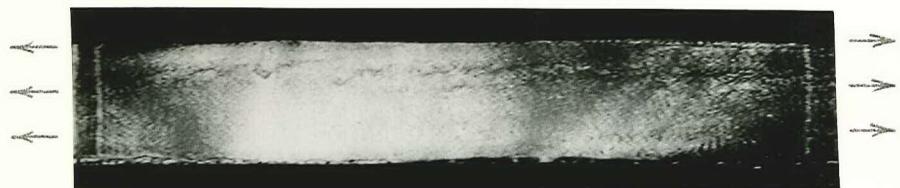
第4.1図 引張り変形されたアルミニウム粗大結晶の歪图形。

(a)～(g)には全体としての引張り変形量および復調に使用したマスクの種類を記した。

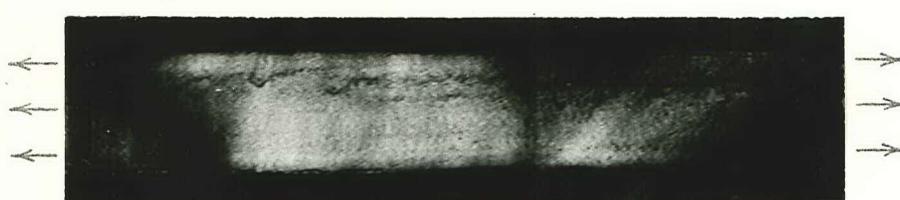
(a) 結晶粒。位置は第4.2図に×および○印で示した。



(b) 0.8% ナイフエッジ



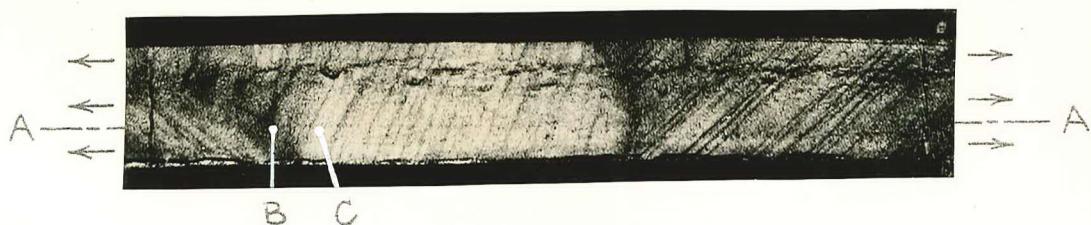
(c) 1.5% ナイフエッジ



(d) 4.9% 光学模



(d-1) 8.9% 光学模



(e-2) 8.9% ナイフエッジ



(e-3) 8.9% ナイフエッジを(e-2)よりも高周波側に挿入



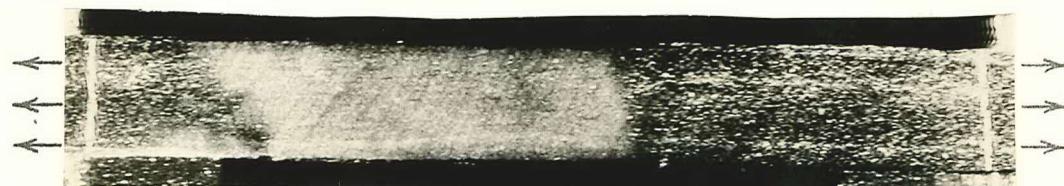
(e-4) 8.9% 幅の狭い光学楔



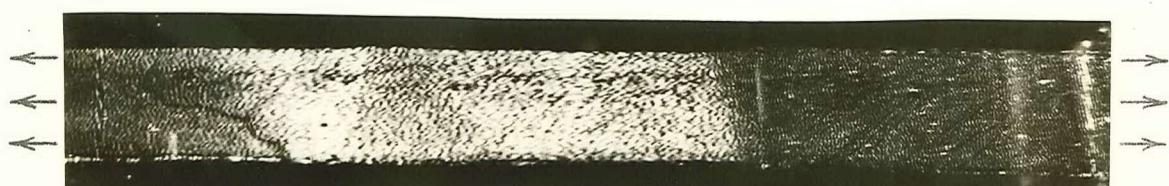
(e-5) 8.9% 幅を持った光源とナイフエッジ



(f) 24.8% 幅を持った光源とナイフエッジ



(g) 39.5% 幅の狭い光学楔



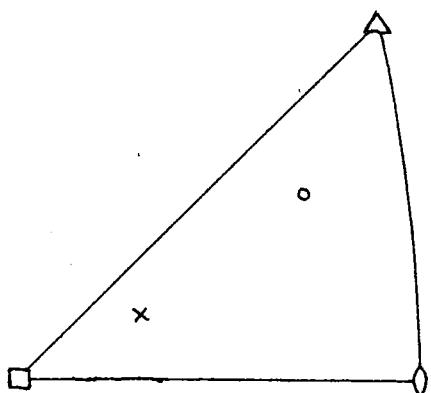


Fig. 4.2 図 アルミニウム
粗大結晶粒 Fig. 4.1 図 (a) の
引張り軸方向に関する
方位。

る。また光の強度分布と伸びの
程度とは量的に一致している。

(b) および (c) は全体としてそ
れぞれ 0.8% , 1.5% の引張り変
形を与えたもので、投影レンズ
に ω_0 とその側帯波である一次光
近傍のスペクトルをすべて通した
場合には歪に基づく图形は何も
観測されなかつたが、その回折
スペクトルの平均周波数の位置

に高周波側からナイフエッジを挿入したときに得られた图形で
ある。この图形と (a) の結晶粒とを対比してみると同一結晶粒
内でも伸びは一様でなく、また結晶粒界は伸びが拘束されて
いることがわかる。

(d) および (e) はそれぞれ 4.9% および 8.9% の引張り変形を加
えたものである。変形量が多くなっているので光学楔を用い、
§2.4で考察したように存在するスペクトルの周波数領域を被
うような光学楔を挿入したときに得られた图形が (d) および
(e-1) である。この場合、光学楔の振幅透過率 $0 \sim 1$ の範囲が
スペクトルの広がりにくらべて広くなるにつれて次第にコント
ラストが低下するのが観測された。したがってスペクトルの
広がりよりもやゝ幅の広い光学楔を用いた。同一結晶粒内で
も伸びは一様でなく、また結晶粒界は伸びが拘束されている
ことは (b) および (c) と同じであるが、さらに線状となって細

かの周期で現われているすべりによる歪が顕著に観測される。

(e-2)の图形はナイフエッジを用いて得られたものであるが、

(e-1)にくらべて中間強度の部分が少ない。コントラストは良い

が、(e-1)のように歪分布が忠実に現われていない。(e-3)は

ナイフエッジを(e-2)のものにくらべてやゝ高周波側へ寄せたも

のである。(2.18)で示した変調波 $m(u) + g$ の定数 g が(e-2)

にくらべて大きくなっているために、増加した g の値だけ光

の強度が全面に加えられていると解釈される。(e-4)はスペ

クトルの広がりよりもやゝ幅の狭い光学楔を用いたときに得

られた图形で、(e-1)にくらべてやゝ忠実度は低下している。

(e-5)は§2.5で考察したように光源幅を広げ、ナイフエッジと組合せて面積型楔の原理を達成して得られた图形である。

これはほとんど(e-1)と同じ強度分布を示しており、忠実に復調されていることがわかる。また装置の干涉フィルターを取り外し、§2.33図に示した超高圧水銀灯そのまゝの光を用い、

546 $m\mu$ の緑の位置にナイフエッジを挿入した。このとき(e-1)

に示した图形の中で光の強度が最も大きい部分は白みがかった青となるのが観測された。また強度の最も小の部分は濃い

青色となって、濃い青色から淡い青色の間を変化する色模様が観測され、§2.6に述べたように色差でも検出された。以

上(e-1)～(e-5)の各图形は§2章で考察した各復調方法の

特徴をそのまま裏づけしている。

(f)は24.8%の変形を加えたもので、幅を持っています光源とナイフエッジを組合せて面積型楔の原理を達成して得られた圖

形である。各結晶粒間の伸びの差が大きくなつて、結晶粒内の変化は相対的に小さくなつてゐるため、粒内の変化はあまり顕著に観測されない。試料の最も左の部分は引張り方向に水平な結晶粒界の影響が試料の上部にもおよんでゐることが観測される。Urie と Wain のアルミニウム粗大結晶を引張り変形させたときの実験結果によれば³⁾、粒界近傍の変形は各結晶粒の方位と形状によつて必ずしも拘束されていなかつた。この実験例では、上の各图形で観測されるように変形は拘束されていゝ。

(g) は 39.5% の大きな引張り変形を加えたもので、中央の結晶粒に注目した。そこで“この部分から”的回折光の伸びを被ることのできる光学楔を使用した。その後 46.5% の引張り変形を加えたときに、中央の結晶粒内で左の明るく見えてゐる伸びた部分で“破断した”。0.8% 変形の (b) を見ると、そこと同じ部分が最も伸びが大で、破断に到る応力集中部は変形の初期ですでに決つてしまつことがわかる。

一例として光学楔を用いて得られた $\text{No}4.1$ 図 (e-1) の結果について图形を撮影したフィルムを microphotometer で走査した。
(e-1) に示した断面 AA を走査して得られた光電流曲線が $\text{No}4.3$ 図に示した曲線で“目盛は等間隔”である。图形の撮影に使用した写真フィルムはイーストマンコダック社の Tri-X で、撮影条件、現像条件を同じにしてその H-D 曲線を作成した。それを用ひて光電流曲線から算出した光強度が $\text{No}4.3$ 図の右に記した光強度目盛によるものである。歪の分布は光の強度分布として

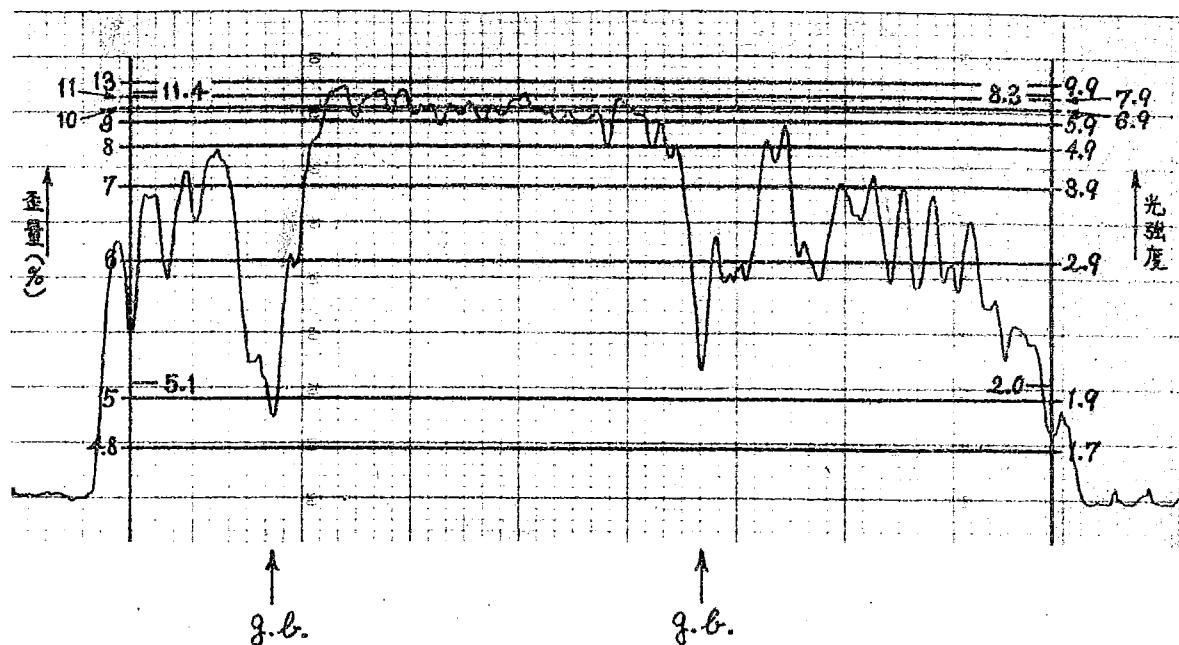


図4.3 図 引張り変形をうけたアルミニウム粗大結晶の高さ分布の定量。測定は図4.1図(e-1)の断面AAについて行ったものであり、g.b.は結晶粒界を示している。

測定されているから、この光強度自盛がそのまま高さの自盛となる。しかしいま測定は相対量について行ったので、縦軸にはゼロ点の位置とその軸倍率とを定めて絶対量を附加してやるなければならぬ。そのためには図4.1図(e-1)のBおよびCと示したところに直径0.8mmのピンホールを置いてそこから回折される回折光の中心位置を測定した。これよりその部分の平均格子間隔を算出した。また格子像を撮影して測定光学系に対する試料を作成したとき、変形の全段階においてアルミニウム試料およびカメラ位置は固定されていたので撮影倍率は全く同じであった。したがって無歪のときの格子を撮影したものから、その回折光の位置を測定して格子間隔を比

較すれば B および C 点の歪量が定まり、それぞれ 5.1% および 11.4% であった。この点の光強度は相対値でそれぞれ 2.0 および 8.3 であるので、それを 5.1 および 11.4 と書き換えてよく、この二点を固定して光強度の数値を書き換えたものが図の左に記した数値である。これが定量的な歪量を与えてい。平均の伸びは 8.9% であるが、これによれば結晶粒界では 5% 程度しか伸びていなく、また中央の結晶内では 12% の伸びを示しているところがあるのがわかる。

4.3 測定方法に対する考察

本測定法の一つの大きな特徴は、ここで試料としたアルミニウム粗大結晶のように不透明物体の測定を感度に無関係に行うことができる点にある。光弾性法では皮膜法²⁾によって測定を行うが、測定感度は皮膜の厚さに比例する。皮膜を厚くすると感度を上げることができると、そのために試料の応力分布あるいは歪分布は影響をうけ、実際のものと異なってくる恐れがある。また試料に発生した歪が厚い皮膜に忠実に伝わられるとは限らないであろう。4.1で述べたように写真法によって格子を試料上に転写する場合、感光膜の膜厚は 5μ 以下であって、測定感度は乳剤膜の厚さに無関係である。したがって試料の歪分布に影響を与えることなく、一定感度で測定できる。また光弾性法で得られた光弾性図から応力分布あるいは歪分布を解析するには種々の手続きを要し、必ずし

も簡単ではない。本測定方法によれば、歪分布が直接光の強度分布として得られるから歪分布を試料全面にわたってそのまま直視することができ、また図4.2で示したように測光すればそれが定量値を与え、解析が簡単である。

モアレ法に対する考察は図3.4で述べたが、モアレ法の一つの欠点は微小領域の測定が困難な点にあった。図4.1図の各图形をみるとすべりに基づく非常に小さな領域で変動する歪もよく現われている。

従来、回折格子を用いた歪の測定としては Bell が行っているように⁶⁾⁷⁾試料上に回折格子を刻線して、その部分が歪んだときの回折光の移動から求めている。しかしこれによれば試料全体の平均的な歪しか知ることができない。試料全体にわたる歪分布を測定するには、細く絞った光を試料にあてるか、あるいはピンホールを置くことによって、その一部分の歪を測定し、それを試料全体にわたって走査しなければならず、非常に手間がかかる。しかし本測定法によれば図4.2で示したように試料全体にわたってその位置と歪の程度が一度に測定でき、従来の方法に比してすぐれていることがわかる。

4.4 まとめ

回折格子を用いて歪測定を行う本測定法の実験例としてアルミニウム粗大結晶を引張り変形させた場合の結果が示された。結晶粒界において変形が拘束されるか、あるいは促進

されるのは、これまで議論のあるところであったが、本実験例では伸びは拘束されている。また結晶粒内において伸びは不均一であること、あるいはすべりによる歪なども観測され、本測定法の持つている次の特徴が確かめられた。

- 対象物を直接に試料とすることができる。
- 歪の分布が光の強度分布あるいは色差として試料全面にわたって一度に検出されるから、直接歪の分布状態をつかみやすい。
- 定量測定も従来の各方法に比して簡単である。
- 高い測定感度を持っており、特に不透明物体の測定には有効である。
- 微小領域の歪の変動を測定できる。

第5章 分光用回折格子のピッチ 誤差の測定

従来、分光用回折格子の検定は、大部分直接に回折光を観測して行われていた。しかしこれによれば回折格子全体として平均的にどの程度の誤差があるかしか知ることができない。ピッチ誤差が存在する部分を場所的に知る方法としては、ピッチ誤差が存在するためには生じる波面の歪み、すなわち位相変化をマイケルソン干渉計を使用して測定する方法³³⁾、あるいはそれを位相差コントラストとして観測する方法³⁴⁾があり、それぞれの特徴を持っている。これまでには荷重に基づく格子歪と対象として采光が、測定の原理から明らかな荷重以外によって生じる格子歪も測定が可能である。ここではその一つの応用例として *ruling engine* によって製作された分光用回折格子のピッチ誤差の測定を行った。

5.1 測定の原理

現在、分光に用いられている回折格子はほとんど位相格子であり、オ5.1図に示したようにフ"レース"を行うことによって、ある特定次数の回折光にエネルギーを集中させて光の利用率をよくしている。このような回折格子を写像光学系における物体として考えるならば、(1.17)において $F(U)$ が一定と考えればよく、 $\Theta(U)$ および $\frac{2\pi}{\lambda}L(U)$ を (1.1) にしたがって変換座標で表

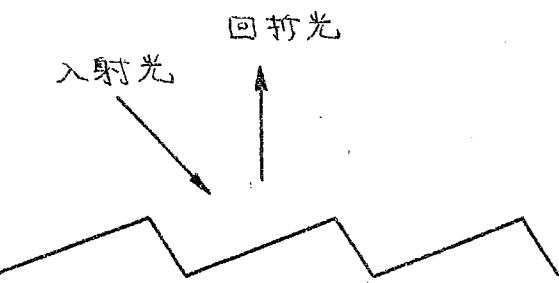
わしたものとを各々 $\Theta(u)$ およ
び $\varphi(u)$ とすれば位相格子は
 $\Theta(u) = \exp\{i\varphi(u)\}$

(5.1)

と書ける。ここに

$$\varphi(u) = a_0 + a_1 \cos \omega_c u$$

(5.2)



第5.1図 ブレーズされた位相格子

であり、 ω_c は位相格子の格子間隔を空間周波数によって表わしたものである。 $\Theta(u)$ は周期函数であるからフーリエ級数に展開でき

$$\Theta(u) = A_0 + A_1 \cos(\omega_c u + \psi_1) + A_2 \cos(2\omega_c u + \psi_2) + \dots \quad (5.3)$$

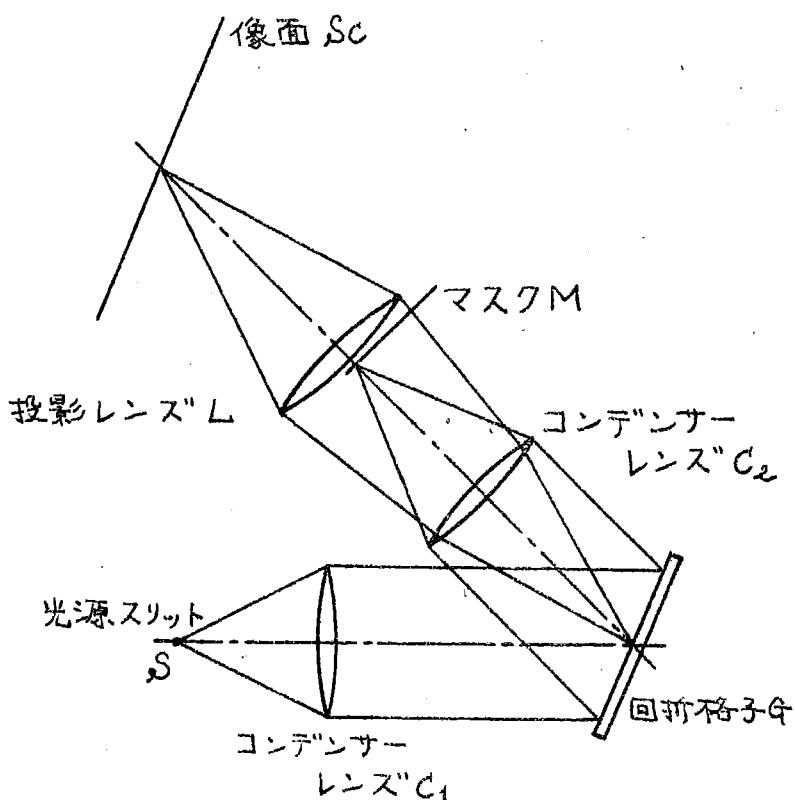
となる。(5.3)を(1.28)と比較してみると位相 ψ_N が加わっただけである。ある特定の次数の回折光に注目した場合、これは定数であるから考える必要がない。したがって位相格子についてもこれまで考察したこととそのまま適用されることがわたり、光学機などマスクを Fraunhofer 回折面に挿入すれば格子歪、すなわちピッチ誤差を測定することができます。

いま、 N 次の回折光に注目すればその項は $A_N \cos(N\omega_c u + \psi_N)$ であって、空間周波数が $N\omega_c$ の回折格子による回折光に等しい。あらためてこれを ω_c と考えれば、これまでの一次光を用いた取り扱いと全く同じであり、 N 次光を用いてもよいことがわかる。この場合、空間周波数が N 倍になっていることから §3.4で考察したように測定感度は増加する。

5.2 試料および測定光学系

次の 5.3 で結果を示した試料は 5.1 表に記したものである。その試料は平面ガラス上にアルミニウムを電着して、そのアルミニウム面に *ruling engine* で刻線したものである。G-I および G-II は試作的な回折格子であるが、G-III は分光器に用いられる程度に完成したものである。

実験には反射光学系を用い、それを 5.2 図に示した。回折格子はブレーズの条件を満たすように配置した。すなわち入射光と回折光の方向が 5.1 図に示したごとく回折格子の溝の一面に対して鏡面反射の関係となるように配置した。コンデン



5.2 図 分光用回折格子のピッチ誤差測定に用いた反射光学系

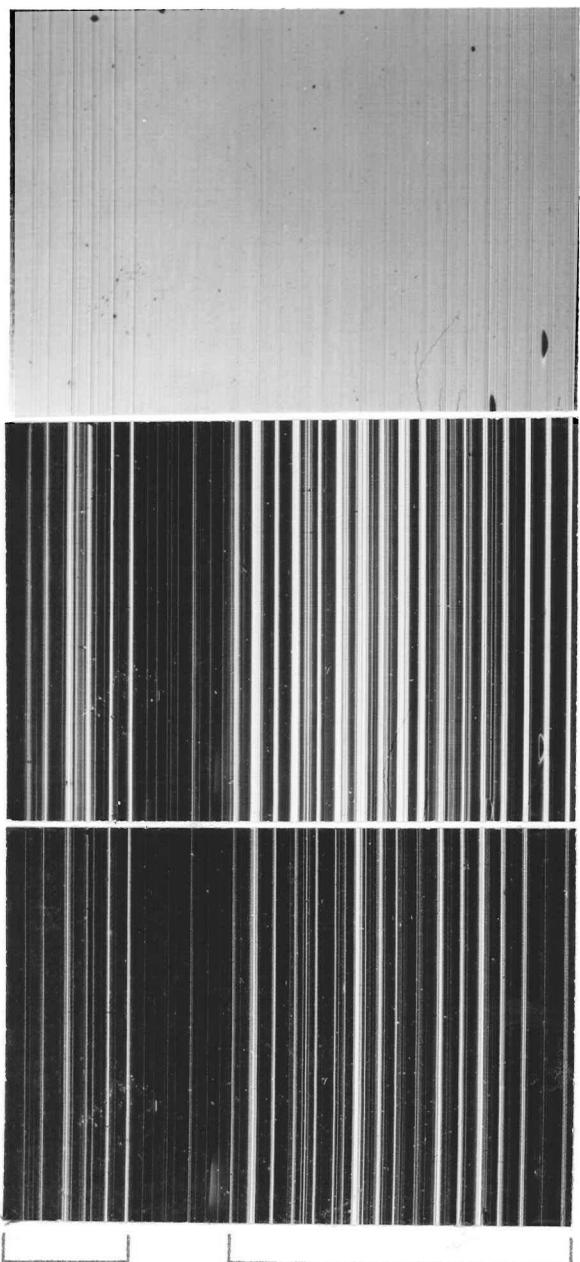
表5.1表 ピッチ誤差の測定に用いられた分光用回折格子。

試料	格子定数	ブレーズ角
G-I	300本/mm	26°45'
G-II	300本/mm	26°45'
G-III	600本/mm	5°00'

サーレンズ C_2 より後の光学系には一次光とその近傍のスペクトルだけを入れるようにして実験を行った。

5.3 実験結果および考察

試料 G-I について行った実験の結果を表5.3図の写真に示した。(a)は一次光近傍のスペクトルがすべて投影レンズを通過した場合であるほとんどコントラストは生じていない。(b)はナイフエッジを Fraunhofer 回折面に挿入して平均周波数以上のスペクトルを取除いた場合に得られた图形であり、これと(a)を比較してみるとピッチ誤差に基づく濃淡が現われている。写真でよく見えている部分は光の強度が大であって、変調波が正の部分、すなわち格子間隔が大きい部分に相当する。(c)はナイフエッジをやや低周波側に寄せた場合に得られた图形の写真である。§2.3で考察したように $m(\mu) + g$ なる変調波を測定しており、ナイフエッジを低周波側に寄せた場合は $g < 0$ となる。したがって減少した g の値だけ光の強度が全体にわたって減少している。表5.3図の图形をみると、回折格子全面にわたってピッチ誤差があるのが観測されるが、特に「印で示した部分では、測定の結果約 0.8 mm 周期で繰返す誤差がある。



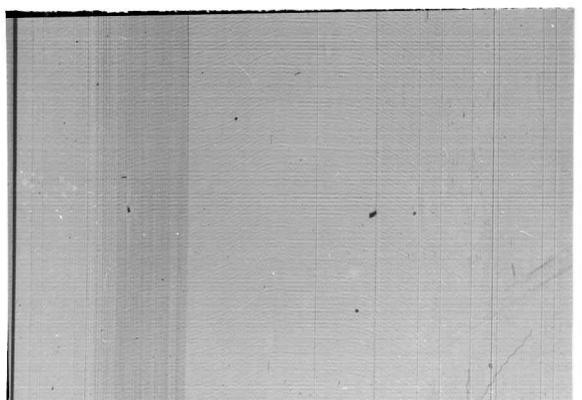
(a) 1次光近傍のスペクトル
をすべて投影レンズに入れた場合。

(b) "ナイフェッジを1次光の中心
まで挿入して高周波側のスペ
クトルを取除いた場合。

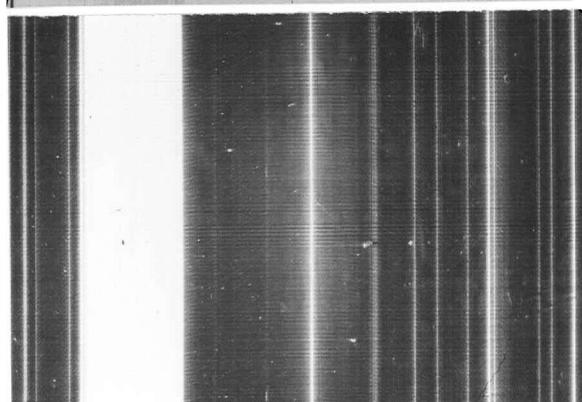
(c) ナイフェッジを1次光の中
心よりも低周波側まで挿入
した場合。

10mm

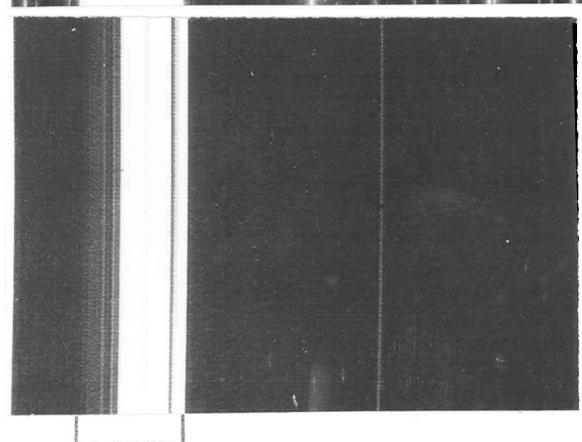
図5.3 図 分光用回折格子G-Iのピッチ誤差。各写真は同一視野を対
応させて示してある。(b), (c)において光の強度と格子間隔の変動と
は対応する。



(a) 1次光近傍のスペクトル
をすべて投影レンズに入れ
た場合。



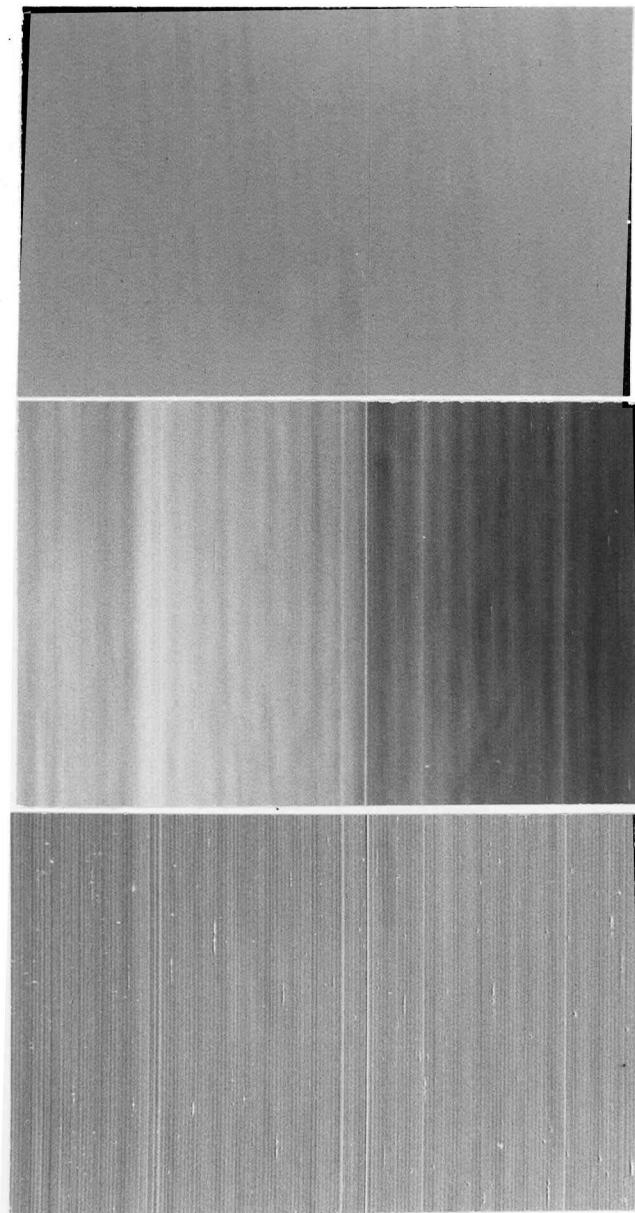
(b) ナイフエッジを1次光の中
心まで挿入して高周波側のス
ペクトルを取除いた場合。



(c) ナイフエッジを1次光の
中心よりも低周波側まで挿
入した場合。

10mm

図5.4図 分光用回折格子G-IIのピッチ誤差。各写真は同一視野を
対応させて示してある。(b),(c)において光の強度と格子間隔の変
動とは対応する。



(a) 1次光近傍のスペクトルをすべて投影レンズに入れた場合。

(b) ナイフエッジを1次光の中心まで挿入して高周波側のスペクトルを取除いた場合。

(c) 光学鏡とFraunhofer回折面に挿入した場合。

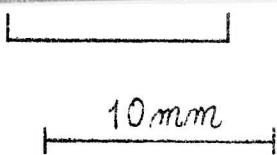


図5.5 図 分光用回折格子4-Ⅲのズック誤差。各写真は同一視野を対応させて示してある。(b),(c)において光の強度と格子間隔の変動とは対応し、図中に観測される0.17mmの細かい濃淡は格子線100本ごとに繰返す周期誤差である。

第5.4図は試料G-IIについて行った実験結果で、回折格子には一印で示した格子間隔の大きい部分が観測されるが、他の部分は試料G-Iよりも良好である。格子間隔の大きい部分の内部には、第5.4図(C)に見られるようにかなりのピッチ変動がある。

第5.5図は試料G-IIIについての結果である。ナイフエッジを用いた(b)、および光学楔を用いた(c)にはそれぞれコントラストが生じて、ピッチ誤差を現わしている。(b)および(c)の图形にはG-Iの試料と同じように約0.8mm周期のピッチ誤差が認められる。またそれよりも細かい周期で繰返す誤差が認められるが、これは光学楔を用いた(c)によく現われており、光学楔を用いたために復調の忠実度が増しているためと思われる。この細かい周期で繰返すピッチ誤差は測定の結果、1周期が0.17mmのものであることがわかった。これより1周期に含まれている格子の本数は

$$600 \times 0.17 = 100 \text{ 本} \quad (5.4)$$

である。したがってそのピッチ誤差は格子線100本を周期として繰返していることがわかる。また一印で示した部分は光の強度が他の部分よりも大であって、全体に他よりも格子間隔が大きい。また周期的变化をするものとは無関係にランダムに生じたピッチ誤差も認められる。

5.4 まとめ

回折格子によって発生した空間搬送波の変調および復調と言う考え方に基づく本測定法によって、分光用回折格子のピッチ誤差が光の強度分布として試料全面にわたって一度に測定できることが明らかとなった。実際の試料について測定した結果、一定の周期で繰返すピッチ誤差が認められ、細かい周期のものは光学楔を用いればよく現われることがわかった。これより *ruling engine* のネジあるいは歯車など周期誤差を生む可能性のある不良箇所を逆算して、*ruling engine* の精度向上に役立てることができる。

総 括

本研究では先ずオ1章において、本研究に用いる写像光学系の結像関係を導くと共に、光学系と通信系との対応から荷重によって歪んだ平面回折格子の歪分布を試料の像面上に光の強度分布として測定する方法について考察した。その結果は次のようにまとめることができること。

- (1) 回折格子はその透過率分布あるいは位相分布にしたがう空間的な波を発生させるとみなされる。歪んだ回折格子は、もとの格子線に直角な断面を考えるとその空間的な波を搬送波とし、その断面方向の歪分布を変調波として空間周波数変調されていることが明らかとなった。
- (2) 歪分布を試料の像面上に光の強度分布として得るには、その変調波を復調すると言う立場で考えることができること。それは通信系において周波数被変調波の復調で行なわれている周波数差別と同じことをすればよい。すなわち試料のスペクトル面である Fraunhofer 回折面に光学櫻などのマスクを挿入して、搬送波の両側に側带波を持つようになった歪んだ回折格子のスペクトルに spatial filtering を施せばよりことがわかった。

オ2章では各種の復調方法について具体的に検討し、さらにそれを実験によって確かめた。それらの結果は次のようである。

- (1) 試料を照明する照明光の coherency から考察した結果、

測定光学系の光源として線光源を用いれば、その線光源に垂直な試料断面についての歪分布が、像面上その断面の共轭位置で測定される。したがって光学系全体を考えれば、試料はその各断面の積み重ねで全面を同時に測定できることがわかった。

- (2) マスクとしてナイフエッジを用いれば復調できる。この場合、変調波を現わしている图形の忠実度とコントラストを兼合せて考えれば、歪をうけた回折格子の平均周波数のスペクトル位置にナイフエッジを挿入して、それより高周波側のスペクトルを取除くのが最もよいことがわかった。
- (3) ナイフエッジを用いた場合に得られる图形は歪量の小ささりときにも良好なコントラストを持っており、忠実度もよい。歪量が大きくなると忠実度は悪くなるので歪量の小ささりときに用いるのが望ましい。
- (4) マスクとして振幅透過率が Fraunhofer 回折面にそって直線的に減少している光学楔を用い、それで側帯波の干渉を完全に被えば忠実に復調され、歪の分布と像面上の強度分布とは正しく一致することがわかった。
- (5) 線光源を用いたとき、Fraunhofer の回折像は矩形状の干渉を示すから、ここへマスクとして面積型楔を挿入する方法によっても復調でき、ナイフエッジを用いたときよりも復調の忠実度は向上する。
- (6) 面積型楔の原理と同じことが、光源幅を増し、回折面にナイフエッジを挿入する方法、あるいは波長幅を持った

線光源を用いて同様にナイフエッジを挿入する方法によつても達成できる。この場合、単色の線光源を用ひるよりも光学系を簡単く使用できる。

(7) 以上の復調方法によつて単色で現われてゐた图形の背景に特定の色を一様に加えることにより色差として歪分布を検出できる。

試料に平面応力が加えられたとき、三方向の歪を測定すれば任意方向の歪を決定することができる。第3章では、そのために回折格子を用いた本測定法をいかに適用するか、実際の歪測定に対する方法を検討した。あわせて測定感度についても考察した。それらをまとめると次のようである。

(1) 平面試料の荷重による厚み変化などによつて生じる光波の位相変化は得られる像面上の強度分布に大きく影響する。それを避けるためには試料を *incoherently* に照明し、荷重状態にある格子像を撮影した写真フィルムを測定光学系に対する試料とすればよいことがわかった。

(2) 歪んだ格子像を撮影したフィルムを測定光学系に対する試料としたときには、光学系と荷重装置とを分離することができる。そのためには荷重装置に対する制限がなくなり、また不透明試料に対しても反射光学系を組立てることを必要としない。

(3) 三方向の歪を測定するには異った格子方向を持つ三個の試料を作成して、一方向の歪を別々に測定すればよい。

(4) 三個の試料が得られない場合は、一試料上に格子を三

交叉させて転写し、そのうち一方向の格子が線光源と平行になるよう試料を回転して測定を行えばよい。

(5) 一方向の格子を持つた試料で"特定方向の歪を測定するには、格子を線光源に対して傾むければ"線光源と垂直方向の歪が"測定できる。

(6) 理論的考察の結果、本測定法による測定感度は格子間隔に逆比例することがわかった。格子間隔を 30本/mm とし、歪分布が 10mm 周期 で、試料がその 1 周期以上の大きさを持っているとすれば、測定可能な変位量としては 0.11μ であり、また歪量としては 0.0067% となって、非常に感度の高い測定方法であることが明らかとなった。

第4章では実際の実験例としてアルミニウム粗大結晶を引張り変形させた場合の歪分布を測定し、粒界では伸びが拘束されていること、あるいは粒内における不均一な伸びなどを知った。その結果、第1章～第3章の考察と合わせて本測定法の持っている次の特徴が確かめられた。

- (1) 対象物を直接に試料とすることができる。
- (2) 歪分布が"光の強度分布あるいは色差として試料全面にわたって一度に検出されるから、直接歪の分布状態をつかみやすい。
- (3) 定量測定も従来の各方法に比して簡単である。
- (4) 高い測定感度を持っており、特に不透明物体の測定には有効である。
- (5) 微小領域の歪の変動を測定できる。

第5章では荷重による格子歪だけでなく、この測定法を分光回折格子のピッチ誤差の検定に利用した。その結果は次のようにまとめられる。

(1) 理論的考察および(2)の結果より、本測定法によって分光回折格子の各部分に生じているピッチ誤差が試料全面にわたって一度に測定できることが明らかとなつた。

(2) 測定に用いた回折格子には部分的に格子間隔が他の部分よりも変動しているところが認められた。また突然的に生じたピッチ誤差および一定の周期で繰返すピッチ誤差があることがわかった。

謝 言

最後に、本研究の着想を与えていただき、本研究の遂行に対してたゞず懇篤な御指導を賜った大阪大学篠田軍治、鈴木達朗両教授に深く感謝いたします。

また、終始有益な御助言、御討論をいたたいた大阪府立大学永田良助教授、ならびに本研究に御協力下さった諸氏に厚くお礼申し上げます。

昭和40年12月9日

大阪大学大学院工学研究科

三野正幸

参考文献

- 1) 湯浅亜一: 材料力学中巻, コロナ社 (1962).
- 2) 中村 寛: 非破壊検査 8, 89 (1959).
- 3) V. M. Urie and H. L. Wain: J. Inst. Metals 81, 153 (1952).
- 4) G. Oster, M. Wasserman and C. Zerling: J. Opt. Soc. Am. 54, 169 (1964).
- 5) D. Post: Experimental Mechanics 5, 368 (1965).
- 6) J. F. Bell: J. Appl. Phys. 27, 1109 (1956).
- 7) J. F. Bell: J. Appl. Phys. 30, 196 (1959).
- 8) P. M. Duffieux: L'integrale de Fourier et ses applications a l'optique. Renne (1946).
- 9) M. Born and E. Wolf: Principles of Optics (Pergamon Press, Oxford, 1964), 2nd ed.
- 10) E. H. Linfoot: J. Opt. Soc. Am. 45, 808 (1955).
- 11) H. H. Hopkins: Proc. Phys. Soc. B, 70, 449 (1957).
- 12) E. L. O'Neil: IRE Trans. Prof. Group on Information Theory IT-2, 56 (1956).
- 13) 斎藤34義: 生産研究 10, 8 (1958).
- 14) R. V. Pole: IBM Research Report RC-750 (1962).
- 15) S. Timoshenko and J. N. Goodier: Theory of Elasticity (McGraw-Hill, Newyork, 1951), 2nd ed.
- 16) H. H. Hopkins and P. M. Barham: Proc. Phys. Soc. B, 63, 737 (1950).
- 17) A. M. Goodbody: Proc. Phys. Soc. 70, 361 (1957).
- 18) 辻内順平: 機械試験所報告 No.40, 4 (1961).
- 19) T. Suzuki: Technol. Repts. Osaka Univ. 12, 61 (1962).
- 20) H. H. Hopkins: Proc. Roy. Soc. A, 208, 263 (1951).
- 21) W. E. Glenn: J. Opt. Soc. Am. 48, 841 (1958).
- 22) W. E. Glenn: J. Appl. Phys. 30, 1870 (1959).
- 23) A. Lohmann und B. Morgenstern: Optik 20, 450 (1963).
- 24) H. H. Hopkins: J. Opt. Soc. Am. 47, 508 (1957).

- 25) H. Boersch und H. Raith: Z. Physik 167, 152 (1962).
- 26) 霜田光一: エレクトロニックスの基礎, 講華房 (1960).
- 27) J. Tsujiuchi: J. Phys. Soc. Japan 12, 744 (1957).
- 28) 朝倉利光: 対用物理 32, 180 (1963).
- 29) 篠田翠治, 鈴木達朗, 中谷登, 永田良: 対用物理 33, 727 (1964).
- 30) 立川利久, 阪尾昭一: ポリカーボネート, 日刊工業新聞社 (1961).
- 31) 帝国人絹株式会社編: ポリカーボネート樹脂技術資料, 物性編 (1961).
- 32) 応力測定技術研究会編: 応力測定法, 朝倉書店 (1955).
- 33) G. W. Stroke: J. Opt. Soc. Am. 45, 30 (1955).
- 34) E. Ingelstam and E. Djurle: Arkiv för fysik 4, 423 (1952).

講演ならびに論文目録

本研究に関する講演ならびに論文は次のとおりである。

I. 講演

「应力測定における回折格子の应用」

第23回応用物理学学会学術講演会 11p-IV-2

昭和37年10月11日

「回折格子を用いた应力測定 歪とコントラストとの詳細な理論」

第10回応用物理学関係連合講演会 1a-VII-7

昭和38年4月1日

「回折格子を用いた应力測定 測定例」

第10回応用物理学関係連合講演会 1a-VII-8

昭和38年4月1日

「回折格子を用いた再回折法による歪測定 定量精度に関する考察」

第24回応用物理学学会学術講演会 3p-II-6

昭和38年10月3日

「回折格子を用いた再回折法による歪測定 荷重の変化および単色光、多色光による歪模様」

第24回応用物理学学会学術講演会 3p-II-7

昭和38年10月3日

「回折格子を用いた再回折法による歪測定 Incoherent 照明を適用し試料の waviness を補正した場合」

第11回応用物理学関係連合講演会 2a-B-2

昭和39年4月2日

「回折格子と空間的な搬送波と考えた歪測定」

第14回応用力学連合講演会 419

昭和39年9月8日

「再回折法による回折格子のピッチ誤差の検出」

第25回応用物理学学会学術講演会 4p-V-9

昭和39年11月4日

「回折格子を用いた再回折法による歪測定 スペクトル面に光学楔を挿入した場合」

第25回応用物理学学会学術講演会 5p-VI-7

昭和39年11月5日

「回折格子を搬送波と考えた歪測定 平面応力による歪分布の測定とその応用」

第12回応用物理学関係連合講演会 6p-K-9

昭和40年4月6日

「回折格子を carrier oscillator と考えた歪測定 引張り変形されたアルミニウム粗大結晶への応用」

第26回応用物理学学会学術講演会 2a-G-10

昭和40年10月2日

「周波数変調をうけた回折格子の像 面積型楔による信号像の復調」

第26回応用物理学学会学術講演会 2p-F-2

昭和40年10月2日

II. 論文

「回折格子を搬送波として用いた応力測定」

応用物理 32, 133 (1963).

"Optical Diffraction Method of Strain Measurement
Based on Modulation Theory"

Technol. Repts. Osaka Univ. 12, 359 (1963).

"Further Consideration on the Measurement of Strain
Distribution by the Use of a Diffraction Grating"

Technol. Repts. Osaka Univ. 14, 521 (1964).

"Image of the Optical Grating Modulated by the Signal
and its Application to the Measurement of Strain
Distribution"

Appl. Opt. 3, 825 (1964).

"Fidelity of Strain Pattern and Measurement of Strain
Distribution in a Plate by Using a Diffraction Grating"

Proc. of the 14th Japan Congress for Applied
Mech., (1965), to be published.